4/7/3

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI (c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

014787863 **Image available** WPI Acc No: 2002-608569/ **200265**

New perfluorovinyl ether monomer for solid polymer electrolyte films for fuel cells comprises sulfonamide group

Patent Assignee: ASAHI KASEI KK (ASAH); ASAHI KASEI KOGYO KK (ASAH)

Inventor: HOSHI N; IKEDA M; KOGA T; UEMATSU N Number of Countries: 101 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
WO 200262749 A1 20020815 WO 2002JP854 A 20020201 200265 B
EP 1359142 A1 20031105 EP 2002711282 A 20020201 200377
WO 2002JP854 A 20020201

Priority Applications (No Type Date): JP 2001343931 A 20011108; JP 200125018 A 20010201; JP 200130955 A 20010207; JP 2001278418 A 20010913; JP 2001342172 A 20011107; JP 2001343780 A 20011108

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes WO 200262749 A1 J 215 C07C-311/24

Designated States (National): AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BY BZ CA CH CN CO CR CU CZ DE DK DM DZ EC EE ES FI GB GD GE GH GM HR HU ID IL IN IS JP KE KG KP KR KZ LC LK LR LS LT LU LV MA MD MG MK MN MW MX MZ NO NZ OM PH PL PT RO RU SD SE SG SI SK SL TJ TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VN YU ZA ZM ZW

Designated States (Regional): AT BE CH CY DE DK EA ES FI FR GB GH GM GR IE IT KE LS LU MC MW MZ NL OA PT SD SE SL SZ TR TZ UG ZM ZW EP 1359142 A1 E C07C-311/24 Based on patent WO 200262749 Designated States (Regional): AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LT LU LV MC MK NL PT RO SE SI TR

Abstract (Basic): WO 200262749 A1

NOVELTY - New perfluorovinyl ether monomer comprises sulfonamide group.

DETAILED DESCRIPTION - Perfluorovinyl ether monomer of formula (1) is new.

m=0-5:

n=1-5; and

R1, R2=H, 1-10C hydrocarbon group (with at most total 15 carbons and optionally substituted with halogen, OH, amino, alkoxy, carbonyl, ester, acid amide, sulfonyl and ether) or silyl with at most total 10 carbons and having at least one 1-10C hydrocarbon substituent group (when R1 and R2 are each optionally substituted 1-10C hydrocarbon

groups or substituted silyl groups, they may be bonded to each other to form a divalent group which may bond to a nitrogen atom to form a saturated or unsaturated nitrogenous hetero-ring).

INDEPENDENT CLAIMS are also included for the following:

(1) production of (1), comprising:

(i) transforming an acyl fluoride (2) into a carboxylate (3);

- (ii) performing amidation of the fluorosulfonyl group of (3) then treating with an alkali compound, to give a sulfonamide (4); and
- (iii) performing decarbonate-vinylation then treating with a protic compound;
 - (2) a sulfonamide (4);
 - (3) production of (1), comprising:
- (i) amidation of a sulfonyl fluoride (5) by reaction with an amine or metal amide, M2NR5R6 (6); and
 - (ii) treating with a protic compound;
 - (4) production of (1) comprising:
- (i) defluorinating (7) using a metal amide, M3NRxRy (8) and a catalyst; and
 - (ii) treating with a protic compound;
 - (5) a compound (7);
 - (6) production of (1) comprising:
 - (i) dehalogenating (9); and
 - (ii) treating with a protic compound; and
 - (7) compound (9).

M1=alkali metal, alkaline earth metal, quaternary ammonium or quaternary phosphonium group;

R3, R4=H, 1-10C hydrocarbon (with at most total 15 carbons and optionally substituted with halogen, OH, amino, alkoxy, carbonyl, ester, acid amide, sulfonyl and ether), silyl with at most total 10 carbons and having at least one 1-10C hydrocarbon substituent, alkali metal, alkaline earth metal, ammonium or phosphonium group (when R3 and R4 are each optionally substituted by 1-10C hydrocarbons or substituted silyl groups, they may be bonded to each other to form a divalent group which may bond to a nitrogen atom to form a saturated or unsaturated nitrogenous hetero-ring; further R3 and R4 are not both H);

R5, R6, Rx, Ry=1-10C hydrocarbon with at most 15 total carbons (optionally substituted with N, N-disubstituted amino substituted with 2 hydrocarbon groups, alkoxy and ether) or silyl with at most total 10 carbons and having at least one 1-10C hydrocarbon substituent group (R5 and/or R6 and Rx and/or Ry=3-10C secondary or tertiary alkyl or substituted silyl; they may be bonded to each other to form a divalent gp. which may bond to a nitrogen atom to form a saturated or unsaturated nitrogenous hetero-ring);

M2=H, alkali metal or alkaline earth metal; M3=alkali metal or alkaline earth metal; and X1, X2=Cl, Br or I.

USE - New perfluorovinyl ether monomer for fluoropolymers, copolymers, fluorocopolymers, copolymer films, modified copolymer films, polymer solid electrolyte films, crosslinked copolymer films and crosslinked polymer solid electrolyte films (all claimed) for electrolytes of fuel cells.

ADVANTAGE - The solid electrolyte has excellent durability and heat resistance, and high proton transport ratio.

pp; 215 DwgNo 0/1

Derwent Class: A14; A41; A85; E16; L03; X16 International Patent Class (Main): C07C-311/24

International Patent Class (Additional): C07C-303/36; C07F-007/12;

C08F-214/26; C08F-216/14; H01M-008/02

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2002 年8 月15 日 (15.08.2002)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 02/062749 A1

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 旭化

成株式会社 (ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA)

(51) 国際特許分類7: C07C 311/24, 303/36, C07F 7/12, C08F 214/26, 216/14, H01M 8/02

特願2001-343931

2001年11月8日(08.11.2001)

(21) 国際出願番号:

PCT/JP02/00854

(22) 国際出願日:

2002年2月1日(01.02,2002)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2001-25018 2001年2月1日(01.02.2001) 特願2001-30955 2001年2月7日(07.02.2001) 特願2001-278418 2001年9月13日(13.09.2001) 特願2001-342172

JP JP 2001年11月7日(07.11.2001) JP 特願2001-343780 2001年11月8日(08.11.2001)

[JP/JP]; 〒530-8205 大阪府 大阪市 北区堂島浜 1 丁目 2番6号 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

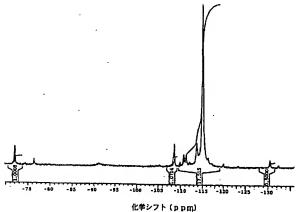
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 池田 正紀 (IKEDA, Masanori) [JP/JP]; 〒417-0801 静岡県 富士市 大渕 3 5 6-9 1 Shizuoka (JP). 星信人 (HOSHI, Nobuto) [JP/JP]; 〒416-0939 静岡県 富士市川成島 8 8-3 レジデンス富士 A-403 Shizuoka (JP). 植松 信之 (UEMATSU,Nobuyuki) [JP/JP]; 〒416-0939 静岡県 富士市 川成島 100 西アパート823 Shizuoka (JP). 古賀 健裕 (KOGA, Takehiro) [JP/JP]; 〒416-0939 静岡県 富士市 川成島 100 西アパート 1036 Shizuoka (JP).

[続葉有]

(54) Title: PERFLUOROVINYL ETHER MONOMER HAVING SULFONAMIDE GROUP

(54) 発明の名称: スルホンアミド基を有するパーフルオロビニルエーテルモノマー

$$\begin{array}{c} \mathrm{CF_2} \!\!=\!\! \mathrm{CF} \!\!-\!\! (\mathrm{OCF_2CF})_{\mathrm{m}} \!\! \mathrm{O}(\mathrm{CF_2})_{\mathrm{n}} \!\! \mathrm{SO_2NR}^{\mathrm{1}} \!\! \mathrm{R}^{\mathrm{2}} \\ \mathrm{I} \\ \mathrm{CF_3} \end{array}$$



CHEMICAL SHIFT (ppm)

(57) Abstract: A perfluorovinyl ether monomer represented by the following formula (1) (1) (wherein m is an integer of 0 to 5; n is an integer of 1 to 5; and R^1 and R^2 each independently represents hydrogen, a C_{1-10} (un) substituted hydrocarbon group, or a substituted silyl group, provided that when R^1 and R^2 each independently represents the hydrocarbon or substituted silyl group, then R^1 and R^2 may be bonded to each other to form a ring); a process for producing the monomer; a fluoropolymer obtained from the monomer and a process for producing the polymer; a polymer film obtained from the polymer; a modified polymer film or crosslinked polymer film obtained from the polymer film; and a solid polymer electrolyte film obtained from the modified polymer film or crosslinked polymer film.

- (74) 代理人: 渡邉 潤三 (WATANABE,Junzo); 〒107-0052 東京都港区 赤坂 1 丁目 3 番 5 号 赤坂アビタシオン ビル 3 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許

(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 一 国際調査報告書
- 一、請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受 領の際には再公開される。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

下記式(1)

$$CF_2 = CF - (OCF_2CF)_mO(CF_2)_nSO_2NR^1R^2$$
 (1)
 CF_3

(式中、mは0~5の整数であり;nは1~5の整数であり;R¹およびR²は、各々独立に、水素原子;炭素数1~10の無置換または置換炭化水素基;或いは置換シリル基であり、但し、R¹およびR²が、各々独立に、該炭化水素基または該置換シリル基であるときは、R¹およびR²が互いたは該置換シリル基であるときは、R¹およびR²が互いたは該置換シリルをきない。)で表されるパーフルオロビニルエーテルモノマーが開示される。また、該モノマーの製造方法、該モノマーを用いて得られるフッスを用いての製造方法、該重合体を用いて得られる変性重合体膜を用いて得られる変性重合体膜または架橋重合体膜、並びに該変性重合体膜または架橋重合体膜、並びに該変性重合体膜が開示される。

1

明 細 書

スルホンアミド基を有するパーフルオロビニルエーテルモノマー

技術分野

本発明は、パーフルオロビニルエーテルモノマーに関する。 より詳細には、本発明は、下記式(1):

$$CF_2 = CF - (OCF_2CF)_mO(CF_2)_nSO_2NR^1R^2$$

$$CF_3 \qquad (1)$$

(式中、mは0~5の整数であり;nは1~5の整数であり;R¹およびR²は、各々独立に、水素原子;無置換、または、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、アルル基、カルボニル基、エステル基、酸アミド基、カルボニル基よりなる群から選ばれる少なくとも1種の置換され、合計15個以下の炭素原子を有する、炭素数1~10の炭化水素基を置換をなくとも1個の炭素数1~10の炭化水素基を置換をして含み、合計10個以下の炭素原子を有強し、R¹およびR²が、各々独立に、
該炭素数1~10の無置換または置換炭化水素基、近いは、水素数1~10の無置換または置換炭化水素基、近いは、水素数1~10の無置換または置換炭化水素基、近い

に結合して2価の基となり、R¹およびR²と結合している窒素原子と共に、飽和または不飽和含窒素複素環を形成していてもよい。)

で表わされるパーフルオロビニルエーテルモノマーに関する。本発明のパーフルオロビニルエーテルモノマーを用いると、優れた特性を有するフッ素化重合体を製造することができる。このフッ素化重合体は種々の用途、例えば、高分子固体電解質の原料として特に好ましく用いることができる。本発明のパーフルオロビニルエーテルモノマーを原料として用いて得られる高分子固体電解質は、耐久性に優れている上、優れた耐熱性および高いプロトン伝導率を示すので、燃料電池用の電解質として特に好ましく用いることができる。

また本発明は、上記パーフルオロビニルエーテルモノマーの製造方法、上記パーフルオロビニルエーテルモノマーを用いて得られるフッ素化重合体およびその製造方法、上記重合体を用いて得られる重合体膜、上記重合体膜を用いて得られる変性または架橋重合体膜を用いて得られる高分子固体電解質膜に関する。

従来技術

フッ素樹脂は種々の用途に用いられているが、近年、燃料電池の材料としての用途が注目されている。

燃料電池の実用化に向けての研究は近年特に盛んになって

いるが、中でも、電解質として高分子固体電解質膜を用いる燃料電池は、小型軽量化が可能であり、かつ比較的低温でも高い出力密度が得られることから注目されており、特に自動車に関連した用途に向けての開発が進められている。

このような高分子固体電解質膜の材料として用いられる高分子には、優れたプロトン伝導度、適度な保水性、水素や酸素等に対する高いガスバリア性などが要求される。このような要件を満たす材料として、スルホン酸基やホスホン酸基を主鎖または側鎖の末端に有する高分子が種々検討され、多くの材料が提案されている(O. Savadogo、 Jounal of New Materials for E1ectrochemical Systems I、47-66(1998)(カナダ)などを参照)。

しかし、実際の燃料電池の運転時には、高分子固体電解質膜の近傍にある電極において、高い酸化力を有する活性酸素種が発生するので、高分子固体電解質膜は過酷な酸化性条件下に置かれることになる。従って、長期に亙って燃料電池を安定に運転するためには、高分子固体電解質膜の材料として、酸化性条件下での耐久性に優れた材料を用いることが必要である。

現在までに高分子固体電解質膜の材料として提案されている材料の多くは炭化水素系材料である。しかし、炭化水素系材料は上記のような酸化性条件下での耐久性が不充分である

4

ため、炭化水素系材料を高分子固体電解質膜の材料として用いる燃料電池は、運転の初期においては優れた特性を示すものが多いが、長期の運転に関しては不安を指摘される例が多い。このため現在、燃料電池の実用化に向けての検討においては、高分子固体電解質膜の材料としてフッ素樹脂が主に採用されている。中でも、下記式(I):

$$-(CF2CF2)k-(CF2CF)1-(OCF2CF)m 1O(CF2)n1SO3H (I)$$

$$CF3$$

(式中、m¹、n¹は正の整数である。)

で表されるパーフルオロポリマーが広く用いられている。このポリマー (I) は、下記式 (II):

$$CF_2 = CF - (OCF_2CF)_m 1O(CF_2)_n 1SO_2F$$

 CF_3 (I I)

(式中、m¹、n¹は正の整数である。)

で表されるパーフルオロビニルエーテルモノマーと、テトラフルオロエチレン(TFE)との共重合体を加水分解反応に付すことによって得られる。この加水分解反応は、上記共重合体をNaOHやKOH等のアルカリ性物質により処理することにより、上記共重合体の側鎖末端の一SO₂F基を一SO₃Na基、一SO₃K基等に変換した後、塩酸などの酸により処理して遊離スルホン酸基(一SO₃H)に変換すると

いう方法によって行われる。

上記ポリマー(I)を原料として高分子固体電解質膜を製造する場合には、通常、上記共重合体を溶融成型などにより製膜し、得られた膜を上記加水分解反応に付すという方法が用いられている。

上記ポリマー(I)のうち、 $m^1=1$ 、 $n^1=2\sim3$ であるポリマーが特に広く用いられている。このポリマーは、上記モノマー(II)のうち $m^1=1$ 、 $n^1=2\sim3$ であるものを原料として製造される。このようなモノマーは、下記スキームに示す方法で製造されている。

即ち、フルオロスルホニル基を有するアシルフルオリドを 2分子のヘキサフルオロプロピレンオキシドと反応させ、得 られた中間体を炭酸ナトリウムで処理すると、フルオロホルミル基1個とフッ素原子1個が脱離してパーフルオロビニル基が形成され、目的のパーフルオロビニルエーテルモノマーが得られる(この反応のように、カルボキシル基またはそれに類する基1個と、他の1個の脱離基を脱離させ、炭素一炭素二重結合を生成させることを、以降「脱炭酸ービニル化」と称する)。

上記ポリマー(I)においては、m¹は小さい方が好ましい。そのようなポリマーを製膜して得られる重合体膜は、イオン交換基として機能するスルホン酸基の密度を高くしても、充分に高い強度を有する。このため、上記のようなポリマーは、イオン伝導度が高く、機械的強度に優れた高分子固体電解質膜の製造に適する。

このことから、上記ポリマー(I)においては $m^1=0$ であることが特に好ましいと考えられる。このようなポリマーは、下記式(III):

CF₂=CFO(CF₂)_nSO₂F (III)
(式中、nは2または3である。)

で表わされるパーフルオロビニルエーテルモノマーをTFE と共重合することにより製造できる。

上記の方法によれば、上記モノマー (III) は下記式 (IV):

 $CF_3CF(COF)O(CF_2)_nSO_2F(IV)$

7

(式中、nは2または3である。)

で表わされる化合物を脱炭酸ービニル化することにより得られると類推される。しかし実際には、上記化合物(IV)を炭酸ナトリウムで処理すると、副反応である環化反応が進行し、5 員環または6 員環を有する副生物が多量に生成するため、目的のモノマー(III)の収率は極めて低いことが知られている。実際、n=3の場合、環化反応のためモノマー(III)の収率は高々50%程度であり、n=2の場合に至っては、実質的に環化反応のみが進行してしまい、モノマー(III)はほとんど得られない。

この環化反応を抑制し、モノマー(III)の収率を向上する方法はこれまでにも種々提案されている。例えば、日本国特開昭 5 7 - 2 8 0 2 4 号明細書には、下記式:

FCOCF₂SO₂F

で表わされるアシルフルオリドを下記式 (V):

$$CICF_2CF-CF_2$$
 (V)

で表わされるエポキシドと反応させて、下記式:

CICF₂CF (COF) OCF₂CF₂SO₂F で表わされる化合物を得、これを脱炭酸ービニル化すること により上記モノマー(III) (n=2)を得る方法が開示 されている。しかしこの方法は、上記エポキシド (V) の製 造方法が繁雑であるという欠点を有している。

国際出願公開公報第WO98/43952号明細書には、 上記化合物 (IV) (n=2) をNaOHと反応させて下記式:

CF₃CF (CO₂Na) OCF₂CF₂SO₃Na で表わされる化合物に変換し、これを加熱処理して脱炭酸ー ビニル化することにより、下記式 (VI):

CF2=CFOCF2CF2SO3Na (VI)で表わされるスルホン酸塩を製造する方法が記載されている。しかし、スルホン酸塩(VI)は蒸留による精製ができないので、高純度のスルホン酸塩(VI)を工業的規模で得ることが困難である。この文献ではスルホン酸塩(VI)の精製を溶媒による洗浄のみにより行っているが、この精製方法ではスルホン酸塩(VI)を十分精製することができない。

またこの文献には、上記スルホン酸塩(VI)自体をTF Eと共重合させて共重合体を得る方法が開示されているが、 この方法によって得られる塩型のスルホン酸基を有する共重 合体や、それを酸で処理して得られる遊離スルホン酸基を有 する共重合体は、溶融流動性や熱安定性に乏しく、製膜が困 難であるという欠点を有している。

またこの文献は、上記スルホン酸塩 (VI) は既知の方法により上記モノマー (III) (n=2) に変換することができることを開示しているが、この方法はプロセスが繁雑な

上、各工程の収率も低く、モノマー(III)の精製も困難であるので実用的ではない。

また日本国特公昭47-2083号明細書には、上記化合物(IV)(n=2)を炭酸ナトリウムで処理することにより上記環化反応を選択的に行ない、下記式:

で表わされる環化反応生成物を得、これをNaOCH₃と反応させて上記スルホン酸塩(VI)を得る方法が記載されているが、この方法は上記国際出願公開公報第WO98/43 952号明細書の方法と同様の問題を有する。

以上から明らかなように、有用なモノマーである上記モノマー(III)を効率よく製造する方法は従来知られておらず、このためm¹ = 0 である上記ポリマー(I)の実用的な製造方法はこれまで知られていなかった。その結果、燃料電池の性能を十分に高めることができなかった。

ところで、燃料電池の運転はより高温で行うことが好ましいとされている。これは、原理的に発電効率が向上することや、排出される高温の排気ガスから熱を回収し、暖房などに利用できること等による。このため、電解質として用いる高分子固体電解質膜の材料は、高温において優れた特性を示すことが求められる。

しかし、従来燃料電池の高分子固体電解質膜の材料として用いられていたポリマーは、高温での特性、特に機械的強度が不充分であった。例えば、k/l=3~10、m¹=1およびn¹=2である上記ポリマー(I)を原料として用いた高分子固体電解質膜は、高温での機械的強度が不充分である。従って、そのような高分子固体電解質膜を用いた燃料電池を高温、例えば100℃以上の温度で運転することは困難である。このため現在、高分子固体電解質膜の材料の高温における特性、即ち耐熱性の改善が望まれている。

ポリマーの耐熱性を向上させる手段として有効なものの一つとして、架橋構造を導入し、架橋重合体とすることを挙げることができる。上記ポリマー(I)のような、スルホン酸基を有するポリマーの膜に対応する架橋重合体膜の例としては、ビススルホニルイミド結合(一SO₂NHSO₂ー)により架橋された架橋重合体膜を挙げることができる。このような架橋重合体膜を得る方法に関しては、これまでに種々の提案がなされている。

日本国特開2000-188013号および2001-3 19521号明細書、並びに日本国特表2001-5224 01号明細書には、側鎖末端に-SO2F基を有する重合体 の膜を架橋剤と反応させることによりビススルホニルイミド 結合を導入し、架橋重合体膜を得る方法が開示されている。

上記日本国特開2000-188013号明細書および日

本国特表 $2\ 0\ 0\ 1\ -\ 5\ 2\ 2\ 4\ 0\ 1\ 5\ 9\ m$ 翻書は、側鎖末端に $-\ S\ O_2\ F$ 基を有するポリマーの膜を架橋剤で処理することにより、架橋重合体膜を得る方法を開示している。この方法では、下記式($V\ I\ I$)に示すように、二官能性架橋剤($A\ -\ 2$)の $2\ 0\ 0\ C\ H_3$) $_3\ S\ i\ N\ (N\ a)$ 基を、ポリマー($A\ -\ 1$)の側鎖末端にある $-\ S\ O_2\ F$ 基と反応させることにより、 $2\ 0\ 0\ C\ A\ C\ A$

Polymer-
$$CF_2SO_2F + (CH_3)_3Si-N(Na)-SO_2-(CF_2)_p-SO_2-N(Na)-Si(CH_3)_3$$
(A-1) (A-2)

Polymer
$$-CF_2SO_2-N-SO_2-(CF_2)_p-SO_2-N-SO_2CF_2$$
-Polymer (A-3)

(N I I).

この方法は、-SO₂F基の反応性を利用して架橋構造を 導入する方法である。しかし、この方法を工業的規模で実施 する場合、二官能性架橋剤(A-2)の原料である、下記式 (VIII):

 $FSO_2-(CF_2)_p-SO_2F$ (VIII) で表わされる化合物を、工業的規模で入手することが困難であるという問題がある。

また、二官能性架橋剤 (A-2) はイオン結合を有する高極性物質である。これに対し、ポリマー (A-1) のような

パーフルオロポリマーは低極性物質であり、極性の低いフッ素含有溶媒以外にはほとんど溶解、膨潤しない。即ち、ポリマー (A-1) に対する架橋剤 (A-2) の親和性が低い。このため、架橋剤 (A-2) をポリマー (A-1) 中に短時間で均一に浸透させ、効率的に架橋構造を導入することは困難である。

また、上記日本国特開20000-1880013号および2001-319521号明細書、並びに日本国特表2001-522401号明細書は、側鎖末端に一S〇2F基を有するポリマーに架橋構造を導入するための架橋剤としてNaN(SiMe3)2などを用いることを用いることを開示している。しかし、これらの架橋剤も上記架橋剤(A-2)と同様パーフルオロポリマーなどの低極性ポリマとは困難である。その結果、架橋反応がポリマー表面およびで対する親和性が低く、その中に短時間で浸透させることでが出まる。その結果、架橋反応がポリマー表面およびである。との話果、架橋反応が起こりやすいのはポリマーの表面は、架橋反応が起こりやすいのはポリマーの表面は、

また、上記日本国特表 2 0 0 1 - 5 2 2 4 0 1 号明細書は、上記のようなイオン性架橋剤を、側鎖末端に - S O 2 F 基を有するポリマーと混練し、得られた組成物を製膜する方法を開示している。しかしこの方法では、低極性のポリマー全体

に高極性のイオン性架橋剤を均一に分散させることが困難である。その上この方法では、高温で混練を行う際に架橋反応が進行し、架橋重合体が生成してしまう。一般に架橋重合体を製膜することは困難であるため、実際には、この方法を実施することは困難である。

上記日本国特開2000-188013号明細書は、-S 〇₂下基を有するパーフルオロポリマーと、NH基を含むス ルホンアミド基を有するパーフルオロポリマー(このポリマーは、前者のパーフルオロポリマーをアンモニアまたは1級 アミンと反応させることによって得られる)を直接反応させることにより、架橋重合体を得る方法を開示している。しかし、本発明者らが検討した結果、この反応を効果的に行うことは、実際には極めて困難であることが判明した。その理由は明らかではないが、両ポリマー間の相溶性が乏しいことが主たる原因と推定される。

また上記日本国特開 2 0 0 1 - 3 1 9 5 2 1 号明細書は、アンモニアを架橋剤として用いる方法を開示している。しかし、本発明者らが検討した結果、アンモニアは反応性が低いため、この方法においてはアンモニアを過剰に用いる必要がある。このため、形成されるビススルホニルイミド結合の量(架橋密度)を制御することが極めて難しい。

またこの方法を実施する際、反応系内に水が混入すると、 その水が優先的に-SO₂F基と反応してスルホン酸基(ア ンモニウム塩型)が生成し、ピススルホニルイミド結合の形成は抑制されてしまう。即ち、極微量の水が反応系内に混入しただけで、ピススルホニルイミド結合よりもスルホン酸基が生成しやすくなり、架橋構造を効果的に導入することができなくなってしまうという問題がある。

国際出願公開公報第WOO1/27167号明細書は、側鎖末端に一SO2F基を有する重合体の膜中の一SO2F基を全てアミド化してスルホンアミド基とし、このスルホンアミド基を上記化合物(VIII)と反応させることにより、架橋重合体膜を得る方法を開示している。

しかし、ポリマーに架橋構造を導入すると、一般にポリマー鎖の運動が抑制される。このため、工業的に有利な条件下では、この文献に記載された方法でスルホンアミド基を全て化合物 (VIII)と反応させることは困難であり、この方法で得られる架橋重合体は実際には未反応のスルホンアミド基が残存していると考えられる。後述するように、スルホンアミド基を有するポリマーはプロトン伝導度が低いため、この方法で得られる架橋重合体は高分子固体電解質の原料として適当でない。

スルホンアミド基の反応率を上げるため、大過剰の上記化合物 (VIII) を用いても、化合物 (VIII) の一方の - SO₂F基のみが反応する確率が高くなるだけで、効果的 に架橋構造を導入することはできない。

また上記したように、化合物(VIII)そのものを工業 規模で入手することは困難である。

上記4件の文献、即ち、上記日本国特開2000-188 013号および2001-319521号明細書、日本国特表2001-522401号明細書、並びに国際出願公開公報第WO01/27167号明細書は、いずれも固体であるポリマー膜を架橋剤と反応させる方法を開示するものである。しかし、一般にこのような不均一系で反応を行う方法では、架橋剤のポリマー中への拡散速度が遅いため、架橋処理を高速で行うことができず、架橋重合体膜の生産性を高めることが困難である。

また、ポリマーの表面と内部とでは反応場としての環境が 著しく異なっており、通常反応は表面でのみ起りやすいため、 ポリマーの表面付近のみに架橋構造が導入され、ポリマー内 部には導入されにくい。このため、上記のような方法では、 均質な、高品質の架橋重合体を得ることが困難である。

SO2F基を有するパーフルオロポリマーのような低極性ポリマーを、上記の架橋剤のような高極性の試薬と反応させる場合、ポリマー全体で均一に反応を行うことは特に困難となる。この場合、ポリマー中の最初に反応した部位の周辺でのみ反応が進行しやすくなる傾向が認められる場合がある。これは以下のような理由によると考えられる。

ポリマーと試薬の反応により、未反応ポリマーよりも極性

の高い生成物が生じる場合、この生成物の試薬との親和性は、 未反応ポリマーと試薬との親和性よりも高い。この結果、こ の生成物が最初に生じた部位の周辺に未反応の試薬が集中し、 この部位での反応が促進される。

いずれにしても、固体であるポリマー膜を架橋剤と反応させる上記のような方法では、均質な、高品質の架橋重合体膜を得ることは困難である。

日本国特開昭 5 0 - 9 2 3 3 9 号明細書には、ハロスルホニル基を有するポリマーをジアミンまたはポリアミンと反応させ、スルホンアミド基を形成させることによって架橋構造を導入する方法が開示されている。

日本国特開昭 5 4 - 4 3 1 9 2 号明細書には、不飽和炭化水素基が結合している窒素原子を含むスルホンアミド基を有するポリマーを、ビニル化合物の存在下に重合反応に付すことにより、架橋構造を導入する方法が開示されている。

しかし、これらの方法は燃料電池用の高分子固体電解質膜の原料として用いられる架橋ポリマーの製造を意図したものではないので、得られる架橋ポリマーには炭化水素基が導入される。この炭化水素基は活性酸素によって酸化分解されてしまうため、この架橋ポリマーの酸化性条件下での耐久性は不充分である。従って、この架橋ポリマーを原料とする高分子固体電解質膜を用いた燃料電池を長期に亙り安定に運転することは困難である。

米国特許第3784399号明細書は、側鎖として一SOュF基を有するフッ素原子含有ポリマーの膜の表面をアンモニアガスで処理することにより、膜表面の一SOュF基のみを一SOュNHュ基に変換した膜が、食塩電解の用途に好適に使用し得る事を開示している。

しかしながら、この方法で得られる重合体膜は、 $-SO_2$ F基と $-SO_2$ N H_2 基の両者が膜全体に均一に分布した構造ではなく、 $-SO_2$ F基を有するポリマーの層と、 $-SO_2$ N H_2 を有するポリマーの層を含む複層構造を有している。従って、この重合体膜においては、近接した $-SO_2$ F基と $-SO_2$ N H_2 基の間での相互作用を利用して、膜全体を均一に変性させることはできない。

また、一S〇₂NH₂基は弱酸性の基であるが、本発明者らが検討したところ、この基をイオン交換基として有する重合体膜のプロトン伝導度は、遊離スルホン酸基をイオン交換基として有する重合体膜のプロトン伝導度の高々1/25程度である。従って、上記の一SО₂NH₂基を有するポリマーの層は、実際には電気抵抗性の層として機能する。この結果、上記の重合体膜はプロトン伝導度が低く、高分子固体電解質膜としての用途には適していない。

上記のような-SO2NH2基を有するポリマーは、スルホンアミド基を有するモノマーを重合させることにより得ることができると考えられる。そのような、スルホンアミド基

を有するモノマーに言及している文献は以前にもあるが、実際にそのようなモノマーを製造した旨の記載を含むものはなかった。

例えば、日本国特開昭 5 7 - 2 8 1 1 9 号明細書には、酸性基を有するフッ素化ポリマーの原料として、種々のパーフルオロビニルエーテルモノマーの構造式が開示されている。この構造式にはスルホンアミド基を有するパーフルオロビニルエーテルモノマーなど、極めて広範な化合物が含まれている。しかしこの文献には、それらのモノマー、特にスルホンアミド基を有するモノマーの構造、製造方法および特性に関する具体的な記載はない。またこの文献には、スルホンアミド基を有するモノマーを用いて得られるフッ素化ポリマーや、そのフッ素化ポリマーの耐熱性を向上させることについての記載もない。

また、米国特許第3282875号明細書には、下記式

$$CF_2 = CF - (OCF_2CF)_qOCF_2CF_2SO_2M$$
 CF_3
 CF_3

(式中、

qは1~3の整数であり、

MはF、OH、アミノ基、ON a 基等を表わす。)で表されるパーフルオロビニルエーテルモノマーと、それを用いて得られる共重合体が開示されている。

またこの文献は、置換基Mとしてフッ素原子を有するモノマー(IX)を用いて製造した共重合体をアンモニアで処理することにより、一SO₂NH₂基を有する共重合体を製造する方法を開示している。しかし、置換基Mとしてアミノ基を有するモノマー(IX)の具体例およびその合成法については記載されていない。

この文献の実施例では、置換基Mとして水酸基やONa基等を有するモノマー(IX)が、いずれも置換基Mとしてフッ素原子を有するモノマー(IX)から合成されている。そこで本発明者らは、この方法と同様に、置換基Mとしてフッ素原子を有するモノマー(IX)をアンモニアやジエチルアミンを反応させ、置換基Mとしてアミノ基やジエチルアミンを反応させ、置換基Mとしてアミノ基やジエチルアミンを有するモノマー(IX)の合成を試みたが、複雑な混合物が得られるのみで、目的物を得ることはできなかった。得られた反応混合物の分析結果より、これはアンモニアやジエチルアミンがモノマー(IX)のパーフルオロビニル基と反応したためと推定される。

以上から明らかなように、本発明のパーフルオロビニルエーテルモノマー(1)のような、スルホンアミド基を含むパーフルオロビニルエーテルを効率よく製造する方法は、これまで全く知られていなかった。

以上から明らかなように、高い耐熱性と高いプロトン伝導 度を有し、燃料電池用高分子固体電解質膜の原料として好適 に用いることのできるフッ素樹脂は、これまで得られていなかった。

発明の概要

このような状況下において、本発明者らは、高い耐熱性と高いプロトン伝導度を有し、燃料電池用高分子固体電解質膜の原料として好適に用いることのできるフッ素樹脂およびその原料となるモノマーを開発すべく鋭意研究を行った。その結果意外にも、本発明者らは、スルホンアミド基を含む特定の新規な構造を有するパーフルオロビニルエーテルモノの製造に初めて成功すると共に、このモノマーを用いると、高い耐熱性と高いプロトン伝導度を有するフッ素化重合体により、高い耐熱性を有する高分子固体電解質を得ることができることを見出した。以上の知見に基づき、本発明を完成した。

従って、本発明の1つの目的は、特定の新規な構造を有し、 燃料電池用高分子固体電解質膜の原料として好適に用いるこ とのできるフッ素樹脂の原料となるパーフルオロビニルエー テルモノマーを提供することにある。

本発明の他の1つの目的は、上記パーフルオロビニルエーテルモノマーの製造方法を提供することにある。

本発明の他の1つの目的は、上記パーフルオロビニルエー

テルモノマーを用いて得られるフッ素化重合体を提供することにある。

本発明の他の1つの目的は、上記フッ素化重合体の製造方法を提供することにある。

本発明の他の1つの目的は、上記フッ素化重合体を用いて得られる重合体膜を提供することにある。

本発明の他の1つの目的は、上記フッ素化重合体を用いて 得られる高分子固体電解質膜を提供することにある。

本発明の上記及びその他の諸目的、諸特徴ならびに諸利益は、添付の図面を参照しながら行う以下の詳細な説明及び請求の範囲の記載から明らかになる。

図面の簡単な説明

図 1 は、実施例 2 で合成した 2 元共重合体の^{1 ®} F - N M R スペクトルである。

図2は、実施例16で合成した変性処理前の3元共重合体の18F-NMRスペクトルである。

発明の詳細な説明

本発明によれば、下記式(1)で表されるパーフルオロビ ニルエーテルモノマー。

$$CF_2 = CF - (OCF_2CF)_mO(CF_2)_nSO_2NR^1R^2$$
 CF_3
 (1)

(式中、

mは0~5の整数であり;

nは1~5の整数であり;

R¹およびR²は、各々独立に、水素原子;無置換、または、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、アルコキシ基、カルボニル基、カルボニル基より置換基により置換基により置換基により置換基により置換基により置換基により置換を有する、炭素数1~10の炭化水素基・で含み、合計10の炭素原子を有する置換シリル基であり、企りの炭素原子を有する置換シリル基であり、企り、R¹およびR²が、各々独立に、該炭素数1~10の無置換または置換炭化水素基、或いはには、R¹およびR²が、路域が互いに、カル基であり、R¹およびR²が、路域が互いに、カル基であり、R¹およびR²と結合している窒素原子と共に、の和または不飽和含窒素原子と共に、い。)

が提供される。

次に、本発明の理解を容易にするために、まず本発明の基本的諸特徴及び好ましい態様を列挙する。

下記式(1)で表されるパーフルオロビニルエーテルモノマー。

$$CF_2 = CF - (OCF_2CF)_mO(CF_2)_nSO_2NR^1R^2$$

$$CF_3$$

$$(1)$$

(式申、

mは0~5の整数であり;

 $n は 1 \sim 5 の整数であり;$

R¹およびR²は、各々独立に、水素原子;無置換、または、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、アルコキシ基、カルボニル基、エステル基よりなる群から選ばれる少なくとも1種の置換基により置換され、合計15個以下の炭素原子を有する、炭素数1~10の炭化水素基を置換をして含み、合計10個以下の炭素原子を有する置換シリル基であり、但し、R¹およびR²が、各々独立に、該炭素数1~10の無置換または置換炭化水素基、或いは該置換シリル基であるときは、R¹およびR²が互いに結合して2価の基となり、R¹およびR²と結合している窒素原子と共に、飽和または不飽和含窒素複素環を形成していてもよい。)

- 2. 式(1)中のR¹が水素原子、該炭素数1~10の無置換または置換炭化水素基、或いは該置換シリル基であり、式(1)中のR²が水素原子または該置換シリル基であることを特徴とする、前項1に記載のモノマー。
- 3. 式(1)中のR¹およびR²の少なくとも一方が該置換 シリル基であることを特徴とする、前項1に記載のモノマー。
- 4. 式(1) 中のR¹およびR²の少なくとも一方が水素原子であることを特徴とする、前項1に記載のモノマー。
- 5. 式(1)中のR¹およびR²がいずれも水素原子である ことを特徴とする、前項1に記載のモノマー。
- .6. 前項1に記載のモノマーを製造する方法であって、 (i)下記式(2):

$$\begin{array}{c|cccc} FC - CF - (OCF_2CF)_m O(CF_2)_n SO_2F \\ \parallel & \parallel & \parallel \\ O & CF_3 & CF_3 \end{array} \tag{2}$$

(式中、mおよびnは上記式(1)において定襲した 通りである。)

で表されるアシルフルオリドを、下記式 (3):

2 5

$$M^{1}OC-CF-(OCF_{2}CF)_{m}O(CF_{2})_{n}SO_{2}F$$
 $II \qquad I \qquad (3)$
 $O \quad CF_{3} \qquad CF_{3}$

(式中;

mおよびnは上記式(1)において定義した通りであり;

M¹はアルカリ金属、アルカリ土類金属、4級アンモニウム基または4級ホスホニウム基である。)で表されるカルボン酸塩に変換し;

(ii) 該カルボン酸塩(3) のフルオロスルホニル基のアミド化反応、次いで場合によりアルカリ性化合物処理を行うことにより、下記式(4):

(式中、

mおよびnは上記式(1) において定義した通り であり;

M¹は上記式(3)において定義した通りであり;

R³およびR⁴は、各々独立に、水素原子;無置 換、または、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、ア ルコキシ基、カルボニル基、エステル基、酸アミド 基、スルホニル基およびエーテル基より置換され、合計15個以下の炭素原子を有する、炭素数1~10の炭化水素基;少なくとも1個の炭素数1~10の炭化水素基を置換をして含み、合計10個以下の炭水素を置換をして含み、合計10個以下の炭素原子を有する置換をリル基;アルカリ金属;アルカリ土類金属;アンモニウム基;が、各々独立に、該炭素数1~10の無置換または置換炭化水素基、或いは防力ときは、R³およびR4が互いに結合して2価の基となり、R³およびR4が互いに結合して2価の基となり、R³およびR4が百いに結合して2価の基となり、R³およびR4が同時に水素原子と共に、飽和または不飽和含窒素で形成していてもよく、よのい。)

で表されるスルホンアミドを得;

(iii) 該スルホンアミド(4) を脱炭酸ービニル化、次いで場合によりプロトン性化合物で処理する ことを含む方法。

7. 式(1)、(2)、(3) および(4) 中のmがいずれ も 0 であることを特徴とする、前項 6 に記載の方法。 8. 下記式(4)で表されるスルホンアミド。

$$M^{1}OC-CF-(OCF_{2}CF)_{m}O(CF_{2})_{n}SO_{2}NR^{3}R^{4}$$
 $II \quad I \quad I \quad (4)$
 $O \quad CF_{3} \quad CF_{3}$

(式中、

mは0~5の整数であり;

 $n は 1 \sim 5 の整数であり;$

M¹はアルカリ金属、アルカリ土類金属、4級アンモニウム基または4級ホスホニウム基であり;

R®およびR4は、各々独立に、水素原子;無置換、または、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、アルル 基、カルボニル基、エステル基、酸アミド基、カルボニル基はガエーテル基より置換され、カルボニルをも1種の置換基により置換され、合計15個以下の炭素原子を有する、炭素数1~10の炭化水素基を置換基とも1個の炭素原子を有する炭素を有する炭素を100炭素を100炭素を100炭素を100炭素を100炭素を100炭素が100炭素が100炭素が100炭素が100炭素が100炭素が100炭素が100炭素が100炭素が100炭素が100炭素が100炭素が100炭素が100炭素が100炭素が100炭素が100炭素数1~100炭素を100炭素数1~100炭素を100炭素数1~100炭素を100炭素数1~100炭素を100炭素数1~100炭素を100炭素数1~100炭素数1~100炭素を100炭素数1~100炭素を100炭素数1~100炭素を100炭素数1~100炭素素を100炭素数1~100炭素を100炭素を100炭素を1

よびR⁴と結合している窒素原子と共に、飽和また は不飽和含窒素複素環を形成していてもよく、また R³およびR⁴が同時に水素原子であることはな -い。)

9. 式 (4) 中のmが 0 であることを特徴とする、前項 8 に 記載のスルホンアミド。

10. 式(1)中のR¹およびR²がいずれも水素原子であるか、または式(1)中のR¹およびR²が、各々独立に、水素原子;無置換、または、2個の炭化水素基を置換基として含むN,N-二置換アミノ基、アルコキシ基およびエーテル基よりなる群から選ばれる少なくとも1種の置換基により置換され、合計15個以下の炭素原子を有する、炭素数1~10の炭化水素基;または該置換シリル基であり、但し、R¹およびR²のうち少なくとも1つは、炭素数3~10の2級または3級のアルキル基、または該置換シリル基である、前項1に記載のモノマーを製造する方法であって、

下記式(5):

$$CF_2=CF-(OCF_2CF)_mO(CF_2)_nSO_2F$$

$$CF_3$$
(5)

(式中、mおよびnは上記式(1)において定義した

• • • •

29

通りである。)

で表されるスルホニルフルオリドをアミド化、次いで場合に より3プロトン性化合物で処理することを含み、

該アミド化を、該スルホニルフルオリド(5)を下記式(6):

$$M^{2}NR^{5}R^{6}$$
 (6)

(式中、

M²は水素原子、アルカリ金属またはアルカリ土 類金属であり;

R⁶およびR⁶は、各々独立に、無置換、または、2個の炭化水素基を置換基として含むN,N-二置換アミノ基、アルコキシ基およびエーテル基よりなる群から選ばれる少なくとも1種の置換基により置換され、合計15個以下の炭素原子を有する、炭素数1~10の炭化水素基を置換基として含み、合計10個以下の炭素原子を有する置換シリル基であり、但し、R⁵およびR⁶のうち少なくとも1つは、炭素数3~10の2級または3級のアルキル基または該置換シリル基であり、

R⁵およびR⁶が互いに結合して2価の基となり、 R⁵およびR⁶と結合している窒素原子と共に、飽 和または不飽和含窒素複素環を形成していてもよ (,,,/)

で表されるアミンまたは金属アミドと反応させることによっ て行う

ことを特徴とする方法。

11.前項1に記載のモノマーの製造方法であって、下記式(7):

$$CF_3CHF$$
- $(OCF_2CF)_mO(CF_2)_nSO_2NR^1R^2$
 CF_3
 (7)

(式中、m、n、R¹およびR²は上記式(1)において定義した通りである。)

で表される化合物を脱フッ化水素、次いで場合によりプロトン性化合物で処理することを含み、

該脱フッ化水素を、該化合物(7)を下記式(8): M³N R * R * (8)

(式中、

M³ はアルカリ金属またはアルカリ土類金属であり;

R*およびR*は、各々独立に、無置換、または、 2個の炭化水素基を置換基として含むN,N-二置 換アミノ基、アルコキシ基およびエーテル基よりな る群から選ばれる少なくとも1種の置換基により置換され、合計15個以下の炭素原子を有する、炭素数1~10の炭化水素基;または、少なくとも1個の炭素数1~10の炭化水素基を置換基として含み、合計10個以下の炭素原子を有する置換シリル基であり、但し、R×およびRyのうち少なくとも1つは、炭素数3~10の2級または3級のアルキル基または該置換シリル基であり、

R×およびRッが互いに結合して2価の基となり、R×およびRッと結合している窒素原子と共に、飽和または不飽和含窒素複素環を形成していてもよい。)

で表される金属アミドと接触させることによって行うことを特徴とする方法。

12. 下記式(7)で表される化合物。

$$CF_3CHF-(OCF_2CF)_mO(CF_2)_nSO_2NR^1R^2$$
 CF_3
 (7)

()中、

mは0~5の整数であり;

nは1~5の整数であり;

R¹およびR²は、各々独立に、水素原子;無置

換、または、ハロゲン原子、水酸基、アミドルコキシ基、カルボニル基、エステル基、酸アミド基、スルホニル基およびエーテル基より置換され、合計15個以下の炭素原子を有する、炭素数1~10の炭化水素基を置換をして含み、合計10個以下の炭素原子を有する置換シリル基であり、但し、R¹およびR²が、各々独立に、該炭素数1~10の無置換または置換炭化水素基、或いは該置換シリル基であるときは、R¹およびR²が互いに結合して2価の基となり、R¹およびR²と結合している窒素原子と共に、飽和または不飽和含窒素複素環を形成していてもよい。)

13. 前項1に記載のモノマーの製造方法であって、下記式(9):

$$CF_2X^1-CFX^2-(OCF_2CF)_mO(CF_2)_nSO_2NR^1R^2$$
 CF_3
 (9)

(式中、

m、n、R¹およびR²は上記式(1) において 定義した通りであり; X¹およびX²は、各々独立に、塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子である。〉

で表される化合物を脱ハロゲン化、次いで場合によりプロトン性化合物で処理する ことを含む方法。

14. 下記式(9)で表される化合物。

$$CF_2X^1$$
— CFX^2 — $(OCF_2CF)_mO(CF_2)_nSO_2NR^1R^2$
 CF_3

(式中、

mは0~5の整数であり;

 $n は 1 \sim 5$ の整数であり:

R¹およびR²は、各々独立に、水素原子;無置換、または、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、アルコキシ基、カルボニル基、エステル基、酸アミド基、スルホニル基およびエーテル基よりなる群から選ばれる少なくとも1種の置換基により置換され、合計15個以下の炭素原子を有する、炭素数1~10の炭化水素基;或いは少なくとも1個の炭素数1~10の炭化水素基を置換基として含み、合計10個以下の炭素原子を有する置換シリル基であり、但

し、R¹およびR²が、各々独立に、該炭素数1~ 10の無置換または置換炭化水素基、或いは該置換シリル基であるときは、R¹およびR²が互いに結合して2価の基となり、R¹およびR²と結合している窒素原子と共に、飽和または不飽和含窒素複素環を形成していてもよく、

X¹およびX²は、各々独立に、塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子である。)

15. 下記式(1):

$$CF_2$$
= CF - $(OCF_2CF)_mO(CF_2)_nSO_2NR^1R^2$
 CF_3 (1)

(式中、

mは0~5の整数であり;

 $n は 1 \sim 5 の整数であり;$

R¹およびR²は、各々独立に、水素原子;無置換、または、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、アルコキシ基、カルボニル基、エステル基、酸アミド基、スルホニル基およびエーテル基よりなる群から選ばれる少なくとも1種の置換基により置換され、合計15個以下の炭素原子を有する、炭素数1~10の炭化水素基;或いは少なくとも1個の炭素数1

~10の炭化水素基を置換基として含み、合計10個以下の炭素原子を有する置換シリル基であり、但し、R¹およびR²が、各々独立に、該炭素数1~10の無置換または置換炭化水素基、或いは該置換シリル基であるときは、R¹およびR²が互いに結合して2価の基となり、R¹およびR²と結合している窒素原子と共に、飽和または不飽和含窒素複素環を形成していてもよい。)

で表されるパーフルオロビニルエーテルモノマーを単独重合 させる、またはオレフィン性不飽和結合を有する少なくとも 1種のコモノマーと共重合させる ことを特徴とする、フッ素化重合体の製造方法。

- 16. 該モノマー(1)を、テトラフルオロエチレンを包含するコモノマーと共重合させることを特徴とする、前項15に記載の方法。
- 17.前項15または16に記載の方法で製造されたフッ素化重合体。
- 18. 下記式(10): CF₂=CFO(CF₂),SO₂NR"R" (10) (式中、

pは1~5の整数であり;

RªおよびRゥは、各々独立に、水素原子;無置換、または、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、アルコキシ基、カルボニル基、エステル基、酸アミド基、スルホニル基およびエーテル基より置換され、合計15個以下の炭素原子を有する、炭素数1~10の炭化水素基を置換を出りの炭素を有するとして含み、合計10の炭素を育する置換シリル基であり、保ªおよびRゥが、各々独立に、該炭素数1~10の無置換または電換炭化水素基、或いは該関クシリル基であるときは、RªおよびRゥが互いに結合して2個の基となり、RªおよびRゥと結合している窒素原子と共に、飽和含窒素原子と共に、いるで表現を形成していてもよい。)

で表わされる少なくとも1種のモノマーに由来するモノマー単位を包含することを特徴とするフッ素化重合体。

19. 該モノマー(10) に由来するモノマー単位およびテトラフルオロエチレンに由来するコモノマー単位を包含するフッ素化共重合体であることを特徴とする、前項18に記載のフッ素化重合体。

- 20.フッ素化共重合体の製造方法であって、
- (a) 部分的または完全にフッ素化されたビニル基、および 下記式(11):

$$- S O_2 N R^7 R^8$$
 (11)

(式 中、

R⁷は水素原子;無置換、または、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、アルコキシ基、カルボニル基、エステル基、酸アミド基、スルホニル基およびエーテル基よりなる群から選ばれる少なくとも1種の置換基により置換され、合計15個以下の炭素原子を有する、炭素数1~10の炭化水素基を置換基として含み、合計10個以下の炭素原子を有する置換シリル基であり;

R®は水素原子または該置換シリル基である。)
で表わされる基を有する少なくとも1種のモノマー;
(b) 部分的または完全にフッ素化されたビニル基、および下記式(12):

$$-SO_{3}X^{3}$$
 (12)

(式中、 X ³ はフッ素原子、塩素原子または - O R ⁹ 基を表わし、 R ⁹ は該炭素数 1 ~ 1 0 個の無置換または置換炭化水素基、或いは該置換シリル基であ

38

る。)

で表わされる基を有する少なくとも1種のモノマー;および 場合により

(c) 該モノマー(a) および(b) 以外の、オレフィン性不飽和結合を有する少なくとも1種のモノマーを共重合させることを含む方法。

21. 該モノマー(a)が、下記式(13):

CF₂=CF-Rf-SO₂NR⁷R⁸ (13)
(式中、

R⁷およびR⁸は上記式(11)において定義し た通りであり;

R f は単結合;下記式(14):

$$-C_{g}X_{g}^{4}$$
 (14)

(式中、

qは1~20の整数であり;

X⁴は、各々独立に、フッ素原子;また は水素原子、塩素原子およびアルコキシ基 よりなる群から選ばれる1価の置換基であ り、但し、該1価の置換基の数は、X⁴の 数の35%以下である。)

で表される炭素数1~20のフッ素化アルキレン

基:または

3 9

::下記式(15):

$$-OC_{q}X_{2q}^{4}$$
 (15)

※ (式中、 q および X ⁴ は上記式(1 4) において ※ 定義した通りである。)

で表される炭素数1~20のフッ素化オキシアルキ: レン基であり、

該炭素数 1~20のフッ素化アルキレン基(1 *** 4)または該炭素数 1~20のフッ素化オキシアル キレン基(15)中の隣接した2個の炭素原子間の 単結合のうち少なくとも1本が、酸素原子、カルボ ニル基、スルホニル基、ビスカルボニルイミド基、 ピススルホニルイミド基およびカルボニルスルホニ ルイミド基よりなる群から選ばれる2価の置換基に よって置換されていてもよく、但し、該2価の置換 基の数は、該整数 q の 50%以下である。)

で表されるモノマーであることを特徴とする、前項20に記載の方法。

22. 該モノマー(a)が、下記式(16):

$$CF_2 = CF - (OCF_2CF)_mO(CF_2)_nSO_2NR^7R^8$$

$$CF_3 \qquad (1 6)$$

(式中、

mは0~5の整数であり;

 $n は 1 \sim 5 の整数であり;$

R⁷およびR⁸は上記式(11)において定義し た通りである。)

で表されるモノマーであることを特徴とする、前項20に記載の方法。

23. 該モノマー(a)、(b) および(c) を共重合し、 該モノマー(c) がテトラフルオロエチレンを含むことを特 徴とする、前項20~22のいずれかに記載の方法。

24. 前項20~23のいずれかに記載の方法で製造された共重合体。

25. (A) 部分的または完全にフッ素化されたビニル基、 および下記式 (11):

$$-SO_2NR^7R^8$$
 (11)

(式中、

R¹は水素原子;無置換、または、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、アルコキシ基、カルボニル基、エステル基、酸アミド基、スルホニル基およびエーテル基よりなる群から選ばれる少なくとも1種の置換基により置換され、合計15個以下の炭素原子を

有する、炭素数1~10の炭化水素基;或いは少なくとも1個の炭素数1~10の炭化水素基を置換基として含み、合計10個以下の炭素原子を有する置-換シリル基であり;

R 8 は水素原子または該置換シリル基である。) で表わされる基を有する少なくとも1 種のモノマーに由来するモノマー単位; および

(B) 部分的または完全にフッ素化されたピニル基、および 下記式(12):

$$-SO_{2}X^{3}$$
 (12)

(式中、 X ³ はフッ素原子、塩素原子または - O R ⁸ 基を表わし、 R ⁹ は該炭素数 1 ~ 1 0 の無置換または置換炭化水素基、或いは該置換シリル基である。)

で表わされる基を有する少なくとも1種のモノマーに由来するモノマー単位

よりなるスルホニル基含有モノマー単位を包含することを特 徴とするフッ素化共重合体。

26. 該モノマー単位(A) および(B)、並びにテトラフルオロエチレンに由来するコモノマー単位を包含することを特徴とする、前項25に記載のフッ素化共重合体。

27. 該モノマー単位(A)の量が、該モノマー単位(A) および(B)の合計モル量に対し0.001~50mo1% であることを特徴とする、前項25または26に記載の共重 合体。

28. 該共重合体の重量(g)を、該モノマー単位(A)および(B)の合計モル量で除することによって求められる、該スルホニル基含有モノマー単位1mol当たりの該共重合体の重量が400~1400g/molであることを特徴とする、前項25~27のいずれかに記載の共重合体。

29. 該モノマー単位(A)が、各々下記式(13):
 CF₂=CF-Rf-SO₂NR⁷R⁸ (13)
 (式中、

 R^7 および R^8 は上記式(11)において定義した通りであり;

R f は単結合;下記式(14):

$$-C_{0}X_{20}^{4}-$$
 (14)

(武中、

qは1~20の整数であり;

X⁴は、各々独立に、フッ素原子;また は水素原子、塩素原子およびアルコキシ基 よりなる群から選ばれる1個の置換基であ り、但し、該1価の置換基の数は、X⁴の 数の35%以下である。)

で表される炭素数 1 ~ 2 0 のフッ素化アルキレン 基:または

下記式(15):

$$-OC_{q}X^{4}_{2q}-$$
 (15)

(式中、 q および X ⁴ は上記式 (14) において定義した通りである。)

で表される炭素数1~20のフッ素化オキシアルキレン基であり、

該炭素数 1~20のフッ素化アルキレン基(14)または該炭素数 1~20のフッ素化オキシアルキレン基(15)中の隣接した2個の炭素原子間の単結合のうち少なくとも1本が、酸素原子、カルボニル基、スルホニル基、ビスカルボニルイミド基およびカルボニルスルホニルイミド基およびカルボニルスルホニルイミド基およびカルボニルスルホニルイミド基よりなる群から選ばれる2価の置換基によって置換されていてもよく、但し、該2価の置換基の数は、該整数 q の 50%以下である。)

で表されるモノマーに由来するモノマー単位であることを特徴とする、前項25~28のいずれかに記載の共重合体。

30. 該モノマー単位(A)が、各々下記式(16):

44

$$CF_2=CF-(OCF_2CF)_mO(CF_2)_nSO_2NR^7R^8$$
 CF_3
 (16)

(式中:

mは0~5の整数であり;

 $n は 1 \sim 5 の整数であり;$

R⁷およびR⁸は上記式(11)において定義し た通りである。)

で表されるモノマーに由来するモノマー単位であることを特徴とする、前項25~28のいずれかに記載の共重合体。

- 31. 前項24~30のいずれかに記載の共重合体またはそれを含む組成物から製造される共重合体膜。
- 32.前項24~30のいずれかに記載の共重合体またはそれを含む組成物を溶融成形することを含む、共重合体膜の製造方法。
- 33. 前項32に記載の方法によって製造される共重合体膜。
- 34. 単層膜であることを特徴とする、前項31または33に記載の共重合体膜。

- 35.前項31、33および34のいずれかに記載の共重合体膜を塩基性物質で処理することを含む、変性共重合体膜の製造方法。
- 36.前項35に記載の方法で製造された変性共重合体膜。
- 37. 前項36に記載の変性共重合体膜を、アルカリ処理および酸処理よりなる群から選ばれる少なくとも一つの処理に付すことを特徴とする、高分子固体電解質膜の製造方法。
- 38. 前項37に記載の方法で製造された高分子固体電解質膜。
- 39. 前項31、33および34のいずれかに記載の共重合体膜を塩基性物質で処理することを含む、架橋共重合体膜の 製造方法。
- 40.前項39に記載の方法で製造された架橋共重合体膜。
- 41. 前項40に記載の架橋共重合体膜を、アルカリ処理および酸処理よりなる群から選ばれる少なくとも一つの処理に付すことを特徴とする、架橋高分子固体電解質膜の製造方法。

42. 前項41に記載の方法で製造された架橋高分子固体電 解質膜。

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明のパーフルオロビニルエーテルモノマーは、下記式(1)で表される。

$$CF_2 = CF - (OCF_2CF)_m O(CF_2)_n SO_2 NR^1 R^2$$

$$CF_3 \qquad (1)$$

上記式(1)中、mは0~5の整数である。上記パーフルオロビニルエーテルモノマー(1)(以降屡々「モノマー(1)」と称する)を原料として得られるポリマーの機械的強度を向上し、またそのポリマーをイオン交換樹脂として用いる場合、そのイオン交換容量を高めるという観点からは、mは0~2が好ましく、0または1が好ましく、0が最も好ましい。

nは1~5の整数である。上記モノマー(1)自体および上記モノマー(1)を原料として得られるポリマーの化学的安定性を向上し、またそのポリマーをイオン交換樹脂として用いる場合、そのイオン交換容量を高めるという観点からは、nは2または3が好ましく、2が最も好ましい。

R¹およびR²は、各々独立に、水素原子;無置換、または、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、アルコキシ基、カル

ボニル基、エステル基、酸アミド基、スルホニル基およびエーテル基よりなる群から選ばれる少なくとも1種の置換基により置換され、合計15個以下の炭素原子を有する、炭素数1~10の炭化水素基:或いは少なくとも1個の炭素数1~10の炭化水素基を置換基として含み、合計10個以下の炭素原子を有する置換シリル基である。

R¹およびR²として用いられる無置換炭化水素基は、炭素数1~10、好ましくは1~7、特に好ましくは1~4の無置換炭化水素基である。この無置換炭化水素基の構造に特に制限はなく、直鎖状、分岐状、環状およびそれらの組み合わせなど、どのような構造を有するものであってもよい。無置換炭化水素基の例としては、アルキル基、アルケニル基、アリール基、アラルキル基等を挙げることができ、特にアルキル基が好ましい。無置換炭化水素基の具体例としては、メチル基、エチル基、プロビル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、secーブチル基、はーブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、ピニル基、アリル基、ブテニル基、シクロヘキセニル基、フェニル基、トリル基、キシリル基、ベンジル基、フェネチル基等が挙げられる。これらのうち、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基等の、炭素数1~4の低級アルキル基が特に好ましい。

R¹およびR²として用いられる置換炭化水素基は、上記 無置換炭化水素基中の少なくとも 1 個の水素原子が、ハロゲ

ン原子、水酸基、アミノ基、アルコキシ基、カルボニル基、エステル基、酸アミド基、スルホニル基およびエーテル基よりなる群から選ばれる少なくとも1種の置換基により置換された構造を有する。この置換炭化水素基が、アルコキシ基等の炭素原子を含む置換基を有する場合、その置換基中の炭素を含む、置換炭化水素基中の合計の炭素数は1~15、好ましくは1~10である。置換炭化水素基の具体例としては、2、2、2~トリフルオロエチル基、3~メトキシプロピル基等が挙げられる。

R¹およびR²として用いられる上記置換シリル基は、少なくとも1個、好ましくは2個以上、特に好ましくは3個の炭素数1~10の炭化水素基を置換基として含み、合計10個以下、好ましくは6個以下、特に好ましくは3個の炭素原子を有する。この置換シリル基中の炭化水素基の構造に特に別なく、直鎖状、分岐状、環状およびそれらの組み合ってもよい、どのような構造を有するものであってもよい。でき、特にアルキル基、アラルキル基等を挙げることができ、特にアルキル基が好ましい。置換シリル基、トリプロピルシリル基、シリル基、トリプロピルシリル基、シリル基、トリプロピルシリル基、シリル基、トリプロピルシリル基、シリル基、トリプロピルシリル基、シリル基、シリル基である。特に好ましくはトリメチルシリル基である。

本発明のパーフルオロビニルエーテルモノマー (1) にお

いては、R¹およびR²がいずれも該炭素数1~10の炭化水素基または該置換シリル基である(換言すれば、R¹およびR²がいずれも水素原子でない)ときは、R¹およびR²が互いに結合して2価の基となり、R¹およびR²と結合して2価の基となり、R¹およびR²と結合している窒素原子と共に、飽和または不飽和含窒素複素環を形成していてもよい。この含窒素複素環は、複数の窒素原子を含んでいてもよく、また、窒素原子以外のヘテロ原子、例えば酸素原子や硫黄原子を含んでいても良い。この含窒素複素環に含まれる炭素原子数は20個以内であり、好ましくは8個以内であり、特に好ましくは4個以内である。

この含窒素複素環が形成されている場合、特に、その含窒素複素環がイミダゾール環やピロール環である場合、この含窒素複素環は置換反応(例えば加水分解)を受けやすい。このため、モノマー(1)中の一SO₂NR¹R²基を最終的に遊離スルホン酸基などに変換する必要がある場合には、上記含窒素複素環が形成されているモノマー(1)を用いることが好ましい。

また、モノマー(1)中のR¹およびR²の少なくとも一方が該置換シリル基である場合、-SO₂NH-基中のプロトンの酸性が低下し解離が抑制されるので、モノマー(1)を酸に接触させることが好ましくない場合、特に好適に用いることができる。該置換シリル基は、モノマー(1)を(共)重合させて重合体とした後でも、-SO₂NH-基や

後述するビススルホニルイミド基に容易に変換することがで きるので好ましい。

一方、モノマー(1)中のR¹およびR²の少なくとも一方が水素原子であると、その水素原子は弱酸性を示す。従って、そのようなモノマー(1)を(共)重合させて得られる重合体は弱酸性の樹脂として利用することができる。また後述するように、NR¹R²基をビススルホニルイミド基等に容易に変換できるので好ましい。

また後述するように、R¹およびR²がいずれも水素原子であると、モノマー(1)を重合させた後NR¹R²基をビススルホニルイミド基に変換する場合、窒素原子上に残ったR¹基またはR²基を脱離させる必要がない。このため、モノマー(1)を重合させた後NR¹R²基をビススルホニルイミド基に変換する場合には、R¹およびR²は両方とも水素原子であることがさらに好ましい。

本発明のモノマー(1)中の-SO₂NR¹R²基の具体 例(上記含窒素複素環が形成されていないもの)を以下に列 挙する。

- $-SO_2NH_2$
- -SO,NHCH₃
- $-SO_2N(CH_3)_2$
- $-SO_2NHC_2H_5$
- S O $_{\rm 2}$ N H C H $_{\rm 2}$ C H $_{\rm 2}$ C H $_{\rm 3}$

- -SO₂NHCH (CH₃)₂
- $-SO_2N(CH_3)C_2H_5$
- $-SO_2N(C_2H_5)_2$
- -SO₂NHCH₂CH₂CH₂CH₃
- -SO₂NHCH₂CH(CH₃)₂
- -SO, NHCH (CH₃) CH₂CH₃
- -SO₂NHC (CH₃)₃
- -SO₂N (CH₃) CH₂CH₂CH₃
- $-SO_2N(CH_2CH_2CH_3)_2$
- $-SO_2N[CH(CH_3)_2]_2$
- S O 2 N H C H 2 C H 2 C H 2 C H 3 C H 3
- $-SO_2NHCH_2C$ (CH₃)₈
- -SO2NHCH2CH2CH2CH2CH3
- $-SO_2N$ (CH₂CH₂CH₂CH₃)₂
- $-SO_2N[Si(CH_3)_3]_2$
- .-SO₂NHSi(CH₃)₃
- -SO₂N(CH₃)Si(CH₃)₃

$$-SO_{2}NH \longrightarrow CH_{3}$$

更に、本発明のモノマー(1)中の $-SO_2NR^1R^2$ 基において、 R^1 および R^2 が互いに結合して2 価の基となり、 R^1 および R^2 と結合している窒素原子と共に、飽和または不飽和含窒素複素環を形成している例を以下に列挙する。

次に、本発明のパーフルオロビニルエーテルモノマー (1) の製造方法について説明する。

本発明のパーフルオロビニルエーテルモノマー (1) は 種々の方法で製造可能であるが、特に、以下に述べる製造方

法1~4によって効率よく製造することができる。

以降、製造方法1~4につき説明する。

• 製造方法 1

第10 製造方法は、

(i)、下記式(2):

(式中、mおよびnは上記式 (1) において定義した 通りである。)

で表されるアシルフルオリドを、下記式(3):

$$M^{1}OC-CF-(OCF_{2}CF)_{m}O(CF_{2})_{n}SO_{2}F$$
|| | | (3)

(式中、

mおよびnは上記式(1)において定義した通りであり;

M¹はアルカリ金属、アルカリ土類金属、4級アンモニウム基または4級ホスホニウム基である。)で表されるカルボン酸塩に変換し;

(ii) 該カルボン酸塩(3) のフルオロスルホニル基のアミド化反応、次いで場合によりアルカリ性化合物処理を行うことにより、下記式(4):

54

$$M^{1}OC-CF-(OCF_{2}CF)_{m}O(CF_{2})_{n}SO_{2}NR^{3}R^{4}$$
 $II \qquad I \qquad (4)$
 $O \qquad CF_{3} \qquad CF_{3}$

(式中、

mおよびnは上記式(1)において定義した通り であり;

M ¹ は上記式 (3) において定義した通りであ り:

R®およびR4は、各々独立に、水素原子;無置換、または、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、アルコキシ基、カルボニル基、エステル基、酸アミド基、カルボニル基よりなる群から、カルボニルをも1種のでは、大変数1~1の成分を有するでは、大変数1~1のの成化水素基を置換をするでは、大変数1~1のの成化水素基を置換をするでは、大変数1~1のの成素をであるでは、大変数1~1のの成素をであるでは、大変数1~1のの無であるとでは、大変数1~1のの無であるとなり、大変数1~1のの無であるとなり、大変を表数1~1のの無であるとなり、大変を表数1~1のの無であるとなり、大変を表数1~1のの基となり、大変を表数1~1のの基となり、大変を表数1~1のの基となり、大変を表数1~1のの基となり、大変を表数1~1のの基となり、大変を表数には結合している窒素原子と共に、他ななないにはいる変素原子と共に、他なない、大変を表している変素を表している変素のよびにはいるでは、大変を表している変素の表した。

は不飽和含窒素複素環を形成していてもよく、また R³およびR⁴が同時に水素原子であることはな い。)

で表されるスルホンアミドを得;

(i i i) 該スルホンアミド(4)を脱炭酸ービニル化、次いで場合によりプロトン性化合物で処理する ことを含む方法である。

この方法は、式 (1)、 (2)、 (3) および (4) 中の m がいずれも 0 であっても、従来の製造方法において問題となっていた環化反応がほとんど起こらないため、モノマー

- (1)の収率が極めて高いという大きな特長を有している。まず、上記アシルフルオリド(2)を上記カルボン酸塩(3)に変換する方法につき説明する。
- アシルフルオリド(2)は、公知の方法によりカルポン酸塩(3)に変換することができる。その例としては、以下の- 方法を挙げることができる。
 - ・アシルフルオリド(2)をM¹(M¹は上記式(3)において定義した通りである)を含む塩基性物質と接触させて中和反応を行う
 - ・アシルフルオリド (2) を適当なアルコール、例えば炭素数 1 0 以下のアルコールと反応させてエステルを得、得られたエステルを M¹ (M¹は上記式 (3) において定義した通りである) を含む塩基性物質を用いてけん化する

これらのうち、前者の中和反応を行う方法が特に好ましい。 ここでいう「中和反応」とは、アシルフルオリド等のアシル ハライドを対応するカルボン酸塩に変換する反応を意味する。

上記M¹を含む塩基性物質の例としては、M¹の水酸化物、 炭酸塩、カルボン酸塩、リン酸塩等を挙げることができる。 なお、上記M¹として用いられる4級アンモニウム基の例と しては、テトラメチルアンモニウム基、テトラエチルアンモニウム基、テトラブチルアンモニウム基等を挙げることができる。また、上記M¹として用いられる4級ホスホニウム基 の例としては、テトラメチルホスホニウム基、テトラエチル ホスホニウム基、テトラブチルホスホニウム基等を挙げることができる。上記M¹として4級アンモニウム基や4級ホス ホニウム基を用いる場合には、各々4級アンモニウムヒドロ キサイドや4級ホスホニウムヒドロキサイドとして用いることが好ましい。

これらの塩基性物質のうち、アルカリ金属およびアルカリ 土類金属の炭酸塩を用いると、中和反応における選択性が高 いので好ましい。

上記中和反応においては、反応の効率を高めるために溶媒を用いてもよい。溶媒を用いる場合、プロトン性溶媒を用いることがより好ることもできるが、非プロトン性溶媒を用いることがより好ましい。いずれの溶媒を用いる場合でも、極性の高い溶媒を用いることが好ましい。

プロトン性溶媒の例としては、水;メタノール、エタノール、プロパノール等のアルコール類を挙げることができる。一方、非プロトン性溶媒の例としては、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、エチレングリコールジメチルエーテル等のエーテル類;アセトニトリル、プロピオニトリル、プチロニトリル、マロノニトリル、アジポニトリル等のコトリル類;ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド等のアミド類を挙げることができる。

溶媒を用いずに上記中和反応を行う場合、反応温度は通常 1 2 0 ℃以下、好ましくは1 0 0 ℃以下、より好ましくは8 0 ℃以下である。一方、溶媒を用いて上記中和反応を行う場合、反応温度は通常1 0 0 ℃以下、好ましくは8 0 ℃以下、 より好ましくは6 0 ℃以下である。反応温度が高すぎると脱 炭酸反応が進行し、副生物が生じる。例えば、m=0の場合 には環化反応生成物が副生する(以降、この副反応を「脱炭 酸一環化反応」と称する)。この結果、目的物であるカルボ ン酸塩(3)の収率が低下してしまう。

上記中和反応が進行する温度である限り、反応温度に特に 下限はないが、通常 0 ℃以上で行われる。また、反応圧力に 特に限定はないが、通常常圧で行われる。

上記中和反応においては、通常アシルフルオリド(2)と当量の上記塩基性物質を用いるが、所望により過剰量用いて

もよい。

次に、上記カルボン酸塩 (3) のフルオロスルホニル基を アミド化し、上記スルホンアミド (4) を得る方法について 説明する。

カルボン酸塩 (3) のフルオロスルホニル基は、公知の方法によりアミド化することができる。その例としては、以下の方法を挙げることができる。

(1-1) カルボン酸塩(3) を、アンモニア、1級アミンまたは2級アミン(以降、これらを単に「アミン」と称する) と反応させる

(1-2) カルボン酸塩(3) を上記アミンの金属アミドと 反応させる

(1-3) フッ化物イオン含有化合物の存在下、カルボン酸塩(3) を、無置換アミノ基、N-一置換アミノ基またはN,N-二置換アミノ基1個を有するアミノシランと反応させる方法(1-1) において用いられるアミンの例としては、下記式(X):

 $HNR^{1}R^{2}$ (X)

(式中、 R ¹ および R ² は、上記式 (1) において 定義した通りである。)

で表わされるアミンを挙げることができるが、これに限定されない。

この方法ではフッ化水素が副生するので、目的の反応を促

進するためフッ化水素の捕獲剤として適当な塩基性物質を用いることができる。塩基性物質の例としては、トリエチルアミン、ピリジン等の3級アミン類や、アルカリ金属の炭酸塩等を挙げることができる。この他、上記アミンを過剰に用い、未反応の上記アミンをフッ化水素の捕獲剤として用いてもよい。フッ化水素は捕獲剤と反応してフッ化物イオンを含む塩となり、反応系から除去される。この塩は濾過等の適当な方法で除去することができる。

上記アミド化反応において用いられる溶媒の例としては、 炭化水素類、ハロゲン化炭化水素類、エーテル類、ニトリル 類、アミド類等を挙げることができる。また、上記アミンが 液体である場合は、上記アミン自体を溶媒として用いてもよ い。

反応温度は、アミンの種類により異なるが、通常-50 $^{\circ}$ ~ 150 $^{\circ}$ 、好ましくは0 $^{\circ}$ ~ 100 $^{\circ}$ である。また、反応 た力に特に限定はないが、通常常圧で行われる。

この方法において、上記アミンとしてアンモニアまたは1 級アミンを用いた場合、R³またはR⁴としてアンモニウム 基を含むスルホンアミド(4)が得られる場合がある。その 機構を、上記アミンとしてメチルアミンを用いた場合を例と して以下に示す。

> $-SO_2F + 3NH_2CH_3$ $1 - NH_3(CH_3) \cdot F$

60

-SO₂NHCH₃ + NH₂CH₃

1

-SO₂NCH₃(NH₃CH₃)

方法 (1-2) においては、上記アミン (X) に代えて金属アミドを用いる以外、上記方法 (1-1) と同様の操作を行う。但し、フッ化水素の捕獲剤は不用である。

金属アミドの例としては、上記アミン (X)中の窒素原子に結合した水素原子が、アルカリ金属、アルカリ土類金属などの金属によって置換された構造を有する金属アミドを挙げることができるが、これに限定されない。この方法においては通常、上記の金属としてリチウム、ナトリウムまたはカリウムを用いる。

方法(1-2)において用いられる金属アミドが、窒素原子に結合したシリル基を含む場合、上記シリル基が脱離する場合がある。これは、カルボン酸塩(3)のフルオロスルホニル基から脱離したフッ化物イオンの影響によると考えられる。推定されるその機構を以下に示す。

・方法 (1-3) においては、上記アミン (X) に代えてアミノシランを用い、またフッ化物イオン含有化合物の存在下

で反応を行う以外、上記方法(1-1)と同様の操作を行う。 但し、フッ化水素の捕獲剤は不用である。

該アミノシランの例としては、上記アミン(X)中の窒素原子に結合した水素原子が無置換または置換シリル基によって置換された構造を有する金属アミドを挙げることができるが、これに限定されない。置換シリル基の例としては、少なくとも1個の炭素数1~10の炭化水素基を置換基として含み、合計10個以下の炭素原子を有する置換シリル基を挙げることができる。

フッ化物イオン含有化合物の例としては、フッ化セシウム、フッ化カリウム等を挙げることができる。

方法 (1-3) においては、溶媒として炭化水素類、エーテル類、ニトリル類またはアミド類を用いることが好ましい。

アシルフルオリド (2) の上記カルボン酸塩 (3) への変換およびカルボン酸塩 (3) のフルオロスルホニル基のアミド化は、別々の反応器中で行ってもよく、同一の反応器の中で連続して行ってもよい。即ち、

第一の反応器中でカルボン酸塩(3)を製造し、得られたカルボン酸塩(3)を単離して、第二の反応器中でアミド化する方法、および

第一の反応器中でカルボン酸塩(3)を製造し、得られたカルボン酸塩(3)を単離することなく、第一の反応器中でアミド化する方法

のどちらを採用してもよい。

なお、これら二段階の反応のいずれかにおいて、水、アルコール、あるいはアンモニア、1級または2級アミンのようなプロトン性化合物を用いる場合や、プロトン性化合物が副生する場合は、反応生成物を充分に乾燥し、プロトン性化合物を除去する必要がある。プロトン性化合物が充分除去されていないと、後述する脱炭酸ービニル化反応において下記(17):

$$CF_3CHF$$
- $(OCF_2CF)_mO(CF_2)_nSO_2NR^3R^4$
 CF_3

(式中、m、n、R³およびR⁴は上記式(4)において定義した通りである。)

で表わされるプロトン付加体(スルホンアミド(4)の-C OOM¹基が水素原子で置換された化合物に相当)が副生し、 本発明のモノマー(1)の収率が低下する。

また、スルホンアミド(4)のR³およびR⁴の両方が水 素原子であると、後述する脱炭酸ービニル化反応において、 上記プロトン付加体(17)が主生成物となってしまい、本 発明のモノマー(1)はほとんど得られない(比較例6を参 照)。

このため、スルホンアミド (4) の R 3 および R 4 の少な

くとも一方は水素原子ではない。 R³および R⁴の両方が水 素原子でないことがより好ましい。

スルホンアミド(4)のR³およびR⁴のうち一方が水素原子以外の基であれば、他の一方は水素原子であってもよい。 この場合、水素原子以外の基としてはアリール基、2級または3級アルキル基および置換シリル基が好ましい。

なお、一般に一S〇₂NH-基の水素原子は酸性であるため、アルカリ性化合物と接触させると、この水素原子を解離させることができる。従って、スルホンアミド(4)のR³およびR⁴のうち一方が水素原子である場合、スルホンアミド(4)をアルカリ性化合物で処理すると、そのR³またはR⁴としての水素原子が解離し、該アルカリ性化合物との塩となる。換言すれば、R³およびR⁴としての水素原子が、アルカリ金属やアンモニウム基等により置換される。この状態のスルホンアミド(4)を用いると、上記副反応を抑制することができる。

アルカリ性化合物の例としては、アルカリ金属およびアルカリ土類金属の水酸化物、炭酸塩、カルボン酸塩、リン酸塩等や、アンモニウムヒドロキシド類、ホスホニウムヒドロキシド類等を挙げることができる。これらを用いると、R³およびR⁴としての水素原子が、アルカリ金属、アルカリ土類金属、アンモニウム基またはホスホニウム基によって置換される。

また、スルホンアミド(4)のR³およびR⁴のうち一方が水素原子であるとき、他の一方は上記M¹であってもよい。

上記スルホンアミド (4) は新規化合物であり、また本発明のモノマー (1) の製造におけるキーマテリアルであるので、本発明に含まれる。

アシルフルオリド (2) からスルホンアミド (4) を製造する方法としては、カルボン酸塩 (3) を中間体とする上記の方法以外の方法も考えられる。しかし、本発明者らが種々の方法を検討した結果、上記の方法はスルホンアミド (4)の収率において最も優れていた。

アシルフルオリド(2)からスルホンアミド(4)を製造する他の方法としては、例えば、初めにアシルフルオリド(2)の-SO2F基をアミド化してスルホンアミドを得、得られたスルホンアミドを中和反応に付し、スルホンアミド(4)を得るという方法が考えられる。しかしこの方法では、スルホンアミド(4)はほとんど得られない。また、アシルフルオリド(2)をエステル化し、得られたエステルの-SO2F基をアミド化してスルホンアミドを得、得られたスルホンアミドのエステル基ををけん化することによりスルホンアミド(4)を得るという方法が考えられる。しかしこの方法は操作が煩雑な上、スルホンアミド(4)の収率も低い。

次に、スルホンアミド (4) を脱炭酸ーピニル化する方法 について説明する。ここでいう「脱炭酸ーピニル化」は、ス ルホンアミド(4)中の一COOM¹基とフッ素原子1個を 脱離させて、パーフルオロビニル基を形成することを意味す る。

スルホンアミド(4)の脱炭酸ービニル化は、溶媒の非存在下または存在下でスルホンアミド(4)を加熱することにより行うことができる。

使用する溶媒としては、非プロトン性溶媒、特に非プロトン性極性溶媒が好ましい。水やアルコール等のプロトン性溶媒は上記プロトン付加体(17)の副生を引き起こすので好ましくない。好ましい溶媒の例としては、エチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、シオキサン等のエーテル類;アセトニトリル、プロピオニトリル、アジポニトリル、マロノニトリル等のニトリル類;ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、Nーメチルピロリドン等・のアミド類等を挙げることができる。

反応温度は、脱炭酸-ビニル化が進行する温度である限り 特に限定されないが、通常 5 0 ~ 3 5 0 ℃、好ましくは 8 0 ~ 3 0 0 ℃である。

好ましい反応温度は反応条件、特に溶媒の有無や種類により異なる。脱炭酸ービニル化を溶媒の非存在下で行う場合、 反応温度は120~300℃が好ましい。脱炭酸ービニル化 を溶媒の存在下で行う場合、反応温度は80~220℃が好 ましい。但し、溶媒が非極性溶媒である場合には、反応温度は脱炭酸ービニル化を溶媒の非存在下で行う場合とほぼ同様である。

スルホンアミド (4) のR³およびR⁴がいずれも上記式 (1) のR¹およびR²の範囲に含まれる基であれば、以上 の方法により得られる反応生成物を本発明のモノマー (1) として用いることができる。

スルホンアミド(4)のR³およびR⁴の少なくとも一方がアルカリ金属、アルカリ土類金属、アンモニウム基またはホスホニウム基である場合(上記したように、カルボン酸塩(3)のフルオロスルホニル基のアミド化の際、窒素原子に結合したシリル基が脱離した場合や、R³またはR⁴としての水素原子をアルカリ金属やアンモニウム基等により置換した場合)には、得られた反応生成物をプロトン性化合物で処理することにより、その金属または基を水素原子により置換し、モノマー(1)を得ることができる。

また、置換シリル基をR¹またはR²として含むモノマー (1) をこの処理に付すことにより、その置換シリル基を水素原子により置換することができる。

プロトン性化合物の例としては、水;塩酸、硫酸、リン酸、 酢酸、トリフルオロメタンスルホン酸、シュウ酸等の酸;メ タノール、エタノール、イソプロパノール、nーブタノール、 t - ブタノール等のアルコール;フェノール等を挙げること ができる。上記の酸は、通常水溶液として用いる。

プロトン性化合物による処理は、上記脱炭酸ービニル化により得られた反応生成物を、室温付近でプロトン性化合物と接触させることにより容易に行うことができる。

上記のプロトン性化合物処理による、窒素原子上の置換基 基交換の例を以下に示す。

$$-SO_{2}NNa(SiMe_{3}) \xrightarrow{H+} -SO_{2}NH_{2}$$

$$-SO_{2}NH(SiMe_{3}) \xrightarrow{\sharp t klMeOH} -SO_{2}NH_{2}$$

$$-SO_{2}NMe(SiMe_{3}) \xrightarrow{\sharp t klMeOH} -SO_{2}NHMe$$

· 製造方法 2_

第2の製造方法は、本発明のモノマー(1)のうち、R¹ およびR²がいずれも水素原子であるか、またはR¹およびR²が、各々独立に、水素原子;無置換、または、2個の炭化水素基を置換基として含むN,N-二置換アミノ基、アルコキシ基およびエーテル基よりなる群から選ばれる少なくとも1種の置換基により置換され、合計15個以下の炭素原子を有する、炭素数1~10の炭化水素基;または該置換シリル基であり、但し、R¹およびR²のうち少なくとも1つは、炭素数3~10の2級または3級のアルキル基、または該置

換シリル基であるものについてのみ適用し得る方法であり、 下記式(5):

$$CF_2=CF-(OCF_2CF)_mO(CF_2)_nSO_2F$$
 CF_3
(5)

(式中、mおよびnは上記式(1)において定義した 通りである。)

で表されるスルホニルフルオリドをアミド化、次いで場合によりプロトン性化合物で処理することを含む。

この方法においては、スルホニルフルオリド (5) のアミド化を、スルホニルフルオリド (5) を下記式 (6):

$$M^{2}NR^{5}R^{6}$$
 (6)

(式中、

M²は水素原子、アルカリ金属またはアルカリ土 類金属であり;

R5およびR6は、各々独立に、無置換、または、2個の炭化水素基を置換基として含むN, N一二置換アミノ基、アルコキシ基およびエーテル基よりなる群から選ばれる少なくとも1種の置換基により置換され、合計15個以下の炭素原子を有する、炭素数1~10の炭化水素基を置換基として含み、合計10個以下の炭素原子を有する置換シリル基で合計10個以下の炭素原子を有する置換シリル基で

あり、但し、R 5 およびR 6 のうち少なくとも1つは、炭素数 $3\sim1$ 0 の 2 級または 3 級のアルキル基または該置換シリル基であり、

R⁵およびR⁶が互いに結合して2価の基となり、 R⁵およびR⁶と結合している窒素原子と共に、飽 和または不飽和含窒素複素環を形成していてもよ い。)

で表されるアミンまたは金属アミドと反応させることによって行う。

スルホニルフルオリド (5) は従来の高分子電解質膜の原料として用いられており、公知の方法により製造することができる。

スルホニルフルオリド (5) をアミド化することを目的として、スルホニルフルオリド (5) を $(NH_2)^-$ 、 $(NEt_2)^-$ などのアミドアニオンと反応させると、このアミドアニオンがパーフルオロビニル基と反応してしまい、目的のモノマー (1) はほとんど得られない。

しかし、本発明者らが種々検討した結果、上記式(6)で表される、嵩高い置換基を有する特定のアミンまたは金属アミドを用いると、上記のようなパーフルオロビニル基との反応が抑制され、目的のモノマー(1)が効率よく得られることが判明した。

上記アミンまたは金属アミド(6)において、R⁵および

R®のうち少なくとも1つは、炭素数3~10の2級または3級のアルキル基、または、少なくとも1個の炭素数1~10の炭化水素基を置換基として含み、合計10個以下の炭素原子を有する置換シリル基である。R®およびR®のいずれもこれらの基でないと、アミンまたは金属アミド(6)が生成した目的のモノマー(1)のパーフルオロビニル基と反応してしまうので、モノマー(1)を得ることができない。

2級または3級のアルキル基の例としては、イソプロピル 基、2ーブチル基、tーブチル基、2、4、4ートリメチル -2ーペンチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基等 の、炭素数3~10個、好ましくは3~6個の分岐構造また は環状構造を有するアルキル基を挙げることができる。

R 5 および R 6 は互いに結合して 2 価の基となり、 R 5 および R 6 と結合している窒素原子と共に、飽和または不飽和含窒素複素環を形成していてもよい。このような例としては、 2 、 6 - ジメチル- 2 、 6 - ペンチレン基等が挙げられる。

また、R 5 およびR 6 として置換シリル基を用いる場合、 該置換シリル基として、モノマー(1)のR 1 またはR 2 と して用いられる置換シリル基と同様の置換シリル基を用いる ことができる。それらの置換シリル基は、置換基として、 2 個以上の炭化水素基を含むことが好ましく、 3 個の炭化水素 基を含むことが特に好ましい。置換シリル基の好ましい例と してはトリメチルシリル基、トリエチルシリル基、 t ープチ ルジメチルシリル基等が挙げられる。

M²としては、アルカリ金属およびアルカリ土類金属が好ましく、通常アルカリ金属、特にリチウム、ナトリウムまたはカリウムが用いられる。

アミンまたは金属アミド(6)の例としては、リチウムジ イソプロピルアミド、リチウムジシクロヘキシルアミド、リ チウムイソプロピルシクロヘキシルアミド、2,2,6,6 ーテトラメチルピペリジンリチウムアミド、リチウム(tー ブチル)(2,4,4ートリメチルー2ーペンチル)アミド、 リチウムヘキサメチルジシラジド、ナトリウムヘキサメチル ジシラジド、カリウムヘキサメチルジシラジド、リチウムベ ンジルトリメチルシリルアミド等の金属アミドおよびこれら に対応するアミン(金属原子が水素原子で置換されたもの) を挙げることができる。

上記アミド化反応は、通常エーテル系等の非プロトン性極 * 性溶媒中、室温以下の比較的低温で行われる。

なお、R³およびR⁴のうち少なくとも一方が置換シリル 基である場合、上記方法(1 − 2)の場合と同じ理由により、 その置換シリル基が脱離する場合がある。そのような場合に は、上記の反応により得られた反応生成物をプロトン性化合 物で処理することにより、モノマー(1)を得ることができ る。プロトン性化合物処理は、製造方法1に関して説明した 方法により行うことができる。 また、以上のようにして得られたモノマー(1)が、R¹またはR²として炭素数 1~10の無置換または置換炭化水素基、或いは置換シリル基を含む場合、モノマー(1)を同様のプロトン性化合物処理に付すことにより、その炭化水素基または置換シリル基を水素原子により置換することができる。

製造方法3

第3の製造方法は、下記式(7):

$$CF_3CHF-(OCF_2CF)_mO(CF_2)_nSO_2NR^1R^2$$
 CF_3
 CF_3

(式中、m、n、R¹およびR²は上記式 (1) にお いて定義した通りである。)

で表される化合物を脱フッ化水素、次いで場合によりプロトン性化合物で処理することを含む方法である。

この方法においては、脱フッ化水素を、上記化合物(7)を下記式(8):

$$M^3NR^*R^y$$
 (8)

(式中、

M³はアルカリ金属またはアルカリ土類金属であり;

R×およびRvは、各々独立に、無置換、または、

2個の炭化水素基を置換基として含むN, N-二置換アミノ基、アルコキシ基およびエーテル基より電力を対して、アルコキシ基およびエーテル基より置換され、合計15個以下の炭素原子を有する、炭素数1~10の炭化水素基を置換基として含み、合計10個以下の炭素原子を有する置換シリル基であり、但し、R×およびRyのうち少なくとも1つは、炭素数3~10の2級または3級のアルキル基または該置換シリル基であり、

R×およびR^ッが互いに結合して2価の基となり、 R×およびR^ッと結合している窒素原子と共に、飽 和または不飽和含窒素複素環を形成していてもよ い。)

で表される金属アミドと接触させることによって行う。

製造方法1について説明したように、プロトン性化合物の存在下でスルホンアミド(4)の脱炭酸ーピニル化を行うと、プロトン付加体(17)が副生する。しかし本発明者らは、プロトン付加体(17)のうち特定のもの、即ち、上記化合物(7)もまたモノマー(1)の前駆体として使用し得ることを見出した。化合物(7)は、R³およびR⁴がモノマー(1)のR¹およびR²として使用し得る基と同じであるプロトン付加体(17)に相当する。

上記化合物 (7) は新規化合物であり、また本発明のモノマー (1) の製造におけるキーマテリアルであるので、本発明に含まれる。

以降、化合物 (7) の脱フッ化水素につき説明する。

この反応は、化合物(7)に塩基性物質を接触させ、CF。CFH基中の水素原子を引き抜くことにより行うことができると考えられる。しかし、化合物(7)をKOH等の通常用いられる塩基性物質と接触させると、副反応が顕著となり、目的のモノマー(1)はほとんど得られない。これは、塩基性物質が脱フッ化水素反応により生成したモノマー(1)のパーフルオロビニル基と反応してしまい、目的のモノマー(1)が分解してしまうためである。

しかし、本発明者らが種々検討した結果、上記式(8)で表される、嵩高い置換基を有する特定の金属アミドを用いると、上記のようなパーフルオロビニル基との反応が抑制され、目的のモノマー(1)が効率よく得られることが判明した。金属アミド(8)は、製造方法2で用いられる化合物(6)のうちM2がアルカリ金属またはアルカリ土類金属であるものに相当する。

化合物(7)の脱フッ化水素は、スルホンアミド(5)に代えて化合物(7)を用い、化合物(6)に代えて金属アミド(8)を用いる以外は、製造方法2と同様の操作により行うことができる。ただし、製造方法3ではSO₂NR¹R²

基を有する化合物 (7) を出発物質として用いるので、製造方法 2 のような、R ¹ および R ² に関する限定はない。

なお上記したように、R¹およびR²のうち少なくとも一方が水素原子の場合、-SO₂NH-基中の水素原子は酸性であるため、反応に付す前に、化合物(7)を製造方法1においてスルホンアミド(4)をアルカリ性化合物で処理する方法と同様にアルカリ性物質で処理し、塩型にする(R¹またはR²としての水素原子をアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオンや、アンモニウムイオンなどで置換する)ことができる。反応前に塩型にしない場合でも、アルカリ性物質である金属アミド(8)を過剰量用いることにより、-SO₂NH-基を中和してから脱フッ化水素することができる。

上記したように、化合物 (7) は、R³およびR⁴がモノマー (1) のR¹およびR²として使用し得る基と同じであるプロトン付加体 (17) に相当する。即ち、化合物 (7) な、下記式 (18):

$$M^{1}OC-CF-(OCF_{2}CF)_{m}O(CF_{2})_{n}SO_{2}NR^{1}R^{2}$$
 II
 I
 CF_{3}
 CF_{3}
 (18)

(式中、

m、n、R¹およびR²は上記式(1)において 定義した通りであり;

M¹は上記式(3)において定義した通りであ

る。)

で表わされる化合物(スルホンアミド(4)のR³およびR 4を各々モノマー(1)のR¹およびR²で置換したものに 相当)を脱炭酸ービニル化する際、反応系内にプロトン性化 合物が存在すると副生する。実際、上記製造方法1によって 製造したモノマー(1)中には少量の化合物(7)が含まれ ることが多い。

モノマー (1) と対応する化合物 (7) とは通常沸点差が 小さく、蒸留で効率よく分別することは難しい。しかしなが ら、化合物 (7) を含むモノマー (1) に対して金属アミド (8) を接触させることにより、化合物 (7) のみを金属ア ミド (8) と反応させ、モノマー (1) に変換することができる。 き、結果として高純度のモノマー (1) を得ることができる。

このような、パーフルオロビニル化合物の純度向上方法としても利用することのできる脱フッ化水素(ビニル化)の方法は、金属アミド(8)と反応するような官能基を有さない限り、モノマー(1)以外のパーフルオロビニルエーテルの製造に対しても一般に適用可能である。

化合物(7)を金属アミド(8)と反応させる場合、通常エーテル系等の非プロトン性極性溶媒中、室温以下の比較的低温で行われる。金属アミド(8)は化合物(7)に対して当量用いればよいが、CF₃CFH基中の水素原子以外の引き抜かれやすいプロトンが化合物(7)中に存在する場合等

には過剰量用いることもできる。

上記したように、化合物(7)は水やアルコールのようなプロトン性化合物の存在下、化合物(18)の脱炭酸により容易に得ることができる。化合物(7)を効率よく製造するためには、プロトン性化合物は化合物(18)に対して当量以上用いることが好ましく、過剰量用いることがより好ましい。

化合物 (7) を製造する別の方法として、以下に示す方法 も挙げられる。即ち、上記のようなプロトン性化合物の存在 下で上記カルボン酸塩 (3) の脱炭酸反応を行い、下記式 (19):

$$\begin{array}{c} \mathsf{CF_3CHF-}(\mathsf{OCF_2CF})_\mathsf{m}\mathsf{O}(\mathsf{CF_2})_\mathsf{n}\mathsf{SO_2F} \\ \mathsf{CF_3} \end{array} \tag{19}$$

(式中、nは上記式(1)において定義した通りである。)

で表わされる化合物を得、得られた化合物(19)のフルオロスルホニル基を、上記製造方法1のカルボン酸塩(3)のフルオロスルホニル基のアミド化と同様の方法でアミド化する方法である。

化合物 (19) のアミド化は、上記のアミド化法 (1-1) または (1-2) と同様に、化合物 (19) をアミンまたは金属アミドと反応させることによりアミド化を行うこと

ができるが、その場合、上記アミンまたは金属アミドは化合物 (19) に対して当量用いることが好ましい。アミンまたは金属アミドがは金属アミドを過剰に用いると、アミンまたは金属アミドが生成した化合物 (7) と2次的に反応して副生物が生じ、目的の化合物 (7) の収率が低下する。

しかし、この方法において金属アミドとして上記金属アミド(8)を用いると、上記の脱フッ化水素とアミド化を一挙に行うことができる。即ち、化合物(7)を中間体として単離することなく、化合物(19)から一段階の反応によってモノマー(1)を得ることができる。このような方法を実施する場合には、金属アミドを化合物(19)に対して過剰に(2 当量以上)用いる。この方法は簡便であり、モノマー(1)の製造方法として優れたものである。但しこの方法では、反応系内において上記製造方法2におけるアミド化反応と同様の反応が起こると考えられるので、この製造方法を適用できるモノマー(1)と同じである。

製造方法 3 は、分子内に解離しやすいプロトンを有するために、スルホンアミド (4) の脱炭酸ービニル化では化合物 (7) が副生しやすく、合成しにくいモノマー (1) の製造において特に有用である。

なお、R*およびR*のうち少なくとも一方が置換シリル 基である場合、上記方法(1-2)の場合と同じ理由により、 その置換シリル基が脱離する場合がある。そのような場合には、上記の反応により得られた反応生成物をプロトン性化合物で処理することにより、モノマー(1)を得ることができる。プロトン性化合物処理は、製造方法1に関して説明した方法により行うことができる。

また、以上のようにして得られたモノマー (1) が、 R¹ または R² として 置換シリル基を含む場合、モノマー (1) を同様のプロトン性化合物処理に付すことにより、その 置換シリル基を水素原子により 置換することができる。

製造方法 4

第4の製造方法は、下記式(9):

$$CF_2X^1-CFX^2-(OCF_2CF)_mO(CF_2)_nSO_2NR^1R^2$$
 (9)

(式中、

m、n、R¹およびR²は上記式(1)において 定義した通りであり;

X¹およびX²は、各々独立に、塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子である。)

で表される化合物を脱ハロゲン化、次いで場合によりプロトン性化合物で処理する

ことを含む方法である。

製造方法4において出発物質として用いられる化合物

- (9) は、モノマー(1) のパーフルオロビニル基にフッ素 以外のハロゲン原子が付加した構造を有する。従って、式
- (9) 中の X 1 および X 2 は、各々独立に、塩素原子 (C
- 1)、臭素原子(Br)またはヨウ素原子(I)である。

 X^1 および X^2 として用いるハロゲン原子は、脱ハロゲン 化反応の容易さの観点からは、I>Br>C1の順に好ましい。一方、原料の入手し易さの観点からはC1>Br>Iの 順に好ましい。

化合物(9)の製造方法は特に限定されない。化合物(9)の製造方法の例1)および2)を以下に示す。

1)公知の方法で製造された、 SO_2F 基を有するパーフルオロビニル基を有するモノマーのパーフルオロビニル基に C I_2 、 Br_2 または I_2 を付加して SO_2F 基を有する中間体を得、得られた中間体をアンモニアや、I 級または 2 級アミンと反応させてアミド化する方法。

2) SO_2F 基を有するハイポフルオライトを 1 、 2-3 ハロー 1 、 2-3 フルオロエチレンと反応させる(J . F 1 u o r i n e Ch e m . , 95 , 27(1999) (オランダ)を参照)、または SO_2F 基を有するハイポクロライトをモノハロトリフルオロエチレン(例えばクロロトリフルオロエチレン)と反応させる(J . F 1 u o r i n e Ch e m . , 58 , 59(1992) (オランダ)を参照)ことにより、 SO_2F 基を有する中間体を得、得られた中間体をアンモニアや、1 級または2 級アミンと反応させてアミド化する方法。

上記のSO2F基を有する中間体のアミド化は、上記製造方法1において説明した、カルボン酸塩(3)のフルオロスルホニル基のアミド化と同様の方法で行うことができる。

上記化合物 (9) は新規化合物であり、また本発明のモノマー (1) の製造におけるキーマテリアルであるので、本発明に含まれる。

次に、化合物(9)の脱ハロゲン化について説明する。

化合物(9)の脱ハロゲン化は、化合物(9)を脱ハロゲン化剤と接触させることにより行う。脱ハロゲン化剤としては通常、Zn、Mg、Cu、Fe、Sn等の金属、またはZn-Cu、Zn-Pb等の、2種以上の金属を含む合金を用いる。特に、Znおよびその合金類が好ましい。

これらの金属または合金は、表面積の大きい形状を有するものが好ましく、通常粉末状、顆粒状または粒状のものが用いられる。またこれらの金属または合金は、予め希塩酸等で洗浄の後、乾燥してから用いることが好ましい。

脱ハロゲン化反応を促進するため、臭素等の触媒を併用してもよい。

脱ハロゲン化反応は、固体の脱ハロゲン化剤を含む不均一系、即ち気ー固系または固ー液系で行う。通常は、溶媒を用いる固ー液系で行われる。溶媒としては通常、グライム、ジグライム、ジオキサン等のエーテル類;ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、Nーメチルピロリドン等のアミド類;アセトニトリル、プロピオニトリル等のニトリル類;ジメチルスルホキシド等の極性溶媒が用いられる。反応温度は通常室温から溶媒の沸点の範囲である。

また、電気化学的手法により化合物 (9) を脱ハロゲン化 することもできる。この方法では上記脱ハロゲン化剤 (金属等) が不用なので、脱ハロゲン化剤に由来する副生物が生成 しない。このため、モノマー(1)の製造に伴う廃棄物の量 を低減させることができるという利点がある。

この方法では通常、適当な電解液に化合物(9)を溶解し、 得られた溶液に陽極および陰極を入れ、両極間に電圧を印加 して電気化学反応を行うことによって脱ハロゲン化を行う。

電気化学反応を行う条件には特に制限はなく、従来行われている電気分解等の条件で行うことができる。

陽極の例としては、炭素、白金、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、イリジウム、金およびこれらの金属でメッキされた電極等を挙げることができる。

陰極の例としては、ニッケル、銅、亜鉛、鉄、チタン、クロム、アルミニウム、コバルト、スズ、カドミウム、アンチモン、水銀、鉛、銀およびこれらの金属でメッキされた電極等を挙げることができる。

所望により、両極の間にイオン交換膜、多孔質樹脂膜、セ ラミックス製多孔質膜などの隔膜を配してもよい。

電解液は、通常溶媒およびこれに溶解した電解質からなる溶液を用いる。

この方法において用いられる溶媒は、上記電解質のみならず、化合物 (9) も溶解する溶媒である必要がある。溶媒の例としては、水; アセトニトリル、プロピオニトリル等のニトリル類; ジメチルホルムアミド、Nーメチルー2ーピロリドン、ヘキサメチルホスホリックトリアミド等のアミド類;

ブタノール、(ポリ)エチレングリコール等のアルコール類;テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル類;アセトン、メチルエチルケトン等のケトン類;ジメチルスルホキシド等の極性有機溶媒等を挙げることができる。これらの溶媒は単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。所望により、化合物(9)の溶解度を高めるため、HFC43-10mee等のフッ素系溶媒を併用することもできる。

電解質の例としては、塩酸、硫酸、テトラフルオロ硼酸等の無機酸; (フルオロ) 脂肪族飽和カルボン酸、 (フルオロ) アルキルスルホン酸等の有機酸; 水酸化ナトリウム等の無機塩基、トリアルキルアミン、テトラアルキルアンモニウムヒドロキサイド等の有機塩基、およびそれらの塩を挙げることができる。溶媒として有機溶媒を用いる場合は、有機溶媒への溶解度が高い電解質、例えば上記有機酸および無機酸の4級アンモニウム塩および4級ホスホニウム塩等を用いることが好ましい。

上記の電解液の他、上記電解質と溶媒の機能を併せ持つイオン性液体を電解液として用いてもよい。イオン性液体の例としては、1ーブチルー3ーメチルー1Hーイミダゾリウムヘキサフルオロホスフェート、1ーエチルー3ーメチルー1Hーイミダゾリウムトリフルオロメタンスルフォネート等を挙げることができる。

両極間に印加する電圧は通常 2. 7~40 V 程度であり、電流密度は一般には 10~500m A/c m²程度の範囲である。また、反応は通常常圧で行い、反応温度は通常 - 20℃から用いる溶媒の沸点の範囲である。

脱ハロゲン化反応により得られる反応混合物からの目的のモノマー(1)の単離は、反応混合物を直接蒸留することにより行うことが好ましいが、所望により、反応混合物から固形物を濾別したり、適当な溶媒を用いて抽出を行った後蒸留してもよい。

また、モノマー(1)が液状であり、反応混合物を放置すると主としてモノマー(1)よりなる層と他の層に分離する場合は、前者の層を回収し、蒸留等の方法で精製することによってモノマー(1)を得ることができる。

以上のようにして得られたモノマー(1)が、R¹または R²として置換シリル基を含む場合、モノマー(1)を製造 方法1において説明したプロトン性化合物処理に付すことに より、その置換シリル基を水素原子により置換することがで きる。

以上、本発明のパーフルオロビニルエーテルモノマー (1) の好ましい製造方法1~4につき説明したが、モノマ ー (1) の製造方法はそれらに限られるものではない。

製造方法1~4以外の製造方法の一例として、

上記製造方法1~4のいずれかによりモノマー(1)を合成し;

得られたモノマー(1)を適当な処理に付して、モノマー(1)の R^1 および/または R^2 を修飾または置換することにより、元のモノマー(1)とは R^1 および/または R^2 の構造が異なるモノマー(1)を得るという方法を挙げることができる。

R¹および/またはR²の修飾または置換の例としては、

- ・R¹および/またはR²としての水素原子をアルキル基で 置換する (N-アルキル化)
- ・R¹および/またはR²としての水素原子を置換シリル基で置換する (N-シリル化)
- ・R¹および/またはR²としてのアルキル基を水素原子で 置換する (N-脱アルキル化)
- ・R¹および/またはR²としての置換シリル基を水素原子 で置換する (N-脱シリル化)

等を挙げることができる。一例として、ヘキサメチルジシラザンを用いる上記N-シリル化を以下に示す。

 $-SO_2NH_2 + (Me_3Si)_2NH \longrightarrow -SO_2NH(SiMe_3)_2$

本発明のモノマー (1) に含まれるスルホンアミド基は反応性が高い。この性質を利用し、モノマー (1) を種々の誘導体に変換することが出来る。これらの誘導体をモノマー

(1) と共重合させることにより、所望の特性を有する共重 合体を得ることができる。

モノマー(1)の誘導体製造の例を以下に示す。例中ではモノマー(1)のNR 1 R 2 基のみを示す。

- -SO₂NH₂ + CF₃SO₂F <u>塩基</u> -SO₂NHSO₂CF₃
- $-SO_2NH_2 + FSO_2R_1^fSO_2F$ $-SO_2NHSO_2R_1^fSO_2F$

(式中、 R^f₁は炭素数 1 ~ 1 0 のエーテル結合を含 んでもよいパーフルオロアルキレン基である。)

- -SO₂NH(tBu) + CF₃SO₂F <u>塩基</u> -SO₂N(tBu)SO₂CF₃
- -SO₂NH₂ + F(CO)CF₂SO₂F <u>塩基</u>
 -SO₂NHCOCF₂SO₂F
- -SO,NH,+ CF,COF 塩基 -SO,NHCOCF,

また、後述するポリマー側鎖構造の変換反応として挙げて ある式 (32)~(35)の反応も、モノマー(1)誘導体 の製造方法として有用である。 以上の方法により得られる本発明のパーフルオロビニルエーテルモノマー(1)を単独重合させる、またはオレフィン性不飽和結合を有する少なくとも1種のコモノマーと共重合させることにより、容易にフッ素化重合体を得ることができる。機械的強度の高いフッ素化重合体を製造するためには、上記モノマー(1)を、オレフィン性不飽和結合を有する少なくとも1種のコモノマーと共重合させる方が好ましい。

本発明のモノマー(1)をコモノマーと共重合させる場合、 使用するコモノマーの種類に特に制限はなく、目的とする共 重合体特性に応じて適宜選択して使用することができる。

コモノマーの例としては、エチレン、プロピレン、アルキルビニルエーテル等のオレフィン類; テトラフルオロエチレン、トリフルオロクロロエチレン、トリフルオロエチレン、フッ化ビニリデン、ヘキサフルオロプロピレン、パーフルオロメチルビニルエーテル、パーフルオロプロピルビニルエーテル等のフッ素化オレフィン類; クロロトリフルオロエチレン等のクロロフルオロオレフィン類等を挙げることができる。これらのコモノマーは単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。

化学的安定性の観点からは、これらのコモノマーのうちフッ素原子を含むものが好ましく、中でもパーフルオロオレフィン類が好ましい。特にテト

ラフルオロエチレンやクロロトリフルオロエチレンが好まし ... く、テトラフルオロエチレンが最も好ましい。

本発明のモノマー(1)をコモノマーと共重合させる場合、モノマー(1)およびコモノマーの量に特に制限はなく、目的のフッ素化共重合体の特性に応じて適宜選択することができる。フッ素化共重合体中のモノマー(1)に由来するモノマー単位の量は、モノマー(1)に由来するモノマー単位およびコモノマーに由来するモノマー単位の合計モル量に対し、通常0.001~50mo1%、好ましくは0.005~30mo1%、より好ましくは0.01~20mo1%である。

本発明のモノマー(1)の単独重合または共重合を行う方法に特に制限はなく、ラジカル重合や放射線重合などの公知の方法で行うことができる。具体的な重合方法の例としては、日本国特開昭57-92026号明細書等に記載されているような溶液重合の他、水等を媒体とした懸濁重合や乳化重合に加え、塊状重合、ミニエマルジョン重合、マイクロエマルジョン重合などを挙げることができる。ラジカル重合を行う場合、重合開始剤として、通常用いられる公知のラジカル開始剤の他、パーフルオロ過酸化物等を用いることができる。

なお、本発明のモノマー(1)の R^1 および/または R^2 が水素原子である(即ち、モノマー(1)が $-SO_2NH-$ 構造を有する)場合、 R^1 または R^2 としての水素原子は弱酸性を示す。そのようなモノマー(1)を(共)重合させる

場合、特に水系の溶媒中で行われる乳化重合等を行う場合には、重合反応系に塩基性物質を添加することにより、R¹またはR²としての水素原子がアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオンや、アンモニウムイオンなどに置換された状態で重合を行ってもよい。

上記したように、このようにして得られるフッ素化重合体をイオン交換樹脂として用いる場合、そのイオン交換容量を高めるという観点からは、上記式(1)中のmは0が最も好ましい。従って、上記フッ素化重合体は、下記式(10):

 $CF_2 = CFO(CF_2)_pSO_2NR^aR^b$ (10) (式中、

pは1~5の整数であり;

RaおよびRbは、各々独立に、水素原子;無置換、または、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、アルコキシ基、カルボニル基、エステル基、酸アミド基、スルホニル基およびエーテル基よりなる群から選ばれる少なくとも1種の置換基により置換され、合計15個以下の炭素原子を有する、炭素数1~10の炭化水素基を置換をして含み、合計10個以下の炭素原子を有する置換シリル基であり、但し、RaおよびRbが、各々独立に、該炭素数1~10の無置換または置換炭化水素基、或いは該置換

シリル基であるときは、R®およびR®が互いに結合して2価の基となり、R®およびR®と結合している窒素原子と共に、飽和または不飽和含窒素複素環を形成していてもよい。)

で表わされる少なくとも1種のモノマーに由来するモノマー単位を包含することが特に好ましい。

上記モノマー (10) に由来するモノマー単位を包含するフッ素化重合体は、本発明者らによって初めて得られた新規な重合体である。

以上のフッ素化重合体に関する研究の過程において、本発明者らは意外にも、(a)部分的または完全にフッ素化されたビニル基、および下記式(11):

$$-SO_2NR^7R^8$$
 (11)

(式中、

R¹は水素原子;無置換、または、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、アルコキシ基、カルボニル基、エステル基、酸アミド基、スルホニル基およびエーテル基よりなる群から選ばれる少なくとも1種の置換基により置換され、合計15個以下の炭素原子を有する、炭素数1~10の炭化水素基を置換基とも1個の炭素数1~10の炭化水素基を置換基として含み、合計10個以下の炭素原子を有する置換シリル基であり;

R®は水素原子または該置換シリル基である。)で表わされる基を有する少なくとも1種のモノマー;
(b) 部分的または完全にフッ素化されたピニル基、および下記式(12):

$$-SO_{2}X^{3}$$
 (12)

(式中、 X ³ はフッ素原子、塩素原子または一〇 R ⁹ 基を表わし、 R ⁹ は該炭素数 1 ~ 1 0 個の無置換または置換炭化水素基、或いは該置換シリル基である。)

で表わされる基を有する少なくとも1種のモノマー;および 場合により

(c) 該モノマー(a) および(b) 以外の、オレフィン性不飽和結合を有する少なくとも1種のモノマーを共重合させることによって得られるフッ素化共重合体が、後述する適当な塩基性物質を用いる変性処理に付すことにより、容易に耐熱性を向上させることができるという好ましい特性を有することを見出した。このような特性は、高い耐熱性を要求される材料、例えば燃料電池用高分子固体電解質の材料の製造において極めて有用である。

このようなフッ素化共重合体は従来知られておらず、本発明者らによって初めて得られたものである。また後述するように、本発明のパーフルオロビニルモノマー(1)のうち特定のものは、上記モノマー(a)として使用できる。

93

以降、モノマー(a)、(b)および(c)につき説明する。

・モノマー (a)

上記したように、モノマー(a)は、部分的または完全にフッ素化されたビニル基、および下記式(11):

$$-SO_2NR^7R^8$$
 (11)

で表わされる基を有する少なくとも1種のモノマーである。

上記式(11)で表わされる基(以降「置換基(11)」と称する)において、R⁷は、水素原子;無置換、または、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、アルコキシ基、カルボニル基、エステル基、酸アミド基、スルホニル基およびエーテル基よりなる群から選ばれる少なくとも1種の置換基により置換され、合計15個以下の炭素原子を有する、炭素数1~10の炭化水素基;或いは少なくとも1個の炭素数1~10の炭化水素基を置換基として含み、合計10個以下の炭素原子を有する置換シリル基である。

R?として用いられる無置換炭化水素基は、炭素数1~1 0、好ましくは1~7、特に好ましくは1~4の無置換炭化水素基である。この無置換炭化水素基の構造に特に制限はなく、直鎖状、分岐状、環状およびそれらの組み合わせなど、どのような構造を有するものであってもよい。無置換炭化水素基の例としては、アルキル基、アルケニル基、アリール基、 アラルキル基等を挙げることができる。化学的安定性の観点からは、これらのうち芳香族炭化水素基、飽和炭化水素基およびそれらを組み合わせた構造の炭化水素基が好ましく、特に、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソプチル基、secーブチル基、tーブチル基等の低級アルキル基が好ましい。

R⁷として用いられる置換炭化水素基は、上記無置換炭化水素基中の少なくとも1個の水素原子が、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、アルコキシ基、カルボニル基、エステル基、酸アミド基、スルホニル基およびエーテル基よりなる群から選ばれる少なくとも1種の置換基により置換された構造を有する。この置換炭化水素基が、アルコキシ基等の炭素原子を含む置換基を有する場合、その置換基中の炭素を含む、置換炭化水素基中の合計の炭素数は1~15、好ましくは1~10である。置換炭化水素基の具体例としては、2,2,2~トリフルオロエチル基、3~メトキシプロピル基等が挙げられる。

R⁷として用いられる上記置換シリル基は、少なくとも1個、好ましくは2個以上、特に好ましくは3個の炭素数1~10の炭化水素基を置換基として含み、合計10個以下、好ましくは6個以下、特に好ましくは3個の炭素原子を有する。この置換シリル基中の炭化水素基の構造に特に制限はなく、直鎖状、分岐状、環状およびそれらの組み合わせなど、どの

ような構造を有するものであってもよい。この炭化水素基の例としては、アルキル基、アルケニル基、アリール基、アラルキル基等を挙げることができ、特にアルキル基が好ましい。置換シリル基の具体例としては、トリメチルシリル基、トリコープロピルシリル基、ジメチルフェニルシリル基、ジメチルシリル基等が挙げられ、特に好ましくはトリメチルシリル基である。

上記置換基(11)において、R⁸は水素原子または上記置換シリル基である。

後述するように、 R^7 および R^8 の種類によっては、本発明のフッ素化共重合体を高分子固体電解質膜とするためには、 R^7 および/または R^8 を水素原子に置換する必要があるが、モノマー(a)の R^7 および R^8 がいずれも水素原子であると、この操作を行う必要がないという点で好ましい。

上記部分的または完全にフッ素化されたビニル基(以降「フッ素化ビニル基」と称する)としては、ビニル基の3個の水素原子の一部または全てがフッ素原子により置換された基の他、ビニル基の水素原子のうち1個がフッ素原子、他の1個または2個が塩素原子で置換された基や、ビニル基の水素原子のうち1個が塩素原子、他の1個または2個がフッ素原子で置換された基を用いることができる。フッ素化ビニル基は、少なくとも2個のフッ素原子を含むことが好ましい。

モノマー(a)は、上記フッ素化ビニル基と上記置換基

TO BE SEED OF THE SECURITY OF THE SEED OF THE SECURITY OF THE

(11)が2価の基を介して連結した構造を有する。この2 価の基の構造には特に限定はないが、この2価の基として完全にフッ素化された2価の炭化水素基を用いると、化学的安定性や熱的安定性に優れるフッ素化共重合体が得られるので好ましい。この基の構造に特に制限はなく、直鎖状、分岐状、環状およびそれらの組み合わせなど、どのような構造を有するものであってもよく、また不飽和結合や芳香環を含んでいてもよい。

上記の完全にフッ素化された 2 価の炭化水素基中の隣接した 2 個の炭素原子間の単結合が、酸素原子、カルボニル基、スルホニル基、ピスカルボニルイミド基、ピススルホニルイミド基、カルボニルスルホニルイミド基等の 2 価の置換基によって置換されていてもよい。

上記フッ素化ビニル基および置換基(11)は、これら2 価の置換基を介して完全にフッ素化された2 価の炭化水素基と結合していてもよい。

また、得られる共重合体の特性に悪影響を及ぼさない範囲で、上記の完全にフッ素化された 2 価の炭化水素基のフッ素原子の一部が、水素原子、塩素原子などの 1 価の置換基によって置換されていてもよい。

このようなモノマー(a)の例として、下記式(13): $CF_2 = CF - Rf - SO_2NR^7R^8 \qquad (13)$ で表されるモノマーを挙げることができる。

上記式(13)において、R⁷およびR⁸は上記式(1 1)において定義した通りである。

Rfは、単結合;下記式(14)で表わされる炭素数1~20のフッ素化アルキレン基;または下記式(15)で表わされる炭素数1~20のフッ素化オキシアルキレン基である。

$$-C_{q}X_{2q}^{4}$$
 (14)

$$- O C_a X_{2a}^4 - (15)$$

上記式(14)および(15)の両者において、qは1~20の整数である。またX⁴は、各々独立に、フッ素原子; または水素原子、塩素原子およびアルコキシ基よりなる群から選ばれる1価の置換基である。1価の置換基の数は、X⁴の数の35%以下であり、好ましくは25%以下であり、最も好ましくは15%以下である。

上記フッ素化アルキレン基(14)およびフッ素化オキシアルキレン基(15)の構造に特に制限はなく、直鎖状、分岐状、環状およびそれらの組み合わせなど、どのような構造を有するものであってもよい。

また、上記フッ素化アルキレン基(14)またはフッ素化オキシアルキレン基(15)中の隣接した2個の炭素原子間の単結合のうち少なくとも1本が、酸素原子、カルボニル基、スルホニル基、ビスカルボニルイミド基、ビススルホニルイミド基およびカルボニルスルホニルイミド基よりなる群から選ばれる2価の置換基によって置換されていてもよい。該2

価の置換基の数は、整数qの50%以下である。

上記Rfの例としては、以下のような2価の基が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

- $-C_aF_{2a}-$
- $-(CF_2)_a CHFCF_2$
- C a F 2 a O C b F 2 b -
- $-(C_aF_{2a}O)_b-C_cF_{2c}-$
- $-(C_aF_{2a}O)_b-C_cF_{2c}SO_2NR^1SO_2C_dF_{2d}-$

(式中:

a、b、cおよびdは各々独立に1~4の整数であり、

R¹は上記式(1)において定義した通りである。)

このようなモノマー (a) の具体的な例の一つとして、下記式 (20):

$$C F_{2} = C F C F_{2} S O_{2} N R^{7} R^{8}$$
 (20)

(式中、R⁷およびR⁸は上記式(11)において定義

した通りである。)

で表わされるモノマーを挙げることができる。

また、下記式(16):

$$CF_2$$
= CF - $(OCF_2CF)_mO(CF_2)_nSO_2NR^7R^8$
 CF_3 (16)

(式中、

mは0~5の整数であり;

 $n は 1 \sim 5 の整数であり;$

向上など)が得られる。

R⁷およびR⁸は上記式(11)において定義し た通りである。)

で表されるモノマーもまた、上記モノマー(a)として好ましく用いることができる。モノマー(16)は、本発明のモノマー(1)において、R²が炭素数1~10の無置換または置換炭化水素基でないものに相当する。モノマー(16)は、モノマー(20)に比して重合性が高いので好ましい。モノマー(16)においては、mは小さい方が好ましい。0~2であることが好ましく、0~1であることがより好ましく、0であることが最も好ましい。このようなモノマー(16)を用いると、その使用量を少なくしても、高い効果(フッ素化共重合体の機械的強度の向上、フッ素化共重合体をイオン交換樹脂として用いる場合、そのイオン交換容量の

nは1~5の整数である。モノマー(16)自体およびモノマー(16)を原料として得られるフッ素化共重合体の化学的安定性を向上し、またモノマー(16)の生産性を高めるという観点からは、nは2または3が好ましく、2が最も好ましい。

これらのモノマー (a) は単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。

・モノマー (b)

上記したように、モノマー(b)は、部分的または完全にフッ素化されたビニル基、および下記式(12):

$$-SO_{2}X^{3}$$
 (12)

で表わされる基(以降「置換基(12)」と称する)を有する少なくとも1種のモノマーである。

即ちモノマー(b)は、上記モノマー(a)の置換基(1)が置換基(12)により置換された構造を有する。

式(12)において、 X^3 はフッ素原子、塩素原子または $-OR^9$ 基を表わし、 R^9 は炭素数 $1\sim 10$ 個の無置換または置換炭化水素基、或いは置換シリル基である。

炭素数 $1 \sim 1$ 0 個の無置換または置換炭化水素基は、上記式 (11) の R^7 としての炭素数 $1 \sim 1$ 0 個の無置換または置換炭化水素基と同じである。また置換シリル基は、上記式 (11) の R^7 または R^8 としての置換シリル基と同じである。

X³は、モノマー(b)の安定性や取り扱いやすさの観点から、フッ素原子または塩素原子が好ましく、フッ素原子がより好ましい。

モノマー (b) の例として、式(21):

$$C F_2 = C F - R f - S O_2 X^3$$
 (21)

で表されるモノマーを挙げることができる。

上記式(21)において、X3は上記式(12)において

定義した通りであり、Rfは上記式(13)において定義した通りである。

また、上記製造方法 2 において使用するスルホニルフルオリド-(5) もまた、モノマー(b) として好ましく用いることができる。

スルホニルフルオリド(5)において、mは0~5の整数であるが、機械的強度の高いフッ素化共重合体を得るためには、0~2が好ましく、0または1がより好ましい。

nは1~5の整数である。スルホニルフルオリド(5)自体およびスルホニルフルオリド(5)を原料として得られるフッ素化共重合体の化学的安定性を向上し、またスルホニルフルオリド(5)の生産性を高めるという観点からは、nは2または3が好ましく、2が最も好ましい。

スルホニルフルオリド (5) の具体例を下記式 (22)、(23)、(24) および (25) に示す。

$$CF_2 = CF - OCF_2CF_2CF_2CF_2CF_2SO_2F$$
 CF_3
 (2.3)

$$CF_2 = CFOCF_2CF_2SO_2F \qquad (24)$$

$$CF_2 = CFOCF_2CF_2CF_2SO_2F \qquad (2.5)$$

これらのモノマー(b)は単独で用いてもよく、2種以上 を組み合わせて用いてもよい。

モノマー(c)

本発明のフッ素化共重合体は、上記モノマー(a)および (b)を共重合させることによっても得られるが、上記した ように、上記モノマー(a)および(b)に加え、該モノマ ー(a)および(b)以外の、オレフィン性不飽和結合を有 する少なくとも1種モノマーであるモノマー(c)を共重合 させることによっても得られる。

オレフィン性不飽和結合を有し、上記モノマー(a)および(b)と共重合し得る限り、モノマー(c)の構造に特に制限はない。

モノマー(c)の例としては、エチレン、プロピレン等のオレフィン類;フッ化ビニリデン、テトラフルオロエチレン、クロロトリフルオロエチレン等のハロゲン化オレフィン類、特にハロゲン化エチレン等を挙げることができる。これらのモノマー(c)は単独で用いてもよく、2種以上を組み合わせて用いてもよい。

これらのモノマー(c)のうち、パーフルオロオレフィン 類やクロロフルオロオレフィン類が好ましい。特にテトラフ ルオロエチレンやクロロトリフルオロエチレンが好ましく、 テトラフルオロエチレンが最も好ましい。

本発明のフッ素化共重合体の製造において、上記モノマー(a)、(b)および(c)の種類は、所望の共重合体特性に応じて適宜選択することができる。モノマー(a)として上記れいたこれでも物(16)を用い、モノマー(b)として上記スルホニルフルオリド(5)を用いる場合、化合物(16)のmおよびnとスルホニルフルオリド(5)のmおよびnを同じにするなどの制限はなく、所望の共重合体の特性に応じて適宜選択することができる。この特長は、従来の・SO2F基を有するポリマーの・SO2F基の一部をアミド化する方法では得ることのできないものである。

上記モノマー (a)、 (b) および (c) の使用量にも特に制限はないが、フッ素化共重合体の取り扱いやすさ等の観点から、モノマー (a)、 (b) および (c) の合計のモル量に対し、モノマー (a) を、0.001~20mo1%用いることが好ましく、より好ましくは0.005~10mo1%、最も好ましくは0.01~5mo1%である。

モノマー (b) については、モノマー (a)、 (b) および (c) の合計のモル量に対し $3 \sim 95 \text{ mol} \%$ 用いることが好ましく、より好ましくは $5 \sim 60 \text{ mol} \%$ 、最も好ましくは $10 \sim 30 \text{ mol} \%$ である。

モノマー (c) については、モノマー (a) 、 (b) および (c) の合計のモル量に対し $0 \sim 9$ 7 m o 1 % 用いること

が好ましく、より好ましくは $50 \sim 92 \text{ mo} 1\%$ 、最も好ましくは $70 \sim 88 \text{ mo} 1\%$ である。

モノマー(b)の置換基(12)は容易に遊離スルホン酸 基に変換できる基である。置換基(12)を多く含むフッ素 化共重合体は、イオン交換用量が高いイオン交換樹脂や、プロトン伝導率の高い高分子固体電解質の原料として好ましい。 従って、モノマー(b)は比較的多量に用いる方が好ましい。

これに対し、モノマー(a)は比較的少量で十分な効果を 発揮する。

上記モノマー(a)に由来するモノマー単位(A)および上記モノマー(b)に由来するモノマー単位(B)を包含してなる本発明のフッ素化共重合体は、本発明者らによって初めて得られた物質である。本発明のフッ素化共重合体は、高速での製膜に適した特性を有する上、高温での機械的強度を高めるための変性処理を効率よく行うことができる等の優れた特性を有する、極めて有用な物質である。

モノマー単位 (A) の量は、モノマー単位 (A) および (B) の合計モル量に対し、好ましくは 0. 001~50m o1%、より好ましくは 0. 005~30m o1%、最も好ましくは 0. 01~20m o1%である。

また、本発明のフッ素化共重合体を取り扱いの容易な、また種々の特性のバランスに優れたものとするためには、本発明のフッ素化共重合体において、上記モノマー(a)に由来

するモノマー単位 (A) および上記モノマー(b) に由来するモノマー単位 (B) よりなるスルホニル基含有モノマー単位 1 m o 1 当たりの、本発明のフッ素化共重合体の重量 (g) が、400~1400g/mo1であることが好ましく、より好ましくは600~1200g/mo1であり、最も好ましくは700~1100g/mo1である。

この値は、本発明のフッ素化共重合体を、置換基(11) および(12)をイオン交換基として有するイオン交換樹脂 と見なしたときのEauivalent weightに相 当し、本発明のフッ素化共重合体の重量(g)を、上記モノ マー単位(A)および(B)の合計モル量で除することによ って求めることができる。

また、本発明のフッ素化共重合体のメルトインデックスは、 荷重2.16kg、オリフィス径2.09mmの条件下、そ の溶融温度以上、分解温度未満の範囲において0.001~ 500であることが好ましく、0.01~200であること がより好ましく、0.1~100であることが最も好ましい。

以上のフッ素化共重合体は、本発明者らによって初めて得られた新規な共重合体であり、側鎖末端に上記置換基(11)および(12)を有する。上記したように、この共重合体を後述する変性処理に付すと、耐熱性を大幅に向上させることができる。

また、このフッ素化共重合体自体も比較的高い耐熱性を有

しており、加熱溶融を伴う成型方法により成形する際にも変性を受けない。また、この共重合体は架橋構造を含んでいないので、溶融成形法等、種々の公知の方法により成型し、共重合体膜などの成形体を容易に得ることができる。溶融成形法により共重合体膜を製造し、得られた共重合体膜を変性処理に付すことにより、変性共重合体膜を得る方法は、工業的に有利に実施できる好ましい方法である。

以上のフッ素化重合体、特にフッ素化共重合体を種々の公知の方法で成形することにより、容易に膜などの成形品を得ることができる。このとき、所望により、このフッ素化重合体を他の重合体と混合して得られる組成物として用いてもよい。

上記フッ素化共重合体それを含む組成物から製造される共 重合体膜は、燃料電池用の耐熱性に優れた高分子固体電解質 膜の原料として特に有用である。以降、本発明のフッ素化重 合体膜を製造する方法につき説明する。

本発明のフッ素化重合体から膜を製造する方法に特に限定はなく、カレンダー法、インフレーション法、Tダイ法、キャスト法、切削法、エマルジョン法、ホットプレス法等、公知の方法により行うことができる。しかし、本発明のフッ素化重合体は耐熱性に優れ、加熱しても顕著な変性を受けないので、製膜における生産性を考慮すると、これらの製膜法のうち、溶融成形法による製膜法、例えばTダイ法やインフレ

ーション法がより好ましい。

また、上記重合体の薄膜を製造する場合は、上記重合体の溶液を用いるキャスト法も好ましい。

膜厚に特に限定はなく、重合体膜の用途によって適宜選択することができるが、好ましくは $5\sim200\,\mu\,m$ 、より好ましくは $10\sim150\,\mu\,m$ 、特に好ましくは $20\sim100\,\mu\,m$ である。

得られた重合体膜は、単層膜として使用しても良いし、他の膜と組み合わせた積層膜として使用してもよい。ここでいう単層膜とは、膜中の組成が均一な膜を意味しており、後述する変性処理を行う場合には最も効果的な形態である。上記単層膜は、所望により他の構造体や他の組成の膜との積層膜の一部を構成していてもよい。

上記単層膜は、その内部全体に上記置換基(11) および(12) が均一に分散した構造を有している。このような単層膜は、本発明者らにより初めて得られたものである。

また上記重合体膜は、繊維状補強材、粒子状補強材、多孔質膜等の各種の補強材と複合化されたものであってもよい。補強材の具体例としては、PTFE微粒子、PTFEフィブリル、PTFE織布、PTFE多孔膜または各種の無機補強材等を挙げることができる。

なお、日本国特開 2 0 0 1 - 3 1 9 5 2 1 号明細書に開示 されている、- S O 2 F 基含有ポリマー膜をアンモニアで処 理する方法(従来技術の項を参照)につき本発明者らが検討したところ、この方法により得られたアンモニア処理膜のIRスペクトルより、膜中に一SO₂NH₂基と同時に多量のスルホン酸基(アンモニウム塩型)が形成されていることが確認された。これは、この方法では極微量の水分が反応系に混入しただけで、一SO₂F基からスルホン酸基(アンモニウム塩型)への変換が起こりやすくなるためと考えられる。これに対し、一SO₂NH₂基を含む本発明の共重合体膜のIRスペクトルからは、スルホン酸基(アンモニウム塩型)の形成は全く確認されなかった。

以上の重合体膜のうち、上記モノマー(a)、(b)および場合により(c)の共重合により得られるフッ素化共重合体から製造されるフッ素化共重合体膜を変性処理すると、耐熱性が大幅に向上する。特に、高温条件下での機械的強度および弾性率が向上する。また、高温でのクリープ変形が著しく低減される。更に、変性処理を施したフッ素化共重合体膜を後述する手法により高分子固体電解質膜に変換しても、プロトン伝導率の低下が起こらないという特長を有する。以降、この共重合体膜の耐熱性を向上させるための変性処理について説明する。

変性処理は、上記フッ素化共重合体膜を各種の塩基性物質に接触させることにより行う。塩基性物質の例としては、各種のルイス塩基やブレンステッド塩基が挙げられる。具体的

には、含窒素有機ルイス塩基、式Q+Y-(Q+は4級アンモニウム基、4級ホスホニウム基、アルカリ金属、アルカリ土類金属等を表し;Y-はアルコキシ基、アリーロキシ基、ヒンダードアミン構造のアミノ基、フッ化物イオン等を表す)で表わされる化合物等が挙げられる。これらの塩基性物質は無水物であることが好ましい。

合窒素有機ルイス塩基は、幅広い種類の上記フッ素化共重合体膜の変性処理に使用できる。含窒素有機ルイス塩基の具体例としては、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリプロピルアミン、トリプチルアミン、テトラメチルエチレンジアミン、ジメチルアニリン等の3級アミン類;N(CH2CH2OCF2CHFCF3)3等の、部分的にフッ素原子で置換された3級アミン類;ピリジン、アルキル置換ピリジン、N、Nージメチルアミノピリジン、キノリン、1、4ージアザビシクロ[2.2.2]オクタン(DABCO)、1、8ージアザビシクロ[5.4.0]-7ーウンデセン(DBU)、1、5ージアザビシクロ[4.3.0]-5ーノネン(DBN)、イミダゾールあるいはその誘導体等の各種の含窒素複素環化合物等が挙げられる。中でも、3級アミン類、N、Nージメチルアミノピリジンおよび超強塩基類(DABCO、DBU、DBNなど)が好ましい。

R ⁷ および R ⁸ の少なくとも一方が 置換シリル基の場合は、 式 Q ⁺ Y ⁻ で表わされる化合物のうち、 Y ⁻ がフッ化物イオ ンである化合物(フッ化物イオン含有化合物)も有効である。 そのような化合物の例としては、フッ化リチウム、フッ化ナトリウム、フッ化カリウム、フッ化ルビジウム、フッ化セシウム等の金属フッ素化物;フッ化テトラブチルアンモニウム、フッ化テトラメチルアンモニウム等の4級アンモニウムフルオライド;フッ化テトラブチルホスホニウムフルオライド等を挙げることができる。中でもフッ化カリウムおよびフッ化セシウムが好ましく、フッ化カリウムがより好ましい。

変性処理は溶媒を用いて行ってもよい。使用する溶媒に特に限定はなく、HCFC225ca/cb、HFC43-10mee等のフッ素系溶媒;グライム類、ジオキサン等のエーテル系溶媒;ジメチルスルホキシド、ジメチルホルムアミド等の極性溶媒等、各種の溶媒を使用することができる。但し、変性処理を多量の水の存在下で行うと、共重合体中の置換基(12)の加水分解が顕著となり、目的とする耐熱性の向上が妨げられるので、変性処理の際の系内への水の混入を極力防ぐことが好ましい。

また変性処理は、通常 $0 \, \mathbb{C}$ 以上、好ましくは $4 \, 0 \, \mathbb{C}$ 以上、 より好ましくは $6 \, 0 \, \mathbb{C}$ 以上で行う。また、通常 $2 \, 0 \, 0 \, \mathbb{C}$ 以下、 好ましくは $1 \, 5 \, 0 \, \mathbb{C}$ 以下で行う。塩基性物質としてフッ化物 イオン含有化合物を用いる場合には、含窒素有機ルイス塩基 を用いる場合に比べやや高温で変性処理を行うことが好まし ٧٧.

以上の変性処理により、上記フッ素化共重合体膜の耐熱性、特に高温での機械的強度が向上する理由は必ずしも明らかではないが、下記式(26)または(27)で示すような反応によって架橋構造が形成されることによるものと推定される。 実際、下記式(26)または(27)に示すピススルホニルイミド結合の生成が、変性共重合体膜のIRスペクトルにより確認されている。

$$-SO_{2}F + -SO_{2}N \stackrel{R^{7}}{+} \frac{塩基}{-HF/塩基の塩} -SO_{2}-N-SO_{2}- (26)$$

$$-SO_{2}F + -SO_{2}N \stackrel{R^{7}}{\underset{SiMe_{3}}{-Me_{3}SiF}} -SO_{2}-N-SO_{2}- (27)$$

(式中、R⁷は上記式(11)において定義した通りである。)

上記のフッ素化共重合体膜を変性処理した場合に、上記式(26) および(27) において、R⁷がアルキル基や置換シリル基の場合、変性処理によって得られた変性共重合体膜を酸処理すると、下記式(28) および(29) に示すように、N-H基を有するビススルホニルイミド結合が生じる。

(式中、 R はアルキル基を表わす)

本発明のフッ素化共重合体は、スルホニルフルオリド (5)に由来するモノマー単位を包含する他の重合体(例えば、TFEとスルホニルフルオリド(5)の共重合体)と分散性の良好な樹脂組成物を形成する。このような樹脂組成物から共重合体膜を製造し、得られた共重合体膜を上記と同様に変性処理することもできる。

上記変性処理を行ったフッ素化共重合体膜は、通常の燃料電池用隔膜等を製造する場合と同様にアルカリ性物質および/または酸で処理することにより、高分子固体電解質膜合体膜をアルカリ性物質で処理を施したフッ素化共重合体膜をアルカリ性物質で処理すると塩型のスルホン酸基を有する。一方、酸での温度を得るの高分子電解質膜を製造する際は、活動ので、後者の高分子電解質膜を製造する際に、な条件で効率的に反応を進行させるために、まずアルカリ性物質で処理して塩型のスルホン酸基を有する高分子電解質に、まり遊離スルホン酸基を得、これを酸で処理することにより遊離スルホン酸基を得、これを酸で処理することにより遊離スルホン酸基を得、これを酸で処理することにより遊離スルホン酸基を

有する高分子電解質膜とする。

アルカリ性物質としては、NaOH、KOH等の無機アルカリ性物質のほか、トリエチルアミン、ジエチルアミン等のアミンも使用できる。アルカリ性物質は通常水溶液として使用する。アルカリ性物質で処理する条件は、一SO₂F基を含有する公知のポリマーを処理する場合と同様でよい。例えば、NaOH水溶液またはKOH水溶液中、室温~100℃で行われる。この際、NaOH水溶液またはKOH水溶液はアルコール、水溶性エーテル、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド等の有機溶媒を含有していてもよい。

酸処理は、通常塩酸、硫酸、トリフルオロメタンスルホシ酸等の強酸の水溶液中、室温~100℃で行う。最後に充分水洗することにより、目的の遊離スルホン酸基を有する高分子固体電解質膜が得られる。

このようにして得られた高分子固体電解質膜は、高温での機械的強度が改善されているので、燃料電池用隔膜として好ましく用いることができる。

本発明のパーフルオロビニルエーテルモノマーを用いて得られるフッ素化重合体は、変性処理の有無にかかわらず、燃料電池用隔膜以外にも、燃料電池用触媒バインダー、ポリマーリチウムイオンバッテリー用高分子固体電解質を初めとする各種の電気化学素子用材料、クロロアルカリプロセス用イオン交換膜、耐オゾン性分離膜等の各種分離膜材料、イオン

交換樹脂材料等の幅広い分野で使用可能である。

以下に本発明のモノマー(1)を用いて得られるフッ素化 重合体のその他の用途について説明する。

本発明のモノマー(1)を用いて得られるフッ素化重合体は、変性処理をしなくとも、各種の機能性樹脂、機能性フイルムの材料として使用することができる。

R¹およびR²の少なくとも一方が水素原子であるモノマー(1)を用いて得られるフッ素化重合体は、R¹および/またはR²としての水素原子が弱酸性であるため、弱酸性のイオン交換性フッ素系ポリマーとして使用することが出来る。このようなポリマーの用途の例としては、米国特許第3,784,399号明細書に記載されている、食塩の電解装置において、電解効率を向上するために食塩電解用隔膜の表面に形成される弱酸性イオン交換性フッ素系ポリマー層の原料としての用途を挙げることができる。

また、このような弱酸性イオン交換樹脂は、球状微粒子状に成形し、分離・精製用のイオン交換樹脂として使用することも出来る。

また、本発明のモノマー(1)の(共)重合体における-SO₂NR¹R²部は、下記a)、b)、c)のようにそれぞれの用途に応じて各種の官能基に変換して使用することも出来る。

a)強酸性イオン交換ポリマーへの変換

本発明のモノマー(1)から製造されるフッ素化重合体は、 - SO₂NR¹R²基を強酸性の-SO₃H基に変換して、燃料電池用隔膜、食塩電解用隔膜、強酸性触媒、分離・精製用のイオン交換樹脂等の幅広い分野に使用することが出来る。

-SO2NR¹R²基から-SO₃Hへの変換は、酸性条件下、アルカリ性条件下、酸化雰囲気下、水存在下等の各種条件下での処理あるいはそれらの組み合わせにより実施する事が出来る。この変換反応は、-SO₂NR¹R²基の構造によってその難易度が異なり、したがって、-SO₂NR¹R²基の構造によってその処理条件を選択する必要がある。その中でも、-NR¹R²基がイミダゾリル基やピロリル基のような含窒素芳香族基である場合には、温和な温度条件下で、酸性雰囲気下等の条件で効率的に-SO₃H基への変換が達成されるので好ましい。

b) 弱酸性イオン交換ポリマーへの変換

R¹およびR²の少なくとも一方がアルキル基または置換シリル基である、モノマー(1)から誘導されるフッ素化重合体は、下記のような酸、アルコール、水などのプロトン性化合物による処理により脱アルキル化または脱シリル化され、NH基含有ポリマーへ変換することが出来る。その結果得られる弱酸性のNH基含有ポリマーは、前述の弱酸性イオン交換ポリマーと同様に各種の用途で使用することが出来る。

<デSO2NH-基への変換の例>

$$R_{1}^{1}$$
 R_{2}^{1} R_{2}^{1} R_{3}^{1} R_{2}^{1} R_{3}^{1} R_{2}^{1} R_{3}^{1} R_{3}^{1} R_{4}^{1} R_{2}^{1} R_{3}^{1} R_{3}^{1} R_{4}^{1} R_{4}^{1} R_{5}^{1} R_{5

(式中、R¹は上記式(1)において定義した通りである。)

c) その他のポリマー変性

R¹およびR²の少なくとも一方が水素原子あるいは置換シリル基であるモノマー(1)から誘導されるフッ素化重合体は、高反応性のNーH基あるいはNーSi結合を有しているので、それらの反応性を利用して各種物質と反応させてポリマー構造を変性させる事も出来る。また、一NR¹R²基がイミダゾリル基やピロリル基のような含窒素芳香族基である場合には、塩化水素(HCl)で代表される各種の活性水素含有化合物(酸性物質)と反応させることで容易に他の官能基に変換することができる。

<ビススルホニルイミド基、スルホニルカルボニルイミド基 への変換の例>

$$-SO_{2}N-W + FSO_{2} + Rf^{3}-SO_{2}NSO_{2} - Rf^{3}-SO_{2}F$$

$$-SO_{2}NSO_{2} + Rf^{3}-SO_{2}NSO_{2} - Rf^{3}-SO_{2}F$$
(35)
塩基(W=Hの場合)

(式中、

R¹およびR²は各々独立に上記式(1)において定義した通りであり;

R f ²は各々独立に炭素数 1 ~ 1 5、好ましくは 1 ~ 8、

特に好ましくは1~4のパーフルオロアルキル基、パーフル オロアルコキシ基またはパーフルオロポリオキシアルキレン 基であり;

Rf³は各々独立に炭素数1~15、好ましくは1~8、特に好ましくは1~4のパーフルオロアルキレン基、パーフルオロオキシアルキレン基またはパーフルオロポリオキシアルキレン基であり;

A は各々独立に 0 ~ 2 0 、好ましくは 0 ~ 5 、特に好ましくは 0 ~ 2 の整数である。)

尚、上記式(32)~(35)における反応生成物中のN-R¹基は、R¹がアルキル基の場合には、これらの部位は酸触媒との接触や加熱等による脱アルキル化反応により、容易にN-H基に変換できる。

<イミダゾール誘導体の反応例>

$$-SO_2-N$$
 N
 $-SO_2-X$
 $+$
 $H-N$
 N

(式中、HXは、塩化水素などの活性水素含有化合物 (酸性物質)を表す。)

また、本発明のモノマー (1) における-SO₂NR¹R

²基も、必要に応じて上記のb) および c) に記載されている各種の変換反応を利用して他の官能基に変換して使用することが出来る。

以上のように、本発明のパーフルオロビニルモノマー (1)は、燃料電池用の高耐熱性高分子固体電解質(隔膜) 等、各種の機能性材料の原料として用いることができ、極め て有用である。 発明を実施するための最良の形態

以下、実施例、比較例および参考例によって本発明を更に詳細に説明するが、これらは本発明の範囲を限定するものではない。

実施例、比較例および参考例において、種々の物性は次の 方法により測定した。

1. フッ素-19およびプロトン核磁気共鳴(¹⁹F-および¹H-NMR)スペクトル

モノマーの¹⁹ F - NMRスペクトルは、測定装置として 日本国日本電子製Lambda-400型またはGSX-400型核磁気共鳴装置、溶媒として重クロロホルム、基準物質としてフレオン-11(CFC1,)を用いて得た。

モノマーの¹ H - N M R スペクトルは、測定装置として日本国日本電子製L a m b d a - 400型またはG S X - 400型核磁気共鳴装置、溶媒として重クロロホルム、基準物質としてテトラメチルシラン(T M S)またはクロロホルム(上記重クロロホルムに含まれている)を用いて得た。

なお、モノマーのNMRスペクトルは二重試料管を用いて 測定した。

ポリマーの固体 ¹⁹ F - N M R スペクトルは、測定装置と してドイツ国 B R U K E R B I O S P I N 社製 D S X - 4 00型核磁気共鳴装置、基準物質としてフレオン-113 (C-FCl₂CF₂Cl)を用い、マジックアングルスピニング (MAS) 法によって得た。

2. 赤外吸収スペクトル

赤外吸収(IR)スペクトルは、測定装置として米国Perkin Elmer社製FT-IRスペクトロメーター 2000FT-IR、または米国BIO-RAD社製FT-IRスペクトロメーター FTS-6000を用い、透過法(試料:窓板に直接塗布(neat)、KBr錠剤法またはフィルム法)または全反射法にて測定した。

3. ガスクロマトグラフィー(GC)

以下の装置および条件で行った。

装置 : 米国HEWLETT PACKARD社製589

0 シリーズII

カラム: 米国J&W Scientific社製 キャピラリーカラム DB-1

(内径 0.25 mm、長さ30 m、膜厚1 μ m)

キャリアガス:He

検出 : FID

4. ガスクロマトグラフィーーマススペクトル(GC-M

1 2 2

S)

以下の装置および条件で行った。

装置 : 日本国日本電子製Automass-Sun

カラム: 米国 J & W S c i e n t i f i c 社製

キャピラリーカラム DB-1

- (内径 0.25 mm、長さ30 m、膜厚1 μm)

キャリアガス:He

5. 引張弹性率

試料(共重合体膜)を約30mm×3mmの長方形に切断したものを試験片とし、動的粘弾性測定装置RHOVIBRON DDV-01FP(登録商標)(日本国エーアンドデイ(株)製)を用いて、室温~300℃、周波数35Hzの条件下で測定した。

6. メルトインデックス (MI)

米国Dynisco社製D4002を用い、温度270℃、荷重2.16kg、オリフィス径2.09mmの条件下で測定した。

実施例1

- (1) 中和反応
 - 31.8gの炭酸ナトリウムと150m1のアセトニトリ

ルからなるスラリー中に、窒素気流下、室温で、下記式:

 CF_3CF (CO_2Na) $OCF_2CF_2SO_2F$ で表わされるカルボン酸ナトリウム塩であることが確認された。

¹⁹ F - N M R : δ (p p m) - 1 2 5 . 5 (1 F) ,
1 1 2 . 7 (2 F) , -8 2 . 9 (3 F) , -8 1 . 7 ,
7 9 . 7 (2 F) , 4 3 . 7 (1 F)

(I I) アミド化反応

11.0gのジエチルアミンを150mlの無水テトラヒドロフラン(THF)に溶かした溶液を-78℃に冷却し、窒素気流下、n-ブチルリチウム(BuLi)のn-ヘキサン溶液(1.6モル/リットル)100mlを滴下して-78℃で1時間攪拌し、得られた溶液に、54.9gの上記カルボン酸ナトリウム塩を150mlの無水THFに溶かした溶液を-78℃で滴下した。得られた混合物を室温まで昇温

後、室温で5時間攪拌することにより反応を行った。得られた反応混合物を濾過することにより、反応で生成した沈殿を除去した後、減圧下で溶媒を留去し、残渣を70℃で真空乾燥して、63.6gの黄色固体を得た。¹ºF-NMRスペクトルおよびIRスペクトルから、この固体は下記式:

 $CF_3CF(CO_2Na)OCF_2CF_2SO_2N(C_2H_5)_2$ で表わされるスルホンアミドであることが確認された。

¹⁹ F - NMR: δ (ppm) - 125. 2 (1F), 116. 1 (2F), -82. 2 (3F), -82 (1F),
-79 (1F)

IR (KBr): 2990, 1695, 1382, 122 3, 1162 c m⁻¹

(III) 脱炭酸-ビニル化反応

蒸留ヘッドを取り付けたフラスコに、上記工程(II)で得られたスルホンアミド 2 0 . 4 gを入れ、 8×1 0 $^{-3}$ M P a の圧力下 2 0 0 $\mathbb C$ で加熱し、発生する蒸気を凝縮し留出液として回収することにより、1 1 . 2 gの淡黄色液体を得た。 19 F $^{-3}$ よび 1 H $^{-1}$ N M R スペクトル、 I R スペクトルおよび G C $^{-1}$ M S から、この液体の主成分は下記式:

 $CF_2 = CFOCF_2CF_2SO_2N$ (C_2H_5) $_2$ で表わされるパーフルオロビニルエーテルであることが確認された。

¹⁹ F - N M R : δ (p p m) - 1 3 7 (1 F), - 1 2 4 (1 F), - 1 1 7. 6 (2 F), - 1 1 6 (1 F), -8 5. 3 (2 F)

 1 H-NMR: δ (ppm) 1. 27 (3H), 3. 3 \sim 3. 7 (2H)

IR (neat): 2988, 1390, 1215, 11 66cm⁻¹

EI-MS: m/z 136, 100, 97, 81, 44, 29

また、上記の液体は下記式:

 CF₃CHFOCF₂CF₂SO₂N (C₂H₅)₂
 で表わされるプロトン付加体を少量含むことも確認された (パーフルオロビニルエーテル:プロトン付加体=94:
 が、環化反応生成物は含んでいなかった。

実施例2

ガス導入管を有するステンレス製 2 0 0 m 1 耐圧容器に、 実施例 1 で得られたパーフルオロビニルエーテル(再蒸留に より精製したもの) 7 . 5 g、 2 2 gのH F C 4 3 - 1 0 m e e 及び(C F 3 C F 2 C F 2 C O O) 2 (重合開始剤) の 5 % H F C 4 3 - 1 0 m e e 溶液 2 . 2 gを入れ、容器内を 充分に窒素置換した後、ガス導入管よりテトラフルオロエチ レン (TFE) を容器内に導入し、容器の内圧を 0.5 MP aまで上昇させた。その後、内圧が 0.5 MP a に保たれる よう適宜TFEを導入しながら、攪拌下 2.5 ℃で 3.5 時間 反応を行った。

その後、TFEの導入を停止し、圧力を常圧に戻した後、得られた反応混合物(白濁した液体)にメタノールを加え、 析出した固体を濾過により回収し、メタノールで洗浄した後 乾燥して、0.7gの白色固体を得た。

19F-NMRスペクトルより、この固体は実施例1で得られたパーフルオロビニルエーテルに由来するモノマー単位 (スルホンアミド単位) およびTFEに由来するモノマー単位 (TFE単位) を含む共重合体であり、スルホンアミド単位とTFE単位の存在比(モル比)は1:8であることが確認された。

また、この共重合体を 2 5 0 ℃にてプレス成形することに より、共重合体膜を得ることができた。

比較例1

蒸留ヘッドを取り付けたフラスコに、実施例1の工程 (I)で合成したカルボン酸ナトリウム塩2、0gを入れ、 常圧下200℃で加熱し、発生する蒸気を凝縮し留出液とし て回収することにより、0.8gの無色液体を得た。¹°F -NMRスペクトルから、この液体は下記式: 1 2 7

で表わされる環化反応生成物であることが確認された。

¹⁹ F - N M R : δ (p p m) - 1 2 5 (1 F), -1 2 0 (1 F), -1 1 5. 3 (1 F), -9 0 (1 F), -8 0. 5 (3 F), -7 8 (1 F)

またこの液体には、実施例1で得られたパーフルオロビニ ルエーテルは全く含まれていなかった。

実施例3

(I) アミド化反応

ジメチルアミンのTHF溶液(2モル/リットル)13.
7m1を60mlのTHFで希釈した溶液を一78℃に冷却し、窒素気流下、n-BuLiのn-ヘキサン溶液(1. 6.
モル/リットル)18. 8mlを滴下して一78℃で1時間 機拌し、得られた溶液に、実施例1の工程(II)で得られたカルボン酸ナトリウム塩10gを40mlの無水THFに 溶かした溶液を一78℃で滴下した。得られた混合物を室温まで昇温後、室温で5時間機拌することにより反応を行った。 得られた反応混合物を濾過することにより、反応で生成した 沈殿を除去した後、減圧下で溶媒を留去し、残渣を70℃で

真空乾燥して、10.9gの黄色固体を得た。¹⁹F-NM Rスペクトルから、この固体は下記式:

 $CF_3CF(CO_2Na)OCF_2CF_2SO_2N(CH_3)_2$ で表わされるスルホンアミドであることが確認された。

^{1 9} F - N M R : δ (p p m) - 1 2 5 . 8 (1 F) , 1 1 5 . 2 (2 F) , -8 2 . 1 (3 F) , -8 2 (1 F) ,
-8 0 (1 F)

(II) 脱炭酸-ビニル化反応

蒸留ヘッドを取り付けたフラスコに、上記工程(I)で得られたスルホンアミド 2.0 gを入れ、 4×10^{-3} M P a の圧力下 250℃で加熱し、発生する蒸気を凝縮し留出液として回収することにより、0.77 gの淡黄色液体を得た。 1^9 F - N M R スペクトルから、この液体の主成分は下記式:

 $CF_2 = CFOCF_2CF_2SO_2N$ (CH_3) 2 で表わされるパーフルオロビニルエーテルであることが確認された。

¹⁹ F - N M R : δ (p p m) - 1 3 7 (1 F), - 1 2 4 (1 F), - 1 1 6. 7 (2 F), - 1 1 6 (1 F), -8 5. 8 (2 F)

また、上記の液体は下記式:

 $CF_3CHFOCF_2CF_2SO_2N$ (CH_3) 2 で表わされるプロトン付加体を少量含むことも確認された (パーフルオロビニルエーテル:プロトン付加体=89:1 1) が、環化反応生成物は含んでいなかった。

実施例4

(I) アミド化反応

ジメチルアミンのTHF溶液に代えて2.54gのアニリンを用いた以外は、実施例3の工程(I)と同様の操作を行い、13.0gの黄色固体を得た。19F-NMRスペクトルから、この固体は下記式:

で表わされるスルホンアミドであることが確認された。

¹⁹ F - N M R : δ (p p m) - 1 3 1 . 2 (1 F) ,
1 1 5 . 5 (2 F) , - 8 6 (1 F) , - 8 2 . 3 (3 F) ,

- 7 5 (1 F)

(I I) 脱炭酸ービニル化反応

上記工程 (I) で得られたスルホンアミド 2. 0 g を 1 0 m l のジグライムに溶解し、得られた溶液を窒素気流下 1 5 0 ℃で加熱した。得られた反応混合物を G C で分析したとこ

ろ 2 種類の生成物が確認されたが、これらはいずれも比較例 1 で得られた環化反応生成物ではなかった。

反応混合物中の溶媒を減圧で留去した後、残液を減圧蒸留して、0.4gの黄色液体を得た。1°F-NMRスペクトルから、この液体の主成分は下記式:

で表わされるパーフルオロビニルエーテルであることが確認された。

¹⁹F-NMR: δ (ppm) - 136 (1F), -12
2 (1F), -114.8 (2F), -113 (1F), 83.7 (2F)

また、上記の液体は下記式:

で表わされるプロトン付加体を少量含むことも確認されたが、 環化反応生成物は含んでいなかった。

実施例5

(I) アミド化反応

ジメチルアミンのTHF溶液に代えて2.0gのt-ブチルアミンを用いた以外は、実施例3の工程(I)と同様の操作を行い、11.3gの黄色固体を得た。¹゚F-NMRスペクトルから、この固体は下記式:

CF₃CF(CO₂Na)OCF₂CF₂SO₂NH^tBu (式中、「Buはtープチル基を表わす。以後も同様。) で表わされるスルホンアミドであることが確認された。

¹⁹ F - NMR: δ (ppm) - 131. 2 (1F),
116 (2F), -86 (1F), -82. 4 (3F),
76 (1F)

(I I) 脱炭酸-ビニル化反応

実施例3の工程(I)で得られたスルホンアミド2.0g に代えて、上記工程(I)で得られたスルホンアミド2.2 gを用いた以外は、実施例3の工程(II)と同様の操作を 行い、0.57gの淡黄色液体を得た。¹⁹F-NMRスペ クトルから、この液体の主成分は下記式:

 $CF_2 = CFOCF_2CF_2SO_2NH$ 「Bu で表わされるパーフルオロビニルエーテルであることが確認 された。

¹⁹ F - NMR: δ (ppm) - 136 (1F), -12
2 (1F), -116.3 (2F), -115 (1F), 83.9 (2F)

また、上記の液体は下記式:

CF₃CHFOCF₂CF₂SO₂NH¹Bu で表わされるプロトン付加体を少量含むことも確認されたが、 環化反応生成物は含んでいなかった。

実施例6

水素化ナトリウム鉱油分散液(水素化ナトリウム含有率: 60%)1.7gを、窒素気流下n-ヘキサンで洗浄して鉱 油を除去し、得られた水素化ナトリウム粉末に150mlの 無水アセトニトリルを加え、得られた混合物を0℃に冷却し、 2.7gのピロールを滴下した後、室温まで昇温して1時間 攪拌し、ピロールナトリウムアミド溶液を得た。

得られた溶液を、実施例1の工程(II)で得られたカルボン酸ナトリウム塩15gを100mlの無水アセトニトリルに溶解した溶液に0℃で滴下した。得られた混合物を室温まで昇温後、室温で12時間攪拌することにより反応を行った。得られた反応混合物を濾過することにより、反応で生成した沈殿を除去した後、減圧下で溶媒を留去し、残渣を50℃で真空乾燥して、18.3gの褐色固体を得た。¹9F-NMRスペクトルから、この固体は下記式:

で表わされるスルホンアミドであることが確認された。

¹⁹F-NMR: δ (ppm) - 125.3 (1F), 115.1 (2F), -82.3 (3F), -81 (1F),
-79 (1F)

(I I) 脱炭酸ービニル化反応

蒸留ヘッドを取り付けたフラスコに、上記工程(I)で得られたスルホンアミド 2.1 gを入れ、2.6×10 $^{-3}$ M P aの圧力下 230 $^{\circ}$ で加熱し、発生する蒸気を凝縮し留出液として回収することにより、0.4gの淡黄色液体を得た。 $^{1.9}$ F $^{-1}$ および 1 H $^{-1}$ N M R スペクトルから、この液体の主成分は下記式:

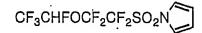
で表わされるパーフルオロビニルエーテルであることが確認された。

¹⁹F-NMR: δ (ppm) - 137 (1F), -12 2 (1F), -115. 9 (2F), -115 (1F), -84. 5 (2F)

 1 H - N M R : δ (ppm) 6. 47 (2 H), 7. 13 (2 H)

134

また、上記の液体は下記式:



で表わされるプロトン付加体を少量含むことも確認されたが、 環化反応生成物は含んでいなかった。

実施例7

(1) 中和反応

下記式:

 $CF_3CF(COF)OCF_2CF_2SO_2F$ で表わされる化合物 1 0 3 . 8 g に代えて、下記式:

CF₃CF(COF)OCF₂CF₂CF₂SO₂Fで表わされる化合物 2 0.0gを用いた以外、実施例 1 の工程(I)と同様の操作を行い、白色固体を得た。機器分析の結果、この固体は下記式:

CF₃CF(CO₂Na)OCF₂CF₂CF₂SO₂Fで表わされるカルボン酸ナトリウム塩であることが確認された。

(II) アミド化反応

実施例1の工程(I)で得られたカルボン酸ナトリウム塩

54.9gに代えて、上記工程(I)で得られたカルボン酸ナトリウム塩15.0gを用いた以外、実施例1の工程

(I)と同様の操作を行い、黄色固体を得た。機器分析の結果、この固体は下記式:

 $CF_3CF(CO_2Na)OCF_2CF_2CF_2SO_2N(C_2H_5)_2$ で表わされるスルホンアミドであることが確認された。

(I I I) 脱炭酸ーピニル化反応

実施例1の工程(II)で得られたスルホンアミド20.4gに代えて、上記工程(II)で得られたスルホンアミド11.4gを用いた以外、実施例1の工程(III)と同様の操作を行い、淡黄色液体を得た。機器分析の結果、この液体の主成分は下記式:

 $CF_2 = CFOCF_2CF_2CF_2SO_2N$ $(C_2H_5)_2$ で表わされるパーフルオロビニルエーテルであることが確認された。

また、上記の液体は下記式:

 $CF_3CHFOCF_2CF_2CF_2SO_2N$ (C_2H_5) 2 で表わされるプロトン付加体を少量含むことも確認されたが、 環化反応生成物は含んでいなかった。

(I) アミド化反応

実施例1の工程(II)で得られたカルボン酸ナトリウム 塩54.9gを150mlの無水THFに溶かし、得られた 溶液を0℃に冷却し、ナトリウムヘキサメチルジシラジドの THF溶液(1M)150mlを滴下し、得られた混合物を 室温まで昇温後、12時間攪拌することにより反応を行った。 得られた反応混合物を濾過することにより、反応で生成した 沈殿を除去した後、減圧下で溶媒を留去し、残渣を80℃で 真空乾燥して、67.5gの黄褐色固体を得た。機器分析の 結果、この固体はスルホンアミド構造を有する化合物であり、 出発物質であるカルボン酸ナトリウム塩を含まないことが確 認された。

(II) 脱炭酸ービニル化反応

上記工程(I)で得られた化合物66gを300m1のジグライムに溶解し、得られた溶液を窒素気流下150℃で1時間加熱した。得られた反応混合物を¹°F-NMRで分析したところ、パーフルオロビニル基を有する生成物2種類(いずれも未同定)の存在が確認された。

反応混合物中の溶媒を減圧で留去した後、残液に水を加え、 さらに塩酸で酸性にしてからHFC43-10meeで抽出 した。得られた抽出物中の溶媒を減圧下で留去した後、残液 を圧力1.3×10⁻³MPaで減圧蒸留し、沸点130~ 133℃の留分を回収することにより、21.1gの微黄色 液体を得た。¹⁹F-NMRスペクトルおよびGC-MSか ら、この液体の主成分は下記式:

 $CF_2 = CFOCF_2CF_2SO_2NH_2$ で表わされるパーフルオロビニルエーテルであることが確認された。

¹⁹ F - NMR: δ (ppm) - 137 (1F), -12
4 (1F), -118. 6 (2F), -116 (1F), 84. 8 (2F)

EI-MS: m/z 180, 100, 97, 81, 80, 64, 16

また、上記の液体は下記式:

CF₃CHFOCF₂CF₂SO₂NH₂で表わされるプロトン付加体を少量含むことも確認されたが、 環化反応生成物は含んでいなかった。

実施例9

実施例8の工程(II)における残液の減圧蒸留を行わないこと以外は、実施例8の工程(I)~(II)と同様の操作を行い、残液を得た。この残液は主として実施例8で得られたパーフルオロビニルエーテルからなるが、実施例8で述べたプロトン付加体等の不純物を含んでいる。

この残液 4.4 gにヘキサメチルジシラザン7.0 gを加えて1.0.0 ℃で2 時間反応させ、得られた反応混合物中の未反応のヘキサメチルジシラザンを留去した後、残液を圧力3...9 × 1.0^{-4} M P a で減圧蒸留し、沸点1.1.5 ~ 1.1.8 ℃の留分を回収することにより、1.7...9 gの淡黄色液体を得た。1.9 F -N M R スペクトルおよび G C -M S から、この液体は下記式:

 $CF_2 = CFOCF_2CF_2SO_2NHSiMe_3$ で表わされるパーフルオロビニルエーテルであることが確認された。

¹⁹ F - N M R : δ (p p m) - 1 3 6 (1 F), -1 2
3. 5 (1 F), -1 1 7. 6 (2 F), -1 1 6 (1 F),
-8 4. 0 (2 F)

実施例10

(I) CF₃CHFOCF₂CF₂SO₂Fの合成

蒸留ヘッドを取り付けたフラスコを用い、炭酸ナトリウム 135gと500mlのジグライムからなるスラリー中に、 室温で、下記式:

CF₃CF (COF) OCF₂CF₂SO₂F で表わされる化合物 (実施例1の工程 (I) で用いたものと 同じ) 400gを滴下し、得られた混合物を室温で1時間、 40℃で1時間攪拌することにより反応を行った。得られた 反応混合物に21m1の水を加えて100℃に加熱し、発生する蒸気を凝縮して留出液として回収し、水で洗浄した後乾燥し、176gの無色液体を得た。19F-NMRスペクトルから、この液体は下記式:

CF₃CHFOCF₂CF₂SO₂F で表わされる化合物であることが確認された。

¹⁹F-NMR: δ (ppm) - 147.9 (1F),
114.2 (2F), -86.5 (3F), -87.0,
84.6 (2F), 42.7 (1F)

(II) アミド化反応

水素化ナトリウム鉱油分散液(水素化ナトリウム含有率: 60%)25gを窒素気流下n-ヘキサンで洗浄して鉱油を 除去し、得られた水素化ナトリウム粉末に300mlの無水 ジメトキシエタンを加え、得られた混合物を0℃に冷却し、 38.5gのイミダゾールを200mlのジメトキシエタン に溶かした溶液を滴下した後、室温まで昇温して1時間攪拌 し、イミダゾールナトリウムアミド溶液を得た。

得られた溶液を0℃に冷却し、上記工程(I)で得られた 化合物170gを滴下した。得られた混合物を室温まで昇温 後、室温で12時間攪拌することにより反応を行った。得ら れた反応混合物に少量の水を加え、ジメトキシエタンを減圧 で留去し、残液に少量の水を加え、HFC43-10mee で抽出した。得られた抽出液を希NaOH水溶液で洗浄し、 乾燥した後、溶媒を留去し、残液を圧力 3. 9×10^{-4} M Paで減圧蒸留し、沸点 $64 \sim 66$ $\mathbb C$ の留分を回収すること により 112 g の無色液体を得た。 19 F - N M R スペクト ルおよび G C - M S から、この液体は下記式:

CF3CHFOCF2CF2SO2N N

で表わされるスルホンアミドであることが確認された。

¹⁹ F - NMR: δ (ppm) - 148.0 (1F), 115.5 (2F), -86.0 (3F), -84.5, 83.0 (2F)

(I I I) ビニル化反応 (脱フッ化水素反応)

ヘキサメチルジシラザン $1 \ 4 \ 5 \ m \ 1 \ \epsilon \ 5 \ 0 \ 0 \ m \ 1 \ 0 \ m \ 1 \ m \ K \ T$ H F に溶解した溶液を $-7 \ 8 \ C$ に冷却し、窒素気流下、 $n-B \ u \ L \ i \ o \ n \ -$ ヘキサン溶液($1 \ . \ 6 \ M$) $4 \ 3 \ 1 \ m \ 1 \ \epsilon \ n$ した。得られた混合物を $-7 \ 8 \ C$ で $3 \ 0 \ D$ 間攪拌してリチウムヘキサメチルジシラジド溶液を得た。

得られた溶液を 0 ℃まで昇温し、上記工程(II)で得られたスルホンアミド 1 0 4 . 4 g を 2 0 0 m 1 の T H F に溶解した溶液を滴下し、得られた混合物を 0 ℃で 1 時間攪拌することにより反応を行った。

得られた反応混合物に少量の水を加え、THFを留去し、残液に少量の水およびHFC43-10meeを加え、得られた混合物を濾過して不溶物を除き、有機相を乾燥後、溶媒を留去し、残液を圧力3.9×10⁻⁴ MPaで減圧蒸留し、沸点60~62℃の留分を回収することにより57.6gの無色液体を得た。 19 F-NMRスペクトルおよびGC-MSから、この液体は下記式:

で表わされるパーフルオロビニルエーテルであることが確認された。

¹ ⁹ F - N M R : δ (p p m) - 1 3 7 . 8 (1 F) , -1 2 3 . 0 (1 F) , - 1 1 5 . 7 (2 F) , - 1 1 5 . 5 (1 F) , - 8 4 . 5 (2 F)

実施例11

実施例10の工程(III)において、ヘキサメチルジシラザン145mlに代えてジイソプロピルアミン96m1を用い、リチウムヘキサメチルジシラジド溶液に代えてリチウムジイソプロピルアミド溶液を調製した以外、実施例10と同様の操作を行った。その結果、実施例10において得られたものと同じパーフルオロビニルエーテルが得られた。

実施例12

実施例3で得られたパーフルオロビニルエーテルおよびプロトン付加体の混合物(パーフルオロビニルエーテル:プロトン付加体=89:11)0.7gを10m1のTHFに溶解し、得られた溶液に、窒素気流下、0℃で、ナトリウムヘキサメチルジシラジドのTHF溶液(1M)を1.5m1滴下し、得られた混合物を室温まで昇温して12時間攪拌することにより反応を行った。

得られた反応混合物をGCで分析したところ、プロトン付加体は消失していた。また、この反応混合物を¹⁹ F - N M R で分析したところ、パーフルオロビニルエーテルのみが含まれていることが確認された。

実施例13

実施例1で得られたパーフルオロビニルエーテル7.5g に代えて実施例5で得られたパーフルオロビニルエーテル1 5gを用いた以外は、実施例2と同様に重合反応を行った。

得られた反応混合物にメタノールを加え、析出した固体を回収し、洗浄、乾燥して1.5gの白色固体を得た。

1°F-NMRスペクトルより、この固体は実施例5で得られたパーフルオロビニルエーテルに由来するモノマー単位(スルホンアミド単位)およびTFEに由来するモノマー単

位 (TFE単位) を含む共重合体であり、スルホンアミド単位とTFE単位の存在比(モル比) は1:4であることが確認された。

実施例14

得られた溶液を0 \mathbb{C} まで昇温し、実施例1 0 の工程(I)で得られた化合物 1 7 0 g を滴下し、得られた混合物を0 \mathbb{C} で 1 時間攪拌することにより反応を行った。

得られた反応混合物に少量の水を加えた後、THFを留去し、残液に希塩酸を加えて酸性にし、HFC43-10meeで抽出した。抽出液を乾燥後、溶媒を留去し、残液を圧力0.4kPaで減圧蒸留し、沸点87℃の留分を回収することにより115gの無色液体を得た。この液体の¹ºF-NMRスペクトルは、実施例8で得られたパーフルオロビニルエーテルの¹ºF-NMRスペクトルと一致した。また、この液体は実施例8で述べたプロトン付加体を含んでいなかった。

実施例15

実施例1で得られたパーフルオロビニルエーテル7.5g に代えて実施例14で得られたパーフルオロビニルエーテル 8gを用いた以外は、実施例2と同様に重合反応を行った。

得られた反応混合物にメタノールを加えた後、溶媒と未反応のモノマーを減圧留去し、析出した固体を回収し、洗浄、乾燥して 0.8gの淡褐色固体を得た。

1°F-NMRスペクトルより、この固体は実施例14で得られたパーフルオロビニルエーテルに由来するモノマー単位(スルホンアミド単位)およびTFEに由来するモノマー単位(TFE単位)を含む共重合体であり、スルホンアミド単位とTFE単位の存在比(モル比)は1:4であることが確認された。

実施例16

(I) 3元共重合体膜の製造

ガス導入管を有するステンレス製200m1耐圧容器に、 ・ ・ ・

で表わされるモノマー (以降「SO₂Fモノマー」と称する) 1 6 g、実施例 1 4 で得られたパーフルオロビニルエー

テル4g、40gのHFC43-10meeおよび重合開始 剤として(CF₃CF₂CF₂COO) $_2$ の5%HFC43- $_1$ 0mee溶液 $_1$ 0.85gを入れ、容器内を充分に窒素置換 した後、ガス導入管よりテトラフルオロエチレン(TFE) を容器内に導入し、容器の内圧を $_1$ 0.3MPaまで上昇させ た。その後、内圧が $_1$ 0.3MPaに保たれるよう適宜TFE を導入しながら、攪拌下 $_2$ 5℃で4.5時間反応を行った。

その後、TFEの導入を停止し、圧力を常圧に戻した後、得られた反応混合物(白色ゲル状)にメタノールを加え、析出した固体を濾過により回収し、洗浄した後乾燥して、6.5gの白色固体を得た。

1°F-NMRスペクトルより、この固体は実施例14で得られたパーフルオロビニルエーテルに由来するモノマー単位(スルホンアミド単位)、上記SO2Fモノマーに由来するモノマー単位(SO2F単位)およびTFEに由来するモノマー単位(TFE単位)を含む3元共重合体であり、スルホンアミド単位、SO2F単位およびTFE単位の存在比(モル比)は0.2:1.0:5.3であることが確認された。またこの固体のIRスペクトルにおいて、スルホンアミド基に基づくピーク(3391、3306および1544cm-1)が確認された。

得られた 3 元共重合体を 2 7 0 ℃でプレス成形することにより、 無色透明な 3 元共重合体膜 (膜厚 8 2 μm) を得るこ

146

とができた。

(II) 高分子固体電解質膜の製造

上記工程 (I) で得られた 3 元共重合体膜を、トリエチルアミンのジオキサン溶液 (ジオキサン:トリエチルアミン=5:3 (容量比)) 中に浸漬して 3 時間加熱還流した後、洗浄、乾燥(以降、この処理を「変性処理」と称する) して変性 3 元共重合体膜を得た。

その後、4N硫酸に90℃で1時間浸漬し、水洗、乾燥することにより、高分子固体電解質膜を得た。

得られた高分子固体電解質膜の引張弾性率は、150℃で 1. 2×10^8 d y n e / c m 2、300℃で 6. 3×10^7 d y n e / c m 2であった。

実施例17

(I) 3元共重合体膜の製造

 SO_2F モノマーの量を 22.1g、パーフルオロビニル

エーテルの量を 0. 1 4 g に変更した以外、実施例 1 6 の工程 (I)と同様に重合を行い、 6. 6 g の白色固体を得た。

¹⁹F-NMRスペクトルより、この固体はSO₂F単位 およびTFE単位を含み、SO₂F単位およびTFE単位の 存在比(モル比)は1.0:4.5であることが確認された。

またIRスペクトルより、この固体はスルホンアミド単位を含み、その含有量はスルホンアミド単位、SO2F単位およびTFE単位の合計量(mol)に対し0.8mol%であることが確認された。

以上のことから、得られた固体はスルホンアミド単位、SO2F単位およびTFE単位を含む3元共重合体であることが確認された。

この3元共重合体のメルトインデックスは3.8であった (上記の共重合を4倍スケールで繰り返し、得られた3元共 重合体のうち11.3gを用いて測定)。

得られた3元共重合体を270℃でプレス成形することにより、無色透明な3元共重合体膜(膜厚83μm)を得ることができた。

(I I) 高分子固体電解質膜の製造

実施例16の工程(I)で得られた3元共重合体膜に代えて上記工程(I)で得られた3元共重合体膜を用いる以外、 実施例16の工程(II)と同様の操作を行い、高分子固体 電解質膜を得た。

得られた高分子固体電解質膜の引張弾性率は、150℃で 8. 6×10^7 d y n e / c m 2 、300 ℃で 2. 0×10^7 d y n e / c m 2 であった。

比較例-2

実施例 1 6 の工程 (I) で得られた 3 元共重合体膜に代えて下記式 (3 6):

で表わされる2元共重合体(k:l=5:1)を製膜することにより得られた2元共重合体膜(膜厚48μm)を用い、変性処理を行わなかった以外、実施例16の工程(II)と同様の操作を行い、高分子固体電解質膜を得た。

得られた高分子固体電解質膜のプロトン伝導率は、0.1 01S/cmであった。

得られた高分子固体電解質膜の引張弾性率は、150 $\mathbb C$ で 3.1×10^7 d y n e / c m 2 であった。しかし、この高分子固体電解質膜は約180 $\mathbb C$ で溶融してしまうため、30 $\mathbb C$ における引張弾性率の測定はできなかった。

また、実施例16の工程(I)で得られた3元共重合体膜に代えて上記の2元共重合体膜を用いる以外、実施例16の

工程(II)と同様の操作を行い、高分子固体電解質膜を得た。

得られた高分子固体電解質膜の引張弾性率は、150℃で 3.1×10^7 d y n e / c m 2 であった。しかし、この高分子固体電解質膜もまた約180℃で溶融してしまうため、300℃における引張弾性率の測定はできなかった。

比較例3

変性処理を行わなかった以外、実施例16の工程(II)と同様の操作を行い、高分子固体電解質膜を得た。

得られた高分子固体電解質膜の引張弾性率は、150℃で 3.1×10^7 d y n e / c m 2 であった。しかし、この高分子固体電解質膜は約200℃で溶融してしまうため、300℃における引張弾性率の測定はできなかった。

実施例18

(1) 臭素化反応

下記式(37):

で表わされるスルホニルフルオリド 5 4 g を 4 0 m 1 の H F C 4 3 - 1 0 m e e に溶解し、得られた溶液に、攪拌下室温

で、色が消えなくなるまで臭素を滴下し(12gの臭素を使用)、得られた混合物を室温で1時間攪拌することにより反応を行った。

得られた反応混合物中の未反応の臭素および溶媒を留去し、 残液を圧力 6 . 7 × 1 0 ³ P a で減圧蒸留し、沸点 1 1 0 [℃] の留分を回収することにより 6 7 g の液体を得た。 ^{1 9} F -N M R スペクトルから、この液体は下記式 (3 8) :

$$CF_2Br-CFBr-OCF_2CFOCF_2CF_2SO_2F$$
 CF_3
(38)

で表わされる臭素付加体であることが確認された。

1 ° F - N M R : δ (p p m) - 1 4 6 . 6 (1 F) , 1 1 4 . 0 (2 F) , -8 7 . 5 , -8 3 . 6 (2 F) , 8 1 . 5 (3 F) , -8 1 (2 F) , -7 3 (1 F) , -6
5 . 0 (2 F) , 4 3 . 4 (1 F)

(II) アミド化反応

上記工程 (I) で得られた臭素付加体 (38) 40gを3 0mlのグライムに溶解し、得られた溶液に室温で20gの ジエチルアミンを滴下し、50℃で5時間反応を行った。

得られた反応混合物を水中に注ぎ、HFC43-10meeで抽出し、得られた抽出液を希塩酸で洗浄後、溶媒を留去することにより、41gの液体を得た。19F-NMRスペ

151

クトルから、この液体は下記式(39):

$$CF_2Br-CFBr-OCF_2CFOCF_2CF_2SO_2NEt_2$$
 (39)

で表わされるスルホンアミドであることが確認された。

¹⁹ F - NMR: δ (ppm) - 146.6 (1F),
117.4 (2F), -87, -83 (2F), -81.2

(3F), -80.6 (2F), -72.7 (1F), -6

4.8 (2F)

(ІІІ) ビニル化反応 (脱ハロゲン反応)

上記工程(II)で得られたスルホンアミド(39)40 gを160gのジメチルホルムアミドに溶解し、得られた溶 液に亜鉛粉末6.1g(予め希塩酸で洗浄した後乾燥したも の)を加え、80℃で2.5時間反応を行った。

得られた反応混合物を水中に注ぎ、HFC43-10mee で抽出し、得られた抽出液中の溶媒を留去し、残液を圧力4. $0 \times 10^2 P$ a で減圧蒸留し、沸点 128∇ の留分を回収することにより 15g の液体を得た。 $1^g F - NMR$ スペクトルから、この液体は下記式(40):

$$CF_2 = CF - OCF_2CFOCF_2CF_2SO_2NEt_2$$
 (4 0)
 CF_3

で表わされるパーフルオロビニルエーテルであることが確認された。

1 ° F - N M R : δ (p p m) - 1 4 6 . 5 (1 F) , 1 3 7 . 9 (1 F) , - 1 2 4 . 1 (1 F) , - 1 1 7 . 9
(2 F) , - 1 1 6 . 5 (1 F) , 8 6 . 7 (2 F) , - 8
1 . 8 (3 F) , - 8 0 . 7 (2 F)

実施例19

ガス導入管を有するステンレス製200m1耐圧容器に、 実施例18で得られたパーフルオロビニルエーテル(40) (再蒸留により精製したもの)7.5g、22gのHFC4 3-10mee及び(CF₃CF₂COO)₂(重合開 始剤)の5%HFC43-10mee溶液2.2gを入れ、 容器内を充分に窒素置換した後、ガス導入管よりTFEを容 器内に導入し、容器の内圧を0.4MPaまで上昇させた。 その後、内圧が0.4MPaに保たれるよう適宜TFEを導 入しながら、攪拌下25℃で3.5時間反応を行った。

その後、TFEの導入を停止し、圧力を常圧に戻した後、得られた反応混合物(白濁した液体)にメタノールを加え、 析出した固体を濾過により回収し、メタノールで洗浄した後 乾燥して、1.2gの白色固体を得た。

1°F-NMRスペクトルより、この固体はパーフルオロ ビニルエーテル (40) に由来するモノマー単位 (スルホン アミド単位) およびTFEに由来するモノマー単位 (TFE単位) を含む共重合体であり、スルホンアミド単位とTFE単位の存在比 (モル比) は1:4であることが確認された。

また、この共重合体を250℃にてプレス成形することにより、共重合体膜を得ることができた。

比較例4

実施例18の工程(I)で用いたスルホニルフルオリド
(37)3gを3m1のグライムに溶解し、得られた溶液に
室温で2gのジエチルアミンを滴下したところ、発熱を伴う
反応が起こり、固体(不溶物)を含む反応混合物が得られた。

得られた反応混合物をGCで分析した結果、反応混合物は複雑な混合物であり、目的のパーフルオロビニルエーテル (即ち、実施例18で得られたパーフルオロビニルエーテル (40)) は極く少量しか含んでいないことが確認された。

実施例20

(I) 塩素化反応

下記式:

 $C.F_2 = CFOCF_2CF_2SO_2F$

で表わされるスルホニルフルオリド14gを40m LのHF С43-10m e e に溶解し、得られた溶液をガス導入管を 有する反応器に入れ、攪拌下室温で、塩素ガスを吹き込むこ とにより反応を行った。反応は、反応器内容物のガスクロマトグラムにおいて、上記スルホニルフルオリドに由来するピークが消失するまで継続した。

得られた反応混合物中の溶媒を留去し、残液を減圧蒸留することにより15gの液体を得た。この液体の19 F -NM R スペクトルが、文献(J. Fluorine Chem., 58, 59 (1992) (オランダ))に記載された数値と一致したことから、この液体は下記式:

CF2CICFCIOCF2CF2SO2F で表わされる塩素付加体であることが確認された。

(II) アミド化反応

上記工程 (I) で得られた塩素付加体 1 3 g を 1 5 m l の グライムに溶解し、得られた溶液に室温で 7 g のジエチルア ミンを滴下し、50℃で5時間反応を行った。

得られた反応混合物を水中に注ぎ、HFC43-10meeで抽出し、得られた抽出液を希塩酸で洗浄後、溶媒を留去することにより、15gの液体を得た。機器分析の結果、この液体は下記式:

 $CF_2CICFCIOCF_2CF_2SO_2N(C_2H_6)_2$

で表わされるスルホンアミドであることが確認された。

(ІІІ) ビニル化反応(脱ハロゲン反応)

上記工程(II)で得られたスルホンアミド15gを60gのジメチルホルムアミドに溶解し、得られた溶液に亜鉛粉末3.1g(予め希塩酸で洗浄した後乾燥したもの)を加え、80℃で2.5時間反応を行った。

得られた反応混合物を水中に注ぎ、HFC43-10mee で抽出し、得られた抽出液中の溶媒を留去し、残液を圧力4. $0 \times 10^3 P$ a で減圧蒸留し、沸点130 $\mathbb C$ の留分を回収することにより7.5gの液体を得た。19F-NMRスペクトルから、この液体は下記式:

 $CF_{2} = CFOCF_{2}CF_{2}SO_{2}N(C_{2}H_{5})_{2}$

で表わされるパーフルオロビニルエーテルであることが確認された。

¹⁹ F - N M R: δ (p p m) - 137 (1 F), -12
4 (1 F), -117. 6 (2 F), -116 (1 F), 85. 3 (2 F)

参考例1

水素化ナトリウム鉱油分散液(水素化ナトリウム含有率: 60%)2.5gを窒素気流下n-ヘキサンで洗浄して鉱油 を除去し、得られた水素化ナトリウム粉末に30m1の無水ジメトキシエタンを加え、得られた混合物を0℃に冷却し、3.9gのイミダゾールを20m1のジメトキシエタンに溶かした溶液を滴下した後、室温まで昇温して1時間攪拌し、イミダゾールナトリウムアミド溶液を得た。

得られた溶液を、比較例2で用いた共重合体(36)の粉末1gを無水ジオキサン中に分散させた分散液中に室温で滴下し、室温で4時間、次いで70℃で8時間攪拌することにより反応を行った。

得られた反応混合物を濾過して固体を回収し、水、ジメトキシエタン、HFC43-10meeの順に洗浄してから乾燥することにより固体を得た。

得られた固体のIRスペクトルを、上記共重合体(36)のIRスペクトルと比較したところ、後者において観測されるSO2F基に基づくピークが前者では観測されず、代わりにスルホンアミド基に基づくピークが観測された。このことから、得られた固体においては上記共重合体(36)のSO2F基がイミダゾールによりアミド化されスルホンアミド基となっていることが確認された。以降この固体を「アミド化共重合体」と称する。

このアミド化共重合体を280℃にてプレス成形すること により、共重合体膜を得ることができた。

この共重合体膜を3cm×3cmの正方形に切断し、3N

硫酸30m1中に浸漬して90℃で1時間浸漬し、水洗、乾燥することにより、高分子固体電解質膜を得た。

得られた高分子固体電解質膜のIRスペクトルは、比較例2で得られた高分子固体電解質膜のIRスペクトルと一致しており、またこのIRスペクトルにはアミド基に基づくピークが観測されなかった。このことから、得られた高分子固体電解質膜においては、スルホンアミド基が遊離スルホン酸基に変換されていることが確認された。

一方、共重合体(36)を製膜することにより得られた2元共重合体膜(比較例2で用いたものと同じ)を、上記と同様に3N硫酸30m1中に浸漬して90℃で1時間浸漬した後、水洗、乾燥したが、2元共重合体膜中のSO2Fは変化しなかった。

実施例21

(I) アミド化反応

参考例1に記載の方法により得られたイミダゾールナトリウムアミド溶液を0℃に冷却し、実施例18の工程(I)で得られた臭素付加体(38)10gを20m1のジメトキシエタンに溶解した溶液を滴下した。得られた混合物を室温まで昇温後、室温で12時間攪拌することにより反応を行った。得られた反応混合物に少量の水を加え、ジメトキシエタンを減圧で留去し、残液に少量の水を加え、HFC43-10m

e e で抽出した。得られた抽出液を水で洗浄した後乾燥し、溶媒を留去することにより11gの液体を得た。¹⁹ F - N M R スペクトルおよび G C - M S から、この液体は下記式 (4-1):

$$-CF_2Br - CFBr - OCF_2CFOCF_2CF_2SO_2N \bigcirc N$$

$$-CF_3$$

$$(4 1)$$

で表わされるスルホンアミドであることが確認された。

¹ ° F - N M R : δ (p p m) - 1 4 7 (1 F), - 1 1
7 (2 F), - 8 7, - 8 3 (2 F), - 8 1 (3 F), 8 0. 5 (2 F), - 7 3 (1 F), - 6 5 (2 F)

(II) ピニル化反応(脱ハロゲン反応)

上記工程(II)で得られたスルホンアミド(41)10 gを40gのジメチルホルムアミドに溶解し、得られた溶液 に亜鉛粉末1.5g(予め希塩酸で洗浄した後乾燥したも の)を加え、80℃で2.5時間反応を行った。

得られた反応混合物を水中に注ぎ、HFC43-10meeで抽出し、得られた抽出液中の溶媒を留去し、残液を圧力4.0×10 2 Paで減圧蒸留し、沸点140~150 $^{\circ}$ Cの留分を回収することにより6gの液体を得た。 $^{19}F-NM$ Rスペクトルから、この液体は下記式(42):

で表わされるパーフルオロビニルエーテルであることが確認された。

1°F-NMR: δ (ppm) -147 (1F), -13
8 (1F), -124 (1F), -118 (2F), -11
6. 5 (1F), 86. 5 (2F), -82 (3F), -8
1 (2F)

実施例 2 2

(I) 中和反応

10.6gの炭酸ナトリウムと50mlのアセトニトリルからなるスラリー中に、窒素気流下、室温で、下記式(43):

で表わされる化合物 5 1. 2 g を滴下し、得られた混合物を室温で1時間、40℃で1時間攪拌することにより反応を行った。得られた反応混合物を濾過することにより、反応で生成した沈殿を除去した後、減圧下で溶媒を留去することにより、5 3. 0 g の白色固体を得た。機器分析の結果、この固

160

体は下記式(44):

であることが確認された。

(II) アミド化反応

上記工程(I)で得られたカルボン酸ナトリウム塩47.9gを100m1の無水THFに溶かし、得られた溶液を0℃に冷却し、ナトリウムヘキサメチルジシラジドのTHF溶液(1 M)90m1を滴下し、得られた混合物を室温まで昇温後、12時間攪拌することにより反応を行った。得られた反応混合物を濾過することにより、反応で生成した沈殿を除去した後、減圧下で溶媒を留去し、残渣を80℃で真空乾燥して、55.4gの黄褐色固体を得た。機器分析の結果、この固体はスルホンアミド構造を有する化合物であり、出発物質であるカルボン酸ナトリウム塩を含まないことが確認された。

(I I I) 脱炭酸-ビニル化反応

上記工程(II)で得られたスルホンアミド 50 g を 20 0 m 1 のジグライムに溶解し、得られた溶液を窒素気流下 1 50 \mathbb{C} で 1 時間加熱した。得られた反応混合物を 1 9 F-N

MRで分析したところ、パーフルオロピニル基を有する生成物 2 種類 (いずれも未同定) の存在が確認された。

反応混合物中の溶媒を減圧で留去した後、残液に水を加え、 さらに塩酸で酸性にしてからHFC43-10meeで抽出 した。得られた抽出物中の溶媒を減圧下で留去した後、残液 を圧力1.3×10⁻³MPaで減圧蒸留し、沸点155~ 160℃の留分を回収することにより、24.5gの微黄色 液体を得た。 19 F-NMRスペクトルおよびGC-MSか ら、この液体は下記式(45):

$$CF_2 = CF - OCF_2CFOCF_2CF_2SO_2NH_2$$

$$CF_3$$

$$(4 5)$$

で表わされるパーフルオロビニルエーテルであることが確認された。

¹⁹ F - N M R : δ (p p m) - 1 4 6 . 5 (1 F) .
1 3 7 (1 F) . - 1 2 4 (1 F) . - 1 1 8 . 9 (2 F) .

- 1 1 6 (1 F) . - 8 6 . 4 (2 F) . - 8 1 . 5 (3

F) . - 8 0 . 5 (2 F)

実施例23

実施例22で得られたパーフルオロビニルエーテル(4 5)10gにヘキサメチルジシラザン30gを加えて10 0℃で2時間反応させ、得られた反応混合物中の未反応のヘ キサメチルジシラザンを留去した後、残液を圧力 3.9 × 1 0^{-4} M P a で減圧蒸留し、沸点 $150\sim155$ \mathbb{C} の留分を 回収することにより、 6.2 g の淡黄色液体を得た。 19 F - N M R スペクトルおよび G C - M S から、 この液体は下記式 (46):

で表わされるパーフルオロビニルエーテルであることが確認された。

¹⁹F-NMR: δ (ppm) - 146.8 (1F),
136 (1F), -123.5 (1F), -117.9 (2

F), -116 (1F), -86.0 (2F), -81.

3 (3F), -80.2 (2F)

実施例24

得られた溶液を0℃まで昇温し、実施例18の工程(I)で用いたスルホニルフルオリド(37)200gを滴下し、

得られた混合物を室温で2時間攪拌することにより反応を行った。

得られた反応混合物に少量の水を加えた後、THFを留去し、残液に希塩酸を加えて酸性にし、HFC43-10meeで抽出した。抽出液を乾燥後、溶媒を留去し、残液を圧力0.4 k P a で減圧蒸留し、沸点118℃の留分を回収することにより、実施例22で得られたパーフルオロビニルエーテル(45)170gを無色液体として得た。

実施例 2 5

実施例18で得られたパーフルオロピニルエーテル(40)7.5gに代えて実施例24で得られたパーフルオロビ . ニルエーテル(45)10gを用いた以外は、実施例19と同様の操作を行い、1.2gの白色固体を得た。

19F-NMRスペクトルより、この固体はパーフルオロビニルエーテル(45)に由来するモノマー単位(スルホンアミド単位)およびTFEに由来するモノマー単位(TFE単位)を含む共重合体であり、スルホンアミド単位とTFE単位の存在比(モル比)は1:4.5であることが確認された。

実施例26

(I) 3元共重合体膜の製造

ガス導入管を有するステンレス製 2 0 0 m 1 耐圧容器に、 実施例 1 8 の工程 (I) で用いたスルホニルフルオリド (3 7) (以降「SO₂Fモノマー」と称する) 6 3 . 6 g、実 施例 2 4 で得られたパーフルオロビニルエーテル (4 5) 3 . 3 g、 4 0 gのHFC43-10meeおよび重合開始剤と して (CF₃CF₂CF₂COO)₂の5%HFC43-10 mee溶液 0 . 8 5 gを入れ、容器内を充分に窒素置換した 後、ガス導入管よりTFEを容器内に導入し、容器の内圧を 0 . 3 MPaまで上昇させた。その後、内圧が 0 . 3 MPa に保たれるよう適宜TFEを導入しながら、攪拌下 2 3 ℃で 4 . 5 時間反応を行った。

その後、TFEの導入を停止し、圧力を常圧に戻した後、得られた反応混合物(白色ゲル状)にメタノールを加え、析出した固体を濾過により回収し、洗浄した後乾燥して、11.6gの白色固体を得た。

1°F-NMRスペクトルより、この固体はパーフルオロピニルエーテル(45)に由来するモノマー単位(スルホンアミド単位)、上記SO2Fモノマーに由来するモノマー単位(SO2F単位)およびTFEに由来するモノマー単位(TFE単位)を含む3元共重合体であり、TFE単位、SO2F単位およびスルホンアミド単位の存在比(モル比)は4.1:1.0:0.04であることが確認された。またこの固体のIRスペクトルにおいて、スルホンアミド基に基づ

くピーク(3391、3306および1544cm $^{-1}$)が確認された。

この3元共重合体のメルトインデックスは7.5であった。 得られた3元共重合体を270℃でプレス成形することにより、無色透明な3元共重合体膜(膜厚88μm)を得ることができた。

(I I) 高分子固体電解質膜の製造

実施例16の工程(I)で得られた3元共重合体膜に代えて上記工程(I)で得られた3元共重合体膜を用いる以外、 実施例16の工程(II)と同様の操作を行い、高分子固体 電解質膜を得た。

得られた高分子固体電解質膜の引張弾性率は、150℃で4. 1×10^7 d y n e / c m²、300℃で3. 6×10^7 d y n e / c m²であった。

実施例27

(I) 3元共重合体膜の製造

 SO_2F モノマーの量を 6 6 . 2 g 、パーフルオロビニルエーテル(4 5)の量を 0 . 6 7 g に変更した以外、実施例 2 6 の工程(I)と同様に重合を行い、 1 3 . 7 g の白色固体を得た。

19F-NMRスペクトルより、この固体はSO2F単位

およびTFE単位を含み、S〇₂F単位およびTFE単位の 存在比(モル比)は1:3.7であることが確認された。

またIRスペクトルより、この固体はスルホンアミド単位を含み、その含有量はスルホンアミド単位、SO₂F単位およびTFE単位の合計量(mol)に対し0.8mol%であることが確認された。

以上のことから、得られた固体はスルホンアミド単位、SO2F単位およびTFE単位を含む3元共重合体であることが確認された。

この3元共重合体のメルトインデックスは12.3であった。また、この3元共重合体をメルトインデクサー中27 0℃で荷重をかけずに1時間保持した後、再びメルトインデックスを測定したが、メルトインデックスは変化しなかった。

得られた 3 元共重合体を 2 7 0 ℃でプレス成形することにより、無色透明な 3 元共重合体膜(膜厚 8 2 μm)を得ることができた。

(II) 高分子固体電解質膜の製造

実施例16の工程(I)で得られた3元共重合体膜に代えて上記工程(I)で得られた3元共重合体膜を用いる以外、 実施例16の工程(II)と同様の操作を行い、高分子固体 電解質膜を得た。

得られた高分子固体電解質膜の引張弾性率は、150℃で

3. 8×10⁷dyne/cm²、300℃で1. 2×10⁷dyne/cm²であった。

実施例28

(I) CF₃CHFOCF₂CF(CF₃) OCF₂CF₂S O₂Fの合成

蒸留ヘッドを取り付けたフラスコを用い、炭酸ナトリウム 1 2 4 g と 2 0 0 m 1 のテトラグライムからなるスラリー中 に、60℃で、下記式:

 CF_3CF (COF)OCF $_2CF$ (CF $_3$)OCF $_2CF_2SO_2F$ で表わされる化合物 6 0 0 g を滴下し、得られた混合物を 6 0 $\mathbb C$ で1時間攪拌することにより反応を行った。得られた反応混合物に 2 1 m 1 の水を加えて 1 2 0 $\mathbb C$ で1時間加熱した。その後、減圧下 1 2 0 $\mathbb C$ で加熱し、発生する蒸気を凝縮して留出液として回収し、水で洗浄した後、圧力 1 3 3 \times 1 0 $\mathbb C$ 4 M P a で減圧蒸留し、沸点 8 2 $\mathbb C$ 8 3 $\mathbb C$ 0 の留分を回収することにより 2 1 9 g の無色液体を得た。 $\mathbb C$ 9 F $\mathbb C$ 7 N M R Z ペクトルから、この液体は下記式:

CF₃CHFOCF₂CF (CF₃) OCF₂CF₂SO₂F で表わされる化合物であることが確認された。

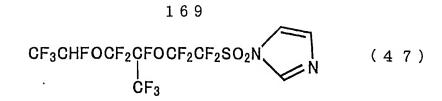
 $^{1.9}$ F - N M R : δ (p p m) - 1 4 8 . 3 (1 F) , - 1 4 6 . 6 (1 F) , - 1 1 4 . 4 (2 F) , - 8 8 . 3 (1 F) , - 8 6 . 9 (3 F) , - 8 5 . 5 (1 F) , - 8

2. 4 (3 F), -81. 4 (2 F), 4 2. 7 (1 F) ¹ H - N M R δ (p p m): 6. 0 (1 H)

(II) アミド化反応

水素化ナトリウム鉱油分散液(水素化ナトリウム含有率: 60%)20.8gを窒素気流下n-ヘキサンで洗浄して鉱 油を除去し、得られた水素化ナトリウム粉末に300mlの 無水ジメトキシエタンを加え、得られた混合物を0℃に冷却 し、32gのイミダゾールを200mlのジメトキシエタン に溶かした溶液を滴下した後、室温まで昇温して1時間攪拌 し、イミダゾールナトリウムアミド溶液を得た。

得られた溶液を0℃に冷却し、上記工程(I)で得られた化合物219gを滴下した。得られた混合物を室温まで昇温後、室温で12時間攪拌することにより反応を行った。得られた反応混合物に少量の水を加え、ジメトキシエタンを減圧で留去し、残液に少量の水を加え、HFC43-10meeで抽出した。得られた抽出液を希NaOH水溶液で洗浄し、乾燥した後、溶媒を留去し、残液を圧力3.9×10⁻⁴MPaで減圧蒸留し、沸点102~104℃の留分を回収することにより135gの無色液体を得た。¹⁹F-NMRスペクトルおよびGC-MSから、この液体は下記式(47):



で表わされるスルホンアミドであることが確認された。

¹⁹ F - NMR: δ (ppm) - 148. 3 (1F),
146. 6 (1F), -115. 5 (2F), -88. 3

(1F), -86. 9 (3F), -85. 5 (1F), -8

2. 4 (3F), -81. 4 (2F)

 1 H-NMR δ (ppm): 7.4 (1H), 6.8 (1H), 6.5 (1H), 6.0 (1H)

(III) ビニル化反応 (脱フッ化水素反応)

ヘキサメチルジシラザン126m1を500m1の無水T HFに溶解した溶液を-78 $\mathbb C$ に冷却し、窒素気流下、n-B u L i の n - ヘキサン溶液(1.6M)375mlを滴下した。得られた混合物を-78 $\mathbb C$ で30分間攪拌してリチウムヘキサメチルジシラジド溶液を得た。

得られた溶液を 0 ℃まで昇温し、上記工程 (I I) で得られたスルホンアミド 1 3 5 g を 3 0 0 m l の T H F に溶解した溶液を滴下し、得られた混合物を 0 ℃で 1 時間攪拌することにより反応を行った。

得られた反応混合物に少量の水を加え、THFを留去し、 残液に少量の水およびHFC43-10meeを加え、得ら れた混合物を濾過して不溶物を除き、有機相を乾燥後、溶媒 を留去し、残液を圧力 4. $0 \times 1 \ 0^2$ P a で減圧蒸留し、沸点 $1 \ 4 \ 0 \sim 1 \ 5 \ 0^2$ の留分を回収することにより $7 \ 9 \ g$ の無色液体を得た。 $1 \ 9 \ F - NMR$ スペクトルおよび $G \ C - MS$ から、この液体は実施例 $2 \ 1$ で得られたパーフルオロビニルエーテル($4 \ 2$)であることが確認された。

比較例5

比較例2で用いた共重合体(36)の粉末30gを、HCFC225ca/cb100m1中に室温で30分間浸漬した。この混合物を-78℃に冷却し、この中にアンモニア0.8gを凝縮させて添加した。得られた混合物を-78℃で30分攪拌後、攪拌下、温度を徐々に室温まで上げることにより反応を行った。この間に、上記混合物中の過剰のアンモニアを揮発させて除いた。

得られた反応混合物を蒸発乾固後、粉末状の残渣を80℃の3N硫酸で2回洗浄し、さらに80℃の熱水で充分に洗浄した後乾燥することにより、SO₂F基が完全にアミド化された共重合体を得た。以降この共重合体を「アミド化共重合体」と称する。

上記アミド化共重合体 1 0 重量部および上記共重合体 (36) 9 0 重量部を混合し、得られた混合物を、日本国東洋精機社製ラボプラストミルを用い、270℃、100 rpmで20分間溶融混練し、組成物を得た。

得られた組成物を270℃でプレス成形することにより重合体膜(膜厚85μm)を得ることができたが、この重合体膜は均一ではなく、無色透明のマトリックス中に微小な粒子が分散した構造を有していた。

この重合体膜を顕微赤外分光法で分析したところ、上記重合体膜中で上記アミド化共重合体と上記共重合体(36)は完全に分離しており、アミド化共重合体は上記粒子のみに、共重合体(36)は上記マトリックスのみに含まれていることがわかった。このことは、上記アミド化共重合体と上記共重合体(36)の間の相溶性が極めて低いことを示すものである。

また、実施例16の工程(I)で得られた3元共重合体膜に代えて上記重合体膜を用いる以外、実施例16の工程(II)と同様の操作を行い、高分子固体電解質膜を得た。

得られた高分子固体電解質膜の引張弾性率は、150℃で 3.2×10^7 d y n e / c m 2 であった。しかし、この高分子固体電解質膜は約180℃で溶融してしまうため、300℃における引張弾性率の測定はできなかった。

実 施 例 2 9

(I) 3元共重合体膜の製造

ガス 導入 管を有するステンレス 製 1 リットル 耐圧容器に、 実 施 例 1 8 の 工程 (I) で 用 い た ス ル ホ ニ ル フ ル オ リ ド (3 7)(以降「 SO_2F モノマー」と称する) 233g、実施例 14で得られたパーフルオロビニルエーテル 4.4g、7 11gのHFC43-10me e および重合開始剤として($CF_3CF_2CF_2COO$)2の5%HFC43-10me e 溶液 3.7gを入れ、容器内を充分に窒素置換した後、ガス導入管よりTFEを容器内に導入し、容器の内圧を0.16MPaまで上昇させた。その後、内圧が0.16MPaから0.14MPaまで徐々に低下するよう適宜TFEを導入しながら、攪拌下35℃で5.5時間反応を行った。またこの反応の途中で、($CF_3CF_2CF_2COO$)2の5%HFC43-10me e 溶液 1.9gを追加した。

その後、TFEの導入を停止し、圧力を常圧に戻した後、 得られた反応混合物中の溶媒および未反応モノマーを留去し、 析出した固体を濾過により回収し、HFC43-10mee で洗浄した後乾燥して、50.0gの白色固体を得た。

1°F-NMRスペクトルより、この固体は上記パーフルオロビニルエーテルに由来するモノマー単位(スルホンアミド単位)、上記SO2Fモノマーに由来するモノマー単位(SO2F単位)およびTFEに由来するモノマー単位(TFE単位)を含む3元共重合体であり、TFE単位、SO2F単位およびスルホンアミド単位の存在比(モル比)は3.2:1.0:0.019であることが確認された。またこの固体のIRスペクトルにおいて、スルホンアミド基に基づく

ピークが確認された。

この3元共重合体のメルトインデックスは15.9であった。

得られた3元共重合体を270℃でプレス成形することにより、無色透明な3元共重合体膜(膜厚56μm)を得ることができた。

(II) 高分子固体電解質膜の製造

実施例16の工程(I)で得られた3元共重合体膜に代えて上記工程(I)で得られた3元共重合体膜を用いる以外、 実施例16の工程(II)と同様の操作を行い、高分子固体 電解質膜を得た。

得られた高分子固体電解質膜のプロトン伝導度を測定したところ、0.099S/cmであった。尚、工程(I)で得られた3元共重合体膜を、変性処理しないこと以外、実施例16の工程(II)と同様の操作を行い、得られた高分子固体電解質膜についてプロトン伝導度を測定したところ、0.107S/cmであった。

得られた高分子固体電解質膜の引張弾性率は、150℃で 2. 9×10^7 d y n e / c m²、300℃で2. 5×10^7 d y n e / c m²であった。

(I) 3元共重合体膜の製造

実施例14で得られたパーフルオロビニルエーテル4.4 gに代えて実施例24で得られたパーフルオロビニルエーテル(45)7.1 gを用いた以外は、実施例29と同様の操作を行い、45.3 gの白色固体を得た。

18F-NMRスペクトルより、この固体はパーフルオロビニルエーテル(45)に由来するモノマー単位(スルホンアミド単位)、上記SO2Fモノマーに由来するモノマー単位(SO2F単位)およびTFEに由来するモノマー単位(TFE単位)を含む3元共重合体であり、TFE単位、SO2F単位およびスルホンアミド単位の存在比(モル比)は3.4:1.0:0.023であることが確認された。またこの固体のIRスペクトルにおいて、スルホンアミド基に基づくピークが確認された。

この3元共重合体のメルトインデックスは17.5であった。

得られた 3 元共重合体を 2 7 0 $\mathbb C$ でプレス成形することにより、無色透明な 3 元共重合体膜(膜厚 5 6 μ m)を得ることができた。

(II) 高分子固体電解質膜の製造

実施例16の工程(I)で得られた3元共重合体膜に代えて上記工程(I)で得られた3元共重合体膜を用いる以外、

実施例16の工程(II)と同様の操作を行い、高分子固体 電解質膜を得た。

得られた高分子固体電解質膜のプロトン伝導度を測定したところ、0.105S/cmであった。尚、工程(I)で得られた3元共重合体膜を、変性処理しないこと以外、実施例16の工程(II)と同様の操作を行い、得られた高分子固体電解質膜についてプロトン伝導度を測定したところ、0.091S/cmであった。

得られた高分子固体電解質膜の引張弾性率は、150℃で3.0×107dyne/cm²、300℃で2.6×107dyne/cm²であった。

実施例31

(I) 3元共重合体膜の製造

実施例14で得られたパーフルオロビニルエーテルの量を 10.9gに変更した以外、実施例29の工程(I)と同様 に重合を行い、40.3gの白色固体を得た。

1°F-NMRスペクトルより、この固体は上記パーフル オロビニルエーテルに由来するモノマー単位(スルホンアミ ド単位)、上記SO2Fモノマーに由来するモノマー単位 (SO2F単位)およびTFEに由来するモノマー単位(T FE単位)を含む3元共重合体であり、TFE単位、SO2 F単位およびスルホンアミド単位の存在比(モル比)は3. 固体の I R スペクトルにおいて、スルホンアミド基に基づく ピークが確認された。

この3元共重合体のメルトインデックスは40.3であった。

得られた高分子固体電解質膜のプロトン伝導度を測定したところ、0.097S/cmであった。尚、工程(I)で得られた3元共重合体膜を、変性処理しないこと以外、実施例16の工程(II)と同様の操作を行い、得られた高分子固体電解質膜についてプロトン伝導度を測定したところ、0.104S/cmであった。

得られた3元共重合体を270℃でプレス成形することにより、無色透明な3元共重合体膜(膜厚40μm)を得ることができた。

(II) 高分子固体電解質膜の製造

実施例16の工程(I)で得られた3元共重合体膜に代えて上記工程(I)で得られた3元共重合体膜を用いる以外、 実施例16の工程(II)と同様の操作を行い、高分子固体 電解質膜を得た。

得られた高分子固体電解質膜の引張弾性率は、150℃で3. 3×10^7 d y n e / c m 2、 300 ℃で4. 6×10^7 d y n e / c m 2であった。

実施例32

実施例31で得られた共重合体14重量部および比較例2で用いた共重合体(37)86重量部を混合し、得られた混合物を、日本国東洋精機社製ラポプラストミルを用い、270℃、100rpmで20分間溶融混練し、組成物を得た。

得られた組成物を 270 \mathbb{C} でプレス成形することにより均一で無色透明な共重合体膜(膜厚 56μ m)を得ることができた。

実施例16の工程(I)で得られた3元共重合体膜に代えて上記共重合体膜を用いる以外、実施例16の工程(II)と同様の操作を行い、高分子固体電解質膜を得た。

得られた高分子固体電解質膜の引張弾性率は、150℃で4. 4×10^7 d y n e / c m²、300℃で4. 1×10^7 d y n e / c m²であった。

比較例6

(I) アミド化反応

実施例 1 の工程(I)で得られたカルボン酸ナトリウム塩 36.6gを100m1のジグライムに溶解し、得られた溶液を<math>-50 ℃に冷却し、アンモニア 17g を凝縮させて添加した。

得られた混合物を、攪拌下、7時間かけて温度を徐々に室温まで上げることにより反応を行った。この間に、混合物中

の過剰のアンモニアを揮発させて除いた。

得られた反応混合物(白濁した液体)を濾過し、得られた 濾液中の溶媒を減圧下で留去し、残渣を60℃で真空乾燥し て、43gの白色の粘稠な液体を得た。¹⁹F-NMRスペ クトルから、この液体は下記式:

CF₃CF(CO₂Na)OCF₂CF₂SO₂NH₂で表わされるスルホンアミドであることが確認された。

 19 F - N M R : δ (p p m) - 1 3 1. 7 (1 F), - 1 2 2. 3 (1 F), - 1 1 8. 6 (1 F), - 8 7. 5 (1 F), - 8 3. 1 (3 F), - 7 4. 6 (1 F)

(I I) 脱炭酸反応

上記工程 (I) で得られたスルホンアミド43gを100m1のジグライムに溶解し、得られた溶液を窒素気流下150℃で2時間加熱した。得られた反応混合物を¹⁹F-NMRで分析したところ、この反応混合物には下記式:

CF₃CHFOCF₂CF₂SO₂NH₂で表わされるプロトン付加体が含まれていることが確認された。

¹⁹ F - NMR: δ (ppm) - 146.7 (1F),
117.9 (2F), -84.7 (1F), -84.5 (3

F), -82.6 (1F),

しかし上記反応混合物には、下記式:

 $\texttt{C} \ \texttt{F} \ {}_{2} = \texttt{C} \ \texttt{F} \ \texttt{O} \ \texttt{C} \ \texttt{F} \ {}_{2} \ \texttt{C} \ \texttt{F} \ {}_{2} \ \texttt{S} \ \texttt{O} \ {}_{2} \ \texttt{N} \ \texttt{H} \ {}_{2}$

で表わされる目的のパーフルオロビニルエーテルは全く含まれて<u>いなかっ</u>た。

産業上の利用可能性

本発明のパーフルオロビニルエーテルモノマーを用いると、優れた特性を有するフッ素化重合体を製造することができる。このフッ素化重合体は種々の用途、例えば、高分子固体電解質の原料として特に好ましく用いることができる。本発明のパーフルオロビニルエーテルモノマーを原料として用いて得られる高分子固体電解質は、耐久性に優れている上、優れた耐熱性および高いプロトン伝導率を示すので、燃料電池用の電解質として特に好ましく用いることができる。

181

請 求 の 範 囲

1. 下記式(1) で表されるパーフルオロビニルエーテルモノマー。

$$CF_2$$
= CF - $(OCF_2CF)_mO(CF_2)_nSO_2NR^1R^2$
 CF_3 (1)

(式中、

mは0~5の整数であり;

nは1~5の整数であり;

R¹およびR²は、各々独立に、水素原子;無置換、または、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、アルコキシ基、カルボニル基、エステル基、酸アド基、スルホニル基およびエーテル基より置換される少なくとも1種の置換基により置換されるの炭素原子を有する、炭素数1~1の炭化水素基を置換をして含み、合計10の炭素原子を有する置換シリル基であり、個以下の炭素原子を有する置換シリル基であり、個以下の炭素原子を有する置換シリル基であり、の無置換または置換炭化水素基、或いはには、R¹およびR²が、各々独立に、該炭素数1~10の無置換または置換炭化水素基、或いにはには、R¹およびR²が互はにはなり、R¹およびR²と結合して2価の基となり、R¹およびR²と結合して2価の基となり、R¹およびR²と結合して2価の基となり、R¹およびR²と結合して2価の基となり、R¹およびR²と結合して2価の基となり、R¹およびR²と結合して2価の基となり、R¹およびR²と結合して2価の基となり、R¹およびR²と結合して2価の基となり、R¹およびR²と結合して2価の基となり、R¹およびR²と結合して2価の基となり、R¹およびR²と結合して2価の基となり、R¹およびR²と結合して2価の基となり、R¹およびR²と結合して2位の基となり、R¹およびR²と対点ないた。

いる窒素原子と共に、飽和または不飽和含窒素複素 環を形成していてもよい。)

- 2. 式(1)中のR¹が水素原子、該炭素数1~10の無置換または置換炭化水素基、或いは該置換シリル基であり、式(1)中のR²が水素原子または該置換シリル基であることを特徴とする、請求項1に記載のモノマー。
- 3. 式(1)中のR¹およびR²の少なくとも一方が該置換シリル基であることを特徴とする、請求項1に記載のモノマー。
- 4. 式(1) 中のR¹およびR²の少なくとも一方が水素原子であることを特徴とする、請求項1に記載のモノマー。
- 5. 式 (1) 中の R ¹ および R ² がいずれも水素原子である ことを特徴とする、請求項 1 に記載のモノマー。
- 6. 請求項1に記載のモノマーを製造する方法であって、(i)下記式(2):

(式中、mおよびnは上記式(1)において定義した通りである。)

で表されるアシルフルオリドを、下記式(3):

$$M^{1}OC-CF-(OCF_{2}CF)_{m}O(CF_{2})_{n}SO_{2}F$$
 $II \quad I \quad I \quad (3)$
 $O \quad CF_{3} \quad CF_{3}$

(式中、

m および n は上記式 (1) において定義した通り であり;

M¹はアルカリ金属、アルカリ土類金属、4級アンモニウム基または4級ホスホニウム基である。)で表されるカルボン酸塩に変換し:

(ii) 該カルボン酸塩(3) のフルオロスルホニル基のアミド化反応、次いで場合によりアルカリ性化合物処理を行うことにより、下記式(4):

(式中、

mおよびnは上記式(1)において定義した通りであり;

M¹は上記式 (3) において定義した通りであり;

R³およびR⁴は、各々独立に、水素原子:無置 換、または、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、ア ルコキシ基、カルボニル基、エステル基、酸アミド 基、スルホニル基およびエーテル基よりなる群から 選ばれる少なくとも1種の置換基により置換され、 合計15個以下の炭素原子を有する、炭素数1~1 0の炭化水素基;少なくとも1個の炭素数1~10 の炭化水素基を置換基として含み、合計10個以下 の炭素原子を有する置換シリル基:アルカリ金属: アルカリ土類金属:アンモニウム基:或いはホスホ ニウム基であり、但し、R3およびR4が、各々独 立に、該炭素数1~10の無置換または置換炭化水 素基、或いは該置換シリル基であるときは、R3お · よびR4が互いに結合して2価の基となり、R3お よびR4と結合している窒素原子と共に、飽和また は不飽和含窒素複素環を形成していてもよく、また R³およびR⁴が同時に水素原子であることはな (,4)

で表されるスルホンアミドを得;

(i i i) 該スルホンアミド(4) を脱炭酸ーピニル化、次いで場合によりプロトン性化合物で処理する ことを含む方法。 7. 式(1)、(2)、(3)および(4)中のmがいずれ も0であることを特徴とする、請求項6に記載の方法。

8. 下記式(4)で表されるスルホンアミド。

(式中、

 $m は 0 \sim 5 の整数であり;$

 $n は 1 \sim 5 の整数であり;$

M¹ はアルカリ金属、アルカリ土類金属、4級ア ンモニウム基または4級ホスホニウム基であり;

R³およびR⁴は、各々独立に、水素原子;無置換、または、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、アルコキシ基、カルポニル基、エステル基、酸アミド基、スルホニル基およびエーテル基より置換される少なくとも1種の置換基により置換されるの炭素原子を有する、炭素数1~10の炭化水素基を置換をして含み、合計10の炭素原子を有する間換シリル基;アルカリ金属;アルカリ土類金属;アンモニウム基であり、但し、R³およびR⁴が、各々独ニウム基であり、但し、R³およびR⁴が、各々独ニウム基であり、但し、R³およびR⁴が、各々独ニウム基であり、但し、R³およびR⁴が、各々独

立に、該炭素数 1~10の無置換または置換炭化水素基、或いは該置換シリル基であるときは、R³およびR⁴が互いに結合して2価の基となり、R³およびR⁴と結合している窒素原子と共に、飽和または不飽和含窒素複素環を形成していてもよく、またR³およびR⁴が同時に水素原子であることはない。)

9. 式 (4) 中のmが 0 であることを特徴とする、請求項 8 に記載のスルホンアミド。

10.式(1)中のR¹およびR²がいずれも水素原子であるか、または式(1)中のR¹およびR²が、各々独立に、水素原子;無置換、または、2個の炭化水素基を置換基として含むN,N一二置換アミノ基、アルコキシ基およびエーテル基よりなる群から選ばれる少なくとも1種の置換基により置換され、合計15個以下の炭素原子を有する、炭素数1~10の炭化水素基;または該置換シリル基であり、但し、R¹およびR²のうち少なくとも1つは、炭素数3~10の2級または3級のアルキル基、または該置換シリル基である、請求項1に記載のモノマーを製造する方法であって、

下記式 (5):

$$CF_2$$
= CF - $(OCF_2CF)_mO(CF_2)_nSO_2F$
 CF_3
 (5)

(式中、mおよびnは上記式(1)において定義した 通りである。)

で表されるスルホニルフルオリドをアミド化、次いで場合によりプロトン性化合物で処理することを含み、

該アミド化を、該スルホニルフルオリド (5) を下記式 (6):

$$M^{2}NR^{5}R^{6}$$
 (6)

(式中、

M² は水素原子、アルカリ金属またはアルカリ土 類金属であり;

R®およびR®は、各々独立に、無置換、または、 2個の炭化水素基を置換基として含むN,N-二置 換アミノ基、アルコキシ基およびエーテル基よりな る群から選ばれる少なくとも1種の置換基により置 換され、合計15個以下の炭素原子を有する、炭素 数1~10の炭化水素基;または、少なくとも1個 の炭素数1~10の炭化水素基を置換基として含み、 合計10個以下の炭素原子を有する置換シリル基で あり、但し、R®およびR®のうち少なくとも1つ は、炭素数3~10の2級または3級のアルキル基 または該置換シリル基であり、

R⁵およびR⁶が互いに結合して2価の基となり、 R⁵およびR⁶と結合している窒素原子と共に、飽 和または不飽和含窒素複素環を形成していてもよ い。)

で表されるアミンまたは金属アミドと反応させることによっ て行う

ことを特徴とする方法。

11. 請求項1に記載のモノマーの製造方法であって、下記式(7):

$$CF_3CHF-(OCF_2CF)_mO(CF_2)_nSO_2NR^1R^2$$
 CF_3
 (7)

(式中、m、n、R¹およびR²は上記式(1)にお いて定義した通りである。)

該脱フッ化水素を、該化合物 (7)を下記式 (8):

$$M^3NR^xR^y$$
 (8)

(式中、

M³はアルカリ金属またはアルカリ土類金属であり;

R×およびRyは、各々独立に、無置換、または、 2個の炭化水素基を置換基として含むN,N一二置 換アミノ基、アルコキシ基およびエーテル基よりな る群から選ばれる少なくとも1種の置換基により置 換され、合計15個以下の炭素原子を有する、炭素 数1~10の炭化水素基;または、少なくとも1個 の炭素数1~10の炭化水素基を置換基として含み、 合計10個以下の炭素原子を有する置換シリル基で あり、但し、R×およびRyのうち少なくとも1つ は、炭素数3~10の2級または3級のアルキル基 または該置換シリル基であり、

R×およびR^yが互いに結合して2価の基となり、R^xおよびR^yと結合している窒素原子と共に、飽和または不飽和含窒素複素環を形成していてもよい。)

で表される金属アミドと接触させることによって行うことを特徴とする方法。

12. 下記式 (7) で表される化合物。

$$CF_3CHF$$
- $(OCF_2CF)_mO(CF_2)_nSO_2NR^1R^2$ (7) CF_3

(式中、

mは0~5の整数であり;

nは1~5の整数であり;

R¹およびR²は、各々独立に、水素原子;無置換、または、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、アルコキシ基、カルボニル基、エステル基、酸アミド基、スルホニル基およびエーテル基より置換され、合計15個以下の炭素原子を有する、炭素数1~10の炭化水素基を置換をして含み、合計10個以下の炭素原子を有する置換シリル基であり、但し、R¹およびR²が、各々独立に、該炭素数1~10の無置換または置換炭化水素基、或いは該置換シリル基であるときは、R¹およびR²が互いに結合して2価の基となり、R¹およびR²と結合している窒素原子と共に、飽和または不飽和含窒素複素環を形成していてもよい。)

13. 請求項1に記載のモノマーの製造方法であって、下記式(9):

$$CF_2X^1$$
— CFX^2 — $(OCF_2CF)_mO(CF_2)_nSO_2NR^1R^2$
 CF_3

191

(式中、

m、n、R¹およびR²は上記式(1) において 定義した通りであり;

- X¹および X²は、各々独立に、塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子である。)

で表される化合物を脱ハロゲン化、次いで場合によりプロトン性化合物で処理する ことを含む方法。

14. 下記式(9)で表される化合物。

$$CF_2X^1$$
— CFX^2 — $(OCF_2CF)_mO(CF_2)_nSO_2NR^1R^2$ (9)

(式中、

mは0~5の整数であり;

nは1~5の整数であり;

R¹およびR²は、各々独立に、水素原子;無置換、または、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、アルコキシ基、カルボニル基、エステル基、酸アミド基、スルホニル基およびエーテル基よりなる群から選ばれる少なくとも1種の置換基により置換され、合計15個以下の炭素原子を有する、炭素数1~10の炭化水素基;或いは少なくとも1個の炭素数1

~10の炭化水素基を置換基として含み、合計10個以下の炭素原子を有する置換シリル基であり、但し、R¹およびR²が、各々独立に、該炭素数1~10の無置換または置換炭化水素基、或いは該置換シリル基であるときは、R¹およびR²が互いに結合して2価の基となり、R¹およびR²と結合している窒素原子と共に、飽和または不飽和含窒素複素環を形成していてもよく、

X¹ および X² は、各々独立に、塩素原子、臭素 原子またはヨウ素原子である。)

15. 下記式(1):

$$CF_2 = CF - (OCF_2CF)_mO(CF_2)_nSO_2NR^1R^2$$

$$CF_3$$

$$(1)$$

(式中、

mは0~5の整数であり;

nは1~5の整数であり;

R¹およびR²は、各々独立に、水素原子;無置換、または、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、アルコキシ基、カルボニル基、エステル基、酸アミド基、スルホニル基およびエーテル基よりなる群から選ばれる少なくとも1種の置換基により置換され、

合計15個以下の炭素原子を有する、炭素数1~10の炭化水素基;或いは少なくとも1個の炭素数1~10の炭化水素基を置換基として含み、合計10個以下の炭素原子を有する置換シリル基であり、但し、R¹およびR²が、各々独立に、該炭素数1~10の無置換または置換炭化水素基、或いは該置換シリル基であるときは、R¹およびR²が互いに結合して2価の基となり、R¹およびR²と結合している窒素原子と共に、飽和または不飽和含窒素複素環を形成していてもよい。)

で表されるパーフルオロビニルエーテルモノマーを単独重合 させる、またはオレフィン性不飽和結合を有する少なくとも 1種のコモノマーと共重合させる ことを特徴とする、フッ素化重合体の製造方法。

- 16. 該モノマー(1)を、テトラフルオロエチレンを包含するコモノマーと共重合させることを特徴とする、請求項15に記載の方法。
- 17. 請求項15または16に記載の方法で製造されたフッ素化重合体。
- 18. 下記式(10):

 $CF_2 = CFO(CF_2)$ pSO₂NR^aR^b (10) (式中、

pは1~5の整数であり;

で表わされる少なくとも1種のモノマーに由来するモノマー単位を包含することを特徴とするフッ素化重合体。

19. 該モノマー(10)に由来するモノマー単位およびテトラフルオロエチレンに由来するコモノマー単位を包含する

195

フッ素化共重合体であることを特徴とする、請求項18に記載のフッ素化重合体。

- 20.フッ素化共重合体の製造方法であって、
- (a) 部分的または完全にフッ素化されたビニル基、および-下記式(11):

$$-SO_2NR^7R^8$$
 (11)

(式中、

R⁷は水素原子;無置換、または、ハロゲン原子、水酸基、アミノ基、アルコキシ基、カルボニル基、 エステル基、酸アミド基、スルホニル基およびエーテル基よりなる群から選ばれる少なくとも1種の置換基により置換され、合計15個以下の炭素原子を有する、炭素数1~10の炭化水素基;或いは少なくとも1個の炭素数1~10の炭化水素基を置換基として含み、合計10個以下の炭素原子を有する置換シリル基であり;

R®は水素原子または該置換シリル基である。)
で表わされる基を有する少なくとも1種のモノマー;
(b) 部分的または完全にフッ素化されたビニル基、および

(ロ) 部分的または元宝にノツ茶化されたヒニル基、およい下記式(12):

$$-SO_2X^3$$
 (12)

(式中、 X³はフッ素原子、塩素原子または-OR®

基を表わし、R % は該炭素数 1 ~ 1 0 個の無置換または置換炭化水素基、或いは該置換シリル基である。)

で表わされる基を有する少なくとも1種のモノマー;および 場合により

(c) 該モノマー(a) および(b) 以外の、オレフィン性不飽和結合を有する少なくとも1種のモノマーを共重合させることを含む方法。

2 1. 該モノマー(a)が、下記式(13):

CF₂=CF-Rf-SO₂NR⁷R⁸ (13)
(式中、

R⁷およびR⁸は上記式(11)において定義し た通りであり;

R f は単結合;下記式(14):

$$-C_{q}X_{q}^{4}$$
 (14)

(式中、

qは1~20の整数であり;

X⁴は、各々独立に、フッ素原子;また は水素原子、塩素原子およびアルコキシ基 よりなる群から選ばれる1価の置換基であ り、但し、該1価の置換基の数は、X⁴の 数の35%以下である。) で表される炭素数 1 ~ 2 0 のフッ素化アルキレン 基:または

下記式(15):

$$- O C_a X_{2a}^4 - (15)$$

(式中、 q および X ⁴ は上記式 (14) において 定義した通りである。)

で表される炭素数 1 ~ 2 0 のフッ素化オキシアルキレン基であり、

該炭素数 1~20のフッ素化アルキレン基(14)または該炭素数 1~20のフッ素化オキシアルキレン基(15)中の隣接した2個の炭素原子間の単結合のうち少なくとも1本が、酸素原子、カルボニル基、スルホニル基、ビスカルボニルイミド基よびカルボニルスルホニルイミド基よりなる群から選ばれる2価の置換基によって置換されていてもよく、但し、該2価の置換

で表されるモノマーであることを特徴とする、請求項20に記載の方法。

基の数は、該整数qの50%以下である。)

22. 該モノマー(a)が、下記式(16):

$$CF_2$$
= CF - $(OCF_2CF)_mO(CF_2)_nSO_2NR^7R^8$
 CF_3 (16)

(式中、

m は 0 ~ 5 の整数であり;

nは1~5の整数であり;

R⁷および R⁸は上記式 (11) において定義した通りである。)

で表されるモノマーであることを特徴とする、請求項20に記載の方法。

23. 該モノマー(a)、(b) および(c) を共重合し、 該モノマー(c) がテトラフルオロエチレンを含むことを特 徴とする、請求項20~22のいずれかに記載の方法。

24.請求項20~23のいずれかに記載の方法で製造された共重合体。

2 5. (A) 部分的または完全にフッ素化されたビニル基、 および下記式(11):

$$- S O_2 N R^7 R^8$$
 (11)

(式中、

R⁷は水素原子;無置換、または、ハロゲン原子、 水酸基、アミノ基、アルコキシ基、カルボニル基、 エステル基、酸アミド基、スルホニル基およびエー テル基よりなる群から選ばれる少なくとも1種の置換基により置換され、合計15個以下の炭素原子を有する、炭素数1~10の炭化水素基;或いは少なくとも1個の炭素数1~10の炭化水素基を置換基として含み、合計10個以下の炭素原子を有する置換シリル基であり;

R®は水素原子または該置換シリル基である。) で表わされる基を有する少なくとも1種のモノマーに由来するモノマー単位;および

(B) 部分的または完全にフッ素化されたピニル基、および 下記式 (12):

$$-SO_{2}X^{3}$$
 (12)

(式中、X³はフッ素原子、塩素原子または-OR°基を表わし、R°は該炭素数1~10の無置換または置換炭化水素基、或いは該置換シリル基である。)

で表わされる基を有する少なくとも 1 種のモノマーに由来するモノマー単位

よりなるスルホニル基含有モノマー単位を包含することを特 徴とするフッ素化共重合体。

2 6. 該モノマー単位 (A) および (B) 、並びにテトラフ ルオロエチレンに由来するコモノマー単位を包含することを 特徴とする、請求項25に記載のフッ素化共重合体。

27. 該モノマー単位(A)の量が、該モノマー単位(A) および(B)の合計モル量に対し0.001~50mo1% であることを特徴とする、請求項25または26に記載の共 重合体。

28. 該共重合体の重量(g)を、該モノマー単位(A) および(B) の合計モル量で除することによって求められる、該スルホニル基含有モノマー単位1mol当たりの該共重合体の重量が400~1400g/molであることを特徴とする、請求項25~27のいずれかに記載の共重合体。

29. 該モノマー単位(A)が、各々下記式(13):
 CF₂=CF-Rf-SO₂NR⁷R⁸ (13)
 (式中、

 R^7 および R^8 は上記式(11)において定義した通りであり;

R f は単結合;下記式(14):

$$-C_{q}X_{2q}^{4}-$$
 (14)

(式中、

qは1~20の整数であり;

X⁴は、各々独立に、フッ素原子;また

は水素原子、塩素原子およびアルコキシ基 よりなる群から選ばれる1価の置換基であ り、但し、該1価の置換基の数は、X⁴の 数の35%以下である。)

で表される炭素数 1 ~ 2 0 のフッ素化アルキレン-基 ;-または

下記式(15):

$$- O C_{q} X_{q}^{4} - (15)$$

(式中、 q および X ⁴ は上記式 (14) において 定義した通りである。)

で表される炭素数1~20のフッ素化オキシアルキレン基であり、

該炭素数 1~20のフッ素化アルキレン基(14)または該炭素数 1~20のフッ素化オキシアルキレン基(15)中の隣接した2個の炭素原子間の単結合のうち少なくとも1本が、酸素原子、カルボニル基、スルホニル基、ビスカルボニルイミド基およびカルボニルスルホニルイミド基よりなる群から選ばれる2価の置換基によって置換されていてもよく、但し、該2価の置換基の数は、該整数 q の 50%以下である。)

で表されるモノマーに由来するモノマー単位であることを特徴とする、請求項25~28のいずれかに記載の共重合体。

30. 該モノマー単位(A)が、各々下記式(16):

$$CF_2$$
= CF - $(OCF_2CF)_mO(CF_2)_nSO_2NR^7R^8$
 CF_3 (1 6)

(式中、

mは $0 \sim 5$ の整数であり;

nは1~5の整数であり;

R⁷およびR⁸は上記式(11)において定義し た通りである。)

で表されるモノマーに由来するモノマー単位であることを特徴とする、請求項25~28のいずれかに記載の共重合体。

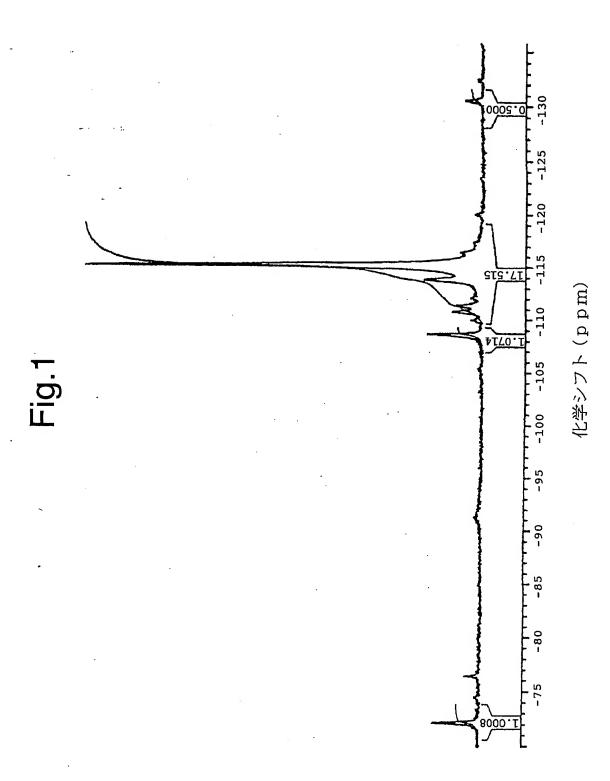
- 31. 請求項24~30のいずれかに記載の共重合体またはそれを含む組成物から製造される共重合体膜。
- 32. 請求項24~30のいずれかに記載の共重合体またはそれを含む組成物を溶融成形することを含む、共重合体膜の製造方法。
- 33.請求項32に記載の方法によって製造される共重合体膜。

- 34. 単層膜であることを特徴とする、請求項31または33に記載の共重合体膜。
- 35.請求項31、33および34のいずれかに記載の共重合体膜を塩基性物質で処理することを含む、変性共重合体膜の製造方法。
- 36.請求項35に記載の方法で製造された変性共重合体膜。
- 37. 請求項36に記載の変性共重合体膜を、アルカリ処理および酸処理よりなる群から選ばれる少なくとも一つの処理に付すことを特徴とする、高分子固体電解質膜の製造方法。
- 38.請求項37に記載の方法で製造された高分子固体電解質膜。
- 39.請求項31、33および34のいずれかに記載の共重合体膜を塩基性物質で処理することを含む、架橋共重合体膜の製造方法。
- 40. 請求項39に記載の方法で製造された架橋共重合体膜。
- 41. 請求項40に記載の架橋共重合体膜を、アルカリ処理

204

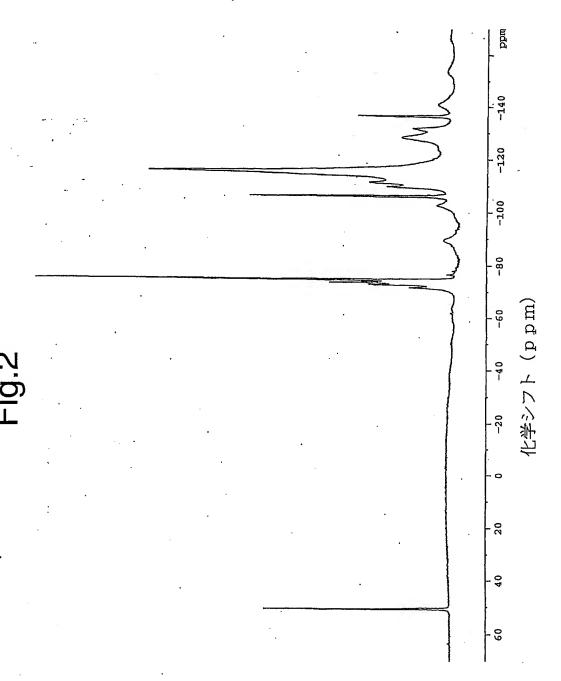
および酸処理よりなる群から選ばれる少なくとも一つの処理 に付すことを特徴とする、架橋高分子固体電解質膜の製造方 法。

42.請求項41に記載の方法で製造された架橋高分子固体電解質膜。



差替え用紙(規則26)





THE PROBLEM INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP02/00854

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl⁷ C07C311/24, 303/36, C07F7/12, C08F214/26, C08F216/14, H01M8/02 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl7 C07C311/00, 303/00, C07F7/00, C08F214/00, H01M8/00 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) REGISTRY(STN); CA(STN) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. X WO 00/52085 A1 (E.I. Du Pont De Nemours and Co.), 1-5,10, 08 September, 2000 (08.09.00), 15-42 Y & EP 1157061 A1 6-9,11-14 Х WO 99/45048 A1 (E.I. Du Pont De Nemours and Co.), 1-5, 10,10 September, 1999 (10.09.99), 15-42 Y & EP 1060200 A1 & JP 2002-505356 A 6-9,11-14 Х WO 99/38842 A1 (Hydro-Quebec), 1-5, 10,05 August, 1999 (05.08.99), 15-42 & EP 973734 A1 Y & JP 2001-522376 A 6-9,11-14 Х EP 302478 A1 (Tosoh Corp.), 1-5, 10,08 February, 1989 (08.02.89), 15-36 Y & JP 1-40498 A & US 4944852 A 6-9,11-14 Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex. Special categories of cited documents: later document published after the international filing date or "A" document defining the general state of the art which is not priority date and not in conflict with the application but cited to considered to be of particular relevance understand the principle or theory underlying the invention "E" earlier document but published on or after the international filing document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is step when the document is taken alone cited to establish the publication date of another citation or other document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document published prior to the international filing date but later "&" document member of the same patent family than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report 28 May, 2002 (28.05.02) 11 June, 2002 (11.06.02) Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer Japanese Patent Office Facsimile No. Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP02/00854

C (Continua	tion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
х	JP 62-104891 A (Toyo Soda Manufacturing Co., Ltd.),	1-5,10, 15-36
_Y	15 May, 1987 (15.05.87), Päges 2 to 6 (Family: none)	6-9,11-14
Y	US 4578512 A (Dow Chemical Co.), 25 March, 1986 (25.03.86), & JP 57-28025 A	6-9
Y	<pre>JP 56-138127 A (Daikin Industries, Ltd.), 28 October, 1981 (28.10.81), Pages 3 to 4 (Family: none)</pre>	11,12
Y	WO 94/27945 A1 (E.I. Du Pont De Nemours and Co.), 08 December, 1994 (08.12.94), & US 5350497 A & JP 9-501406 A & EP 699176 A1	13,14
Х	ZHU, Shizheng et al., "Synthesis of diethyl N- (perfluoroalkanesulfonyl) phosphoramidates and N-(perfluoroalkanesulfonyl) phosphoramidic acids", Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements, 1998, Vol.140, pages 53 to 61	8
Х	KENNEDY, Gerald L. Jr., "Increase in mouse liver weight following feeding of ammonium perfluoro-octanoate and related fluorochemicals", Toxicol. Lett., 1987, Vol.39, Nos. 2 to 3, pages 295 to 300	14
	. (2)	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.

PCT/JP02/00854

	observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)		
This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:			
1.	Claims Nos.:		
	because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:		
-			
1			
	Claims Nos.:		
	because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:		
	out of the second secon		
	-		
3.	Claims Nos.:		
	because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).		
	Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)		
The	national Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows: subject matters of the claims are classified into the following groups.		
(I) (Claims 1-19 and		
t on a	that part of claims 22-24 and 30-42 which relates to the compound (1)		
	Claims 20-21 and 25-29 and that part of claims 22-24 and 30-42 which does not relate to the compound		
((1)		
Betwe	en these groups, there is no relationship involving any special technical		
be so	re common to these. Consequently, these groups are not considered to linked as to form a single general inventive concept.		
The	refore, the number of inventions disclosed in the claims of this		
	As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable		
C	claims.		
2.	As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment		
	of any additional fee.		
	As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers		
C	only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:		
4. 🗀 N	No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is		
	estricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:		
-	contains to the mitaliant memories in the staining, it is covered by staining 1405		
n .			
Remark o			
	No protest accompanied the payment of additional search fees.		

INTERNATIONAL SEARCH REPORT International application No.

International application No.
PCT/JP02/0085

PCT/JP02/00854 Continuation of Box No.II of continuation of first sheet(1) international application is 2.

Form PCT/ISA/210 (extra sheet) (July 1998)

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP02/00854

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl⁷ C07C311/24, 303/36, C07F7/12, C08F214/26, C08F216/14, H01M8/02

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl⁷ C07C311/00, 303/00, C07F7/00, C08F214/00, H01M8/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

REGISTRY (STN), CA (STN)

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X Y	WO 00/52085 A1(E. I. Du Pont De Nemours and Co.)2000.09.08 & EP 1157061 A1	1-5, 10, 15-42 6-9, 11-14
X Y	WO 99/45048 A1(E. I. Du Pont De Nemours and Co.)1999.09.10 & EP 1060200A A1 & JP 2002-505356 A	1-5, 10, 15-42 6-9, 11-14
Х	WO 99/38842 A1 (Hydro-Quebec) 1999. 08. 05 & EP 973734 A1 & JP 2001-522376 A	1-5, 10, 15-42 6-9, 11-14
		0 0,11 11

|X|| C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 · 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 28.05.02 国際調査報告の発送日 11.06.02 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 4H 8318 前 田 窓 彦 印 単便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3443

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する
X Y	EP 302478 A1 (Tosoh Corp.) 1989. 02. 08 & JP 1-40498 A & US 4944852 A	請求の範囲の番号 1-5, 10, 15-36 6-9, 11-14
X Y	JP 62-104891 A(東洋曹達工業株式会社)1987.05.15 第2-6頁 (ファミリーなし)	1-5, 10, 15-36 6-9, 11-14
Y	US 4578512 A(Dow Chemical Company) 1986.03.25 & JP 57-28025 A	6-9
· Y	JP 56-138127 A(ダイキン工業株式会社)1981.10.28 第3-4頁 (ファミリーなし)	11, 12
Y	WO 94/27945 A1(E. I. Du Pont De Nemours and Co.)1994.12.08 & US 5350497 A & JP 9-501406 A & EP 699176 A1	13, 14
X	ZHU, Shizheng et al. "Synthesis of diethyl N-(perfluoroalkane sulfonyl) phosphoramidates and N-(perfluoroalkanesulfonyl) phosphoramidic acids", Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements, 1998, Vol. 140, p. 53-61	8
Х	KENNEDY, Gerald L., Jr., "Increase in mouse liver weight following feeding of ammonium perfluoroctanoate and related fluorochemicals", Toxicol. Lett., 1987, Vol. 39, No. 2-3, p. 295-300	14
		•

第Ⅰ欄	請求の範囲の一部の調査ができないときの意見 (第1ページの2の続き)			
法第8条第3項 (PCT17条(2)(a)) の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。				
1. [請求の範囲は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。 つまり、			
2.	請求の範囲 は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、			
з. 🗌	請求の範囲は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に 従って記載されていない。			
- Iron				
第Ⅱ概	発明の単一性が欠如しているときの意見(第1ページの3の続き)			
、次に述	☆べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。			
① ② の群 一の	での範囲に記載された発明はそれぞれ、 ②請求の範囲1-19 請求の範囲22-24,30-42のうち化合物(1)に関する部分 ②請求の範囲20-21,25-29 請求の範囲22-24,30-42のうち化合物(1)以外に関する部分 挙に区分され、それぞれの群の間は共通する特別な技術的特徴を含む関係にないから、単 の一般的発明概念を形成するように連関しているものとは認められない。 にがって、請求の範囲に記載されている国際出願の発明の数は2である。			
1. X	出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求 の範囲について作成した。			
2.	追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追 加調査手数料の納付を求めなかった。			
3. 🗌	出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。			
4.	出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。			
追加調查	至手数料の異議の申立てに関する注意			
[X	追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。 退加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。			
<u> </u>	3 足が関連す政府や別に大に山殿八から天殿中立にかなかった。			